

整理No.	タイトル	著者	巻	号	ページ	発行年	記事の種類	分野-1	キーワード
4047	巻頭言:表面技術の拡大発展を期待して	二瓶公志	41	1	1	1990	1:巻頭言		
4048	電気ブリキライン全不溶性陽極化技術の開発と工業化	齋藤隆穂	41	1	2	1990	3:解説	B02	電気すずめっき,不溶性陽極システム,電気ブリキライン
4049	ポリバラキシレン高分子薄膜の気相成長	高井吉明,水谷昭吉,家田正之	41	1	9	1990	3:解説	B09	ポリバラキシレン(PPX),高分子薄膜,気相成長
4050	シリーズ/表面物性評価技術-薄膜の物理的性質評価(5)-光学的性質の評価法	若木守明	41	1	15	1990	9:シリーズ-2	A10	光学特性,光解析,FT-IR,ラマン,固体表面
4051	シリーズ/表面物性評価技術-表面状態の解析(5)-金属及び半導体/水溶液界面の電気化学反応とIn-Situ STM法	板谷謹悟	41	1	21	1990	9:シリーズ-2	B09	STM,その場測定,電極表面
4052	シリーズ開始にあたって	伊藤 滋	41	1	26	1990	10:比べてみよう		
4053	シリーズ/くらべてみよう物性値-融点	伊藤 滋	41	1	27	1990	10:比べてみよう	A10	融点
4054	現場の知恵-亜鉛めっき黒色クロメート皮膜の乾燥法(2)	*	41	1	28	1990	16:現場の知恵	B08	亜鉛めっき,クロメート,乾燥方法
4055	ガス軟窒化とレーザー焼入との複合処理	薬師寺正男,近藤喜之,石井孝也,辻井弘和,池永 勝	41	1	29	1990	5:原著論文	B06	ガス軟窒化,レーザー焼き入れ,複合熱処理
4056	高周波スパッタリングによるチタン-ニッケル合金皮膜の作製とその腐食挙動	富岡秀徳,上田重朋	41	1	34	1990	5:原著論文	A01	Ti-Ni合金,非晶質合金,rf-スパッタリング,腐食耐性
4057	スパッタリングによるSiC薄膜の特性に及ぼす窒素ガス添加の影響	桑野三郎,大竹輝徳,沖 猛雄	41	1	40	1990	5:原著論文	A01	SiC,スパッタリング,窒素ガス添加
4058	無電解Ni-Mo-P合金皮膜の構造	逢坂哲彌,新井克矢,増淵長則,澤井達彦,増淵長則,新井克矢,奥野齋藤哲男,吉村俊一,佐藤栄一	41	1	45	1990	5:原著論文	B03	無電解めっき, Ni-Mo-P合金皮膜,皮膜成長プロセス
4059	無電解Ni-Mo-P合金皮膜の結晶化に及ぼすMo原子的の影響	逢坂哲彌,増淵長則,新井克矢,奥野齋藤哲男,吉村俊一,佐藤栄一	41	1	49	1990	5:原著論文	B03	無電解めっき, Ni-Mo-P合金皮膜,皮膜構造
4060	無電解Ni-Co-B合金皮膜の作製	逢坂哲彌,新井克矢,増淵長則,澤井達彦,増淵長則,新井克矢,奥野齋藤哲男,吉村俊一,佐藤栄一	41	1	53	1990	5:原著論文	B03	無電解めっき, Ni-Co-B合金,ヒドラン
4061	アミノシラン処理ガラス上への無電解ニッケル-パラジウムの吸着状態と触媒活性	浜谷健生,熊谷八百三	41	1	57	1990	5:原著論文	B03	無電解めっき, Niめっき, アミノシラン, パラジウム
4062	溶融亜鉛めっき処理条件が高張力鋼の衝撃特性に及ぼす影響	千葉和茂,首藤治三,嵯峨卓郎	41	1	62	1990	5:原著論文	A03	溶融亜鉛めっき,高張力鋼,衝撃特性,シャルピー衝撃試験
4063	ピロリン酸浴からのCu-Zn合金めっき過程の交流インピーダンス挙動	藤原 裕,榎本英彦	41	1	67	1990	7:速報論文	B02	Cu-Znめっき,ピロリン酸浴,交流インピーダンス
4064	空気中中性化したセメント模擬溶液における鉄の腐食挙動	山下嗣人,永田 誠	41	1	69	1990	7:速報論文	B09	鉄,腐食,セメント溶液,インピーダンス解析
4065	巻頭言:カナダを旅して	苗村 博	41	2	85	1990	1:巻頭言		
4066	溶剤洗浄の今後のあり方-フロン削減・全廃の動向から	竹内節三	41	2	86	1990	3:解説	C06	溶剤洗浄,フロン削減
4067	装飾用ニッケル-クロムめっきの耐食性-硫黄の影響を中心として	G.A.Dibari,R.A.Cover,A.T.Dill(訳)佐藤	41	2	91	1990	3:解説	B02	Ni-Crめっき,装飾めっき,腐食,硫黄
4068	すきま腐食の防止に対する陰極防食法の適用	福沢秋刀,白水 司	41	2	99	1990	3:解説	B09	すきま腐食,カソード防食,再不動電位,ステンレス鋼
4069	歯科材料の表面処理	坂 清子	41	2	107	1990	3:解説	A10	歯科材料,表面処理,接合
4070	シリーズ/表面物性評価技術-薄膜の物理的性質評価(6)-薄膜の摩擦・磨耗特性	柳沢雅広	41	2	113	1990	9:シリーズ-2	A10	摩擦・磨耗特性,薄膜
4071	シリーズ/くらべてみよう物性値-融点(酸化物)	伊藤 滋	41	2	118	1990	10:比べてみよう	A10	融点
4072	現場の知恵-III主合金ホルムリンの凹み	原 健作	41	2	119	1990	16:現場の知恵	B02	凹みめっき,回転めっき
4073	Oプラズマアッシングによるデバイス汚染	岩黒弘明,黒田 司,平井 実	41	2	121	1990	5:原著論文	C04	酸素プラズマアッシング,デバイス,汚染
4074	ベ-スト法によるTi ₂ 及びTi合金のホウ化処理	渋谷佳男,磯部賢二,佐藤憲治,若林 袁,本鎮,興戸正純,沖 猛雄	41	2	126	1990	5:原著論文	B08	ホウ化,チタン,チタン合金
4075	NaOH水溶液中での電解着色ステンレス鋼の表面組成と耐食性	岸 富也,高橋栄一,今井隆之	41	2	131	1990	5:原著論文	B07	着色,腐食挙動,表面皮膜,ステンレス鋼
4076	アルミナ表面へのスズ(II)とパラジウム(II)イオンの吸着	園田 司,杉本 謹,西羅正芳,縄舟秀美,水本省三	41	2	136	1990	5:原著論文	B03	アルミナ,吸着,スズ,パラジウム
4077	グルコン酸浴からの光沢すずめっき	園田 司,杉本 謹,西羅正芳,縄舟秀美,水本省三	41	2	140	1990	5:原著論文	B02	光沢めっき,すず,グルコン酸浴,添加剤
4078	微粒子への電気めっきに関する液抵抗による考察	竹島鋭機	41	2	145	1990	5:原著論文	B02	電気めっき,微粒子,液抵抗,粒子分散
4079	微粒子への電気めっきにおける最適電解槽の構造決定	竹島鋭機,高津 清	41	2	151	1990	5:原著論文	B02	電気めっき,微粒子,液抵抗,沈降速度,粒子分散
4080	EDTA錯体浴からの電気銅めっき及びその皮膜物性	水本省三,縄舟秀美,小島環生,芳賀正記,園田 司	41	2	156	1990	5:原著論文	B02	電気銅めっき,EDTA,均一電着性,機械特性,結晶構造
4081	トリフルオロ酢酸銅-添加剤-メタノール浴からの銅電析	武井たつ子	41	2	161	1990	5:原著論文	B02	トリフルオロ酢酸銅,電気銅めっき,メタノール浴
4082	無電解ニッケルめっきの初期析出過程	本間英夫,野口雅司	41	2	164	1990	5:原著論文	B03	無電解Niめっき,初期析出過程,触媒
4083	無電解銅めっき皮膜の熱膨張特性	水本省三,縄舟秀美,園田 司,荒木小野幸子,川口朋子,増子 昇	41	2	169	1990	7:速報論文	B03	無電解銅めっき,熱膨張,水素含量
4084	種々の酸溶液中で生成したアルミニウムアノード酸化皮膜の電解着色	引地貴義,下屋敷重広,竹内 純,鶴岡良	41	2	171	1990	7:速報論文	B07	アノード酸化皮膜,アルミニウム,電解着色
4085	化学除染法によるステンレス鋼からのMnの除染試験	引地貴義,下屋敷重広,竹内 純,鶴岡良	41	2	173	1990	7:速報論文	B09	除染試験,放射性腐食生成物,ステンレス鋼,ナトリウム,Mn
4086	巻頭言:厚みのある表面	増子 昇	41	3	187	1990	1:巻頭言		
4087	ステンレス鋼とは	今井八郎	41	3	188	1990	2:総説	A10	ステンレス鋼,分類,表面処理
4088	ステンレス鋼のパッシベーション	滝沢貴久男	41	3	195	1990	3:解説	B09	ステンレス鋼,不動態化,酸洗い,腐食
4089	ステンレス鋼の化学的なら磨法の現状-電解研磨と化学研磨	金子 智,佐藤義和	41	3	203	1990	3:解説	C02	ステンレス鋼,電解研磨,化学研磨
4090	ステンレス鋼の発色	出口武典	41	3	207	1990	3:解説	B09	ステンレス鋼,着色,インコ法,交番電流電解法
4091	ステンレス鋼の塗装	水谷 滋	41	3	212	1990	3:解説	A05	ステンレス鋼,塗装,塗膜剥離,クロメート
4092	ステンレス鋼上の金めっき	岩城泰彦,山下嗣人	41	3	217	1990	3:解説	B02	ステンレス鋼,金めっき
4093	ステンレス鋼上のクロムめっき	大串徹太郎	41	3	221	1990	3:解説	B02	ステンレス鋼,クロムめっき,大気腐食,ガルバニック腐食
4094	制御雰囲気のもとでの加熱処理によるステンレス鋼の不動態化	八代利之,寺島慶一,山崎桓友	41	3	227	1990	3:解説	B06	ステンレス鋼,加熱処理,制御雰囲気,不動態化
4095	ステンレス鋼の表面改質のための熱処理	八代利之,寺島慶一,山崎桓友	41	3	235	1990	3:解説	B06	ステンレス鋼,熱処理,酸化,窒化

4096	ステンレス鋼ほうろう	祖川 理・大角 務	41	3	244	1990	3:解説	A10	ステンレス鋼, ほうろう, セラミックコーティング
4097	ドライコーティングによるステンレス鋼の表面処理	伊藤 叡	41	3	249	1990	3:解説	A10	ステンレス鋼, PVD, CVD, 腐食耐性, 装飾性
4098	酸化反応制御機能を有する触媒膜の作製シリーズ / 表面物性評価技術 - 薄膜の物理的性質評価(7) - 機械的パルス・テスターによる薄膜のダクティリティ(柔軟性・延性)の測定について	角田達朗・早川 孝・亀山哲也	41	3	255	1990	3:解説	A10	モリブデン酸ビスマス, 薄膜, 安定化ジルコニア, 触媒
4099	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(6) - X線マイクロアナリシス	中原昌平・沖中 裕	41	3	260	1990	9:シリーズ-2	B03	柔軟性, 延性, 無電解銅めっき, 電解銅めっき
4100	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(6) - X線マイクロアナリシス	横石規子	41	3	267	1990	9:シリーズ-2	A10	EPMA, 定量分析, 定性分析, 元素分布, 状態分析
4101	オゾン酸化処理によるポリプロピレンの塗装性の改良	伊藤 滋	41	3	272	1990	10:比べてみよう	A10	融点, 化合物
4102	微粒子電気めっきの電流効率に関する研究	于 建・白石振作	41	3	273	1990	5:原著論文	A05	オゾン酸化処理, ポリプロピレン, 塗装性
4103	微粒子電気めっきの生産性の向上	竹島鋭機・藤井孝浩・高津 清・坂倉 昭	41	3	278	1990	5:原著論文	B02	微粒子めっき, 電流効率, 電流密度
4104	異種水酸化物の凝集コロイドを利用する無電解めっきについて	岩井正雄・栗倉泰弘・広瀬茂行・笹野 益生・眞嶋 宏	41	3	290	1990	5:原著論文	B03	無電解めっき, 凝集コロイド, プラスティックの活性化, グラファイト
4105	ク - ロスタット法による無電解ニッケルめっき速度のモニタリング	松岡政夫・岩本和也・林 忠夫	41	3	295	1990	5:原著論文	B03	無電解Niめっき, クロスタット法, モニタリング
4106	チタン - ニッケル系非晶質合金皮膜の耐食性に及ぼすクロム及びタングステン添加アルミニウム基板上的非晶質チタン - ニッケル合金皮膜の耐食性	富岡秀徳・上田重朋	41	3	300	1990	5:原著論文	A01	Ti-Ni合金, Cr合金, W合金, 非晶質合金, 腐食耐性
4107	ニッケルめっきにおける塩化物イオンの役割	富岡秀徳・上田重朋	41	3	306	1990	5:原著論文	A01	Ti-Ni合金, 非晶質合金, β -スバタリング, 腐食耐性
4108	還元剤添加示差原子吸光分析によるCr(III),(IV)の定量とクロム分析への応用	安田光宏・大野 淑・春山志郎	41	3	312	1990	5:原著論文	B03	ニッケルめっき, 水素ガス量, 塩素イオン
4109	Al - Mn合金板の陽極酸化皮膜のXMA及びESCA測定	吉村長蔵・藤野隆由	41	3	318	1990	5:原著論文	B02	原子吸光分析, Cr(), Cr(), クロムめっき浴
4110	電気泳動電着法を利用した酸化イリジウム被覆チタン基体電極の作製	桜井定人・加藤久雄・酒井光生・西 保・小林秀彦・加藤巴幸・下田宏之・三田村孝・亀ヶ谷洋一・黒河圭子・小平隆士・福島 誠・滝沢貴久・男・今井八郎	41	3	323	1990	13:研究ノート	B07	Al-Mn合金, 陽極酸化, XMA, ESCA
4111	HCD法によるTiNコーティング鋼の硫酸水溶液中での耐食性	幸・下田宏之・三田村孝・亀ヶ谷洋一・黒河圭子・小平隆士・福島 誠・滝沢貴久・男・今井八郎	41	3	325	1990	7:速報論文	A06	電気泳動電着法, IrO ₂ 被覆, チタン電極
4112	巻頭言: 技術と芸術	土 福島 誠・滝沢貴久・男・今井八郎	41	4	337	1990	1:巻頭言	A10	HCD, イオンプレーティング, 腐食, TiN, ステンレス鋼
4113	電極表面の原子・分子の吸着とその挙動	本間 禎一	41	4	338	1990	3:解説	A10	単結晶電極, 赤外分光分析, ラマン分光分析
4114	走査型トンネル電子顕微鏡によるめっきの初期過程の観察	伊藤正時	41	4	344	1990	3:解説	B02	その場STM, 電気めっき, UPD, 単結晶電析
4115	無電解めっきの初期過程と構造	板谷 謹悟	41	4	349	1990	3:解説	B03	無電解めっき, 構造, 非晶質, 初期析出過程
4116	電析法によるNi - B非晶質合金の作製	渡辺 徹	41	4	349	1990	3:解説	B03	Ni-B合金, 電気めっき, 非晶質, 構造
4117	ヒスチジン添加ピロリン酸浴からのCu - Zn合金電析物の構造と形態	小野田元伸・土屋武司・小川勝明・渡辺 徹	41	4	388	1990	5:原著論文	B02	Cu-Zn合金めっき, ピロリン酸浴, ヒスチジン, 表面形態
4118	トリフルオロ酢酸ニッケル - ホウ酸 - ホルムアミド溶液にチオ尿素を添加した浴から電析したニッケルのXPS解析	藤原 裕・榎本英彦	41	4	392	1990	5:原著論文	B02	XPS, ニッケルめっき, 硫黄
4119	結晶化ガラスへのCuめっき	武井たつ子	41	4	397	1990	5:原著論文	B02	無電解銅めっき, ほうろう配線, スルーホール
4120	表面・界面プローブとしての低速陽電子	津山宏一・岡村寿郎・中山 肇	41	4	442	1990	6:技術論文	B03	低速陽電子, 表面, 界面, 薄膜
4121	微小くし形電極を用いる電気化学測定	森田雅夫	41	4	361	1990	11:アカデミック研究会シリーズ	A10	微小電極, くし形電極, IDA, ボルタンメトリー
4122	水晶振動子による微量重量分析法 - エレクトロクロミズムに対する応用	馬場宣良・益田秀樹	41	4	366	1990	11:アカデミック研究会シリーズ	B09	水晶振動子, 微量重量分析, QCM, エレクトロクロミズム
4123	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(7) - 薄膜X線解析法	荒木宏侑	41	4	370	1990	9:シリーズ-2	A10	薄膜, X線回折, JCPDSカード
4124	クロム基板上に作製したチタン - ニッケル非晶質合金皮膜の耐食性	伊藤 滋	41	4	375	1990	10:比べてみよう	A10	沸点, 単体
4125	反応性イオンプレーティングによるTiN薄膜の配向性・モルフォロジー及びその特性	富岡秀徳・上田重朋	41	4	377	1990	5:原著論文	A01	Ti-Ni合金, 非晶質合金, β -スバタリング, 腐食耐性
4126	電気めっき複合粉末の作製及びそれを用いた複合材料の開発	王 東冬・村田英昭・沖 猛雄	41	4	382	1990	5:原著論文	A01	TiN, 反応性イオンプレーティング, 配向性, 皮膜特性
4127	無電解Ni - P - SiC複合めっき皮膜の性質	竹島鋭機・藤井孝浩	41	4	401	1990	5:原著論文	B02	粒子, 電気めっき, SEM, Cu-W合金, 焼結
4128	電位差滴定法による無電解銅めっき液中のホルムアルデヒドの定量	西羅正芳・杉本 謹・鷹野 修	41	4	407	1990	5:原著論文	B03	複合めっき, 無電解めっき, Ni-P, Si-C, 耐摩耗性
4129	フッ化物添加アミンアルカリ性浴中でのアルミニウムの陽極酸化	水本省三・縄舟秀美・川崎元雄・木下 朱美・荒木 建	41	4	412	1990	5:原著論文	B03	電位差滴定法, 無電解銅めっき, ホルムアルデヒド
4130	Al - Si 鑄造合金の硫酸溶液中におけるアノード酸化挙動	野口駿雄・吉村長蔵	41	4	417	1990	5:原著論文	B07	アノード酸化, アルミニウム, アミンアルカリ浴, フッ化物
4131	パルス電解法で形成したSUS430とSUS304ステンレス鋼表面皮膜の構造と性質	高橋英明・渡辺啓一・橋本定典・古市 袁 本鎮・興戸正純・沖 猛雄	41	4	423	1990	5:原著論文	B07	アノード酸化, アルミニウム合金, ダイカスト
4132	EXAFSのカ - プフィッティング法による改質hopeite結晶の局部構造解析と構造決	佐藤 登 南 達郎	41	4	431	1990	5:原著論文	B09	SUS430, SUS304, 着色, 表面皮膜, 孔食
4133	無電解ニッケル - タングステン - ボロン合金めっき皮膜の電気抵抗特性について	青木公二・鷹野 修	41	4	446	1990	7:速報論文	B03	Hopeite結晶, EXAFS, カーブフィッティング法, 構造解析
4134	巻頭言: ドライプロセスとソフト化	沖 猛雄	41	5	461	1990	1:巻頭言	B03	無電解めっき, Ni-W-B合金, 電気抵抗
4135	ドライプロセスによる表面硬化技術とその動向	沖 猛雄	41	5	462	1990	3:解説	A10	表面硬化, ドライプロセス, PVD, CVD, イオン注入
4136	低温プラズマ利用の先端技術	村山洋一	41	5	471	1990	3:解説	A10	プラズマ, PVD, CVD
4137	熱プラズマを利用した堆積技術の展開 - 高速CVDと溶射に重点を置いて	明石和夫	41	5	477	1990	3:解説	B01	プラズマ, CVD, 溶射, プラズマスプレー, 表面改質
4138	固体表面上の薄膜の付着及びその制御	金原 黎・馬場 茂	41	5	485	1990	3:解説	A10	付着, 内部応力, 薄膜
4139	スパッタイオンプレーティングによるTiAlN膜の作製と応用	服部幸司・前原博志	41	5	490	1990	3:解説	A01	TiAlN, 反応性スパッタ, イオンプレーティング, 耐酸化性
4140	II - IV族結晶の腐食模様と極性方向の判定法	岩永 浩	41	5	495	1990	3:解説	C04	エッチング, 極性, 族化合物, 双晶

4144	シリーズ/表面物性評価技術 - 表面状態の解析(8) - グロー放電分光分析法	古主泰子	41	5	502	1990	9:シリーズ-2	A10	グロー放電分光分析, 定量分析, 深さ方向元素分析
4145	シリーズ/表面物性評価技術 - スパッタリング法によるTiN, ZrN及びHfN薄膜の形成とその特性	澤井秀夫	41	5	507	1990	10:比べてみよう	A10	スパッタ率
4146	AIP法によるTiN, ZrN及びHfN薄膜の形成とその特性	水口 隆, 黄 燕清, 古川哲也, 辻 邦彦	41	5	509	1990	5:原著論文	A01	アーキオンプレーティング (AIP), TiN, ZrN, HfN, 薄膜
4147	反応性イオンプレーティング法によるZrB ₂ 薄膜の合成	嶋影和宣, 佐藤忠夫, 戸田茂雄, 菊池	41	5	514	1990	5:原著論文	B01	反応性イオンプレーティング, 合成, ZrB ₂ , B ₂ H ₆ , 薄膜
4148	反応性イオンプレーティングによる窒化クロム薄膜の諸特性	王 東冬, 沖 猛雄	41	5	519	1990	5:原著論文	A01	CrN, イオンプレーティング, 形態, 配向性, 硬さ
4149	HCD法によるTiNコーティング鋼の耐孔食, 耐すきま腐食性	黒河圭子, 小平隆志, 中山佳則, 滝沢貴久男, 今井八郎	41	5	524	1990	5:原著論文	A01	腐食, イオンプレーティング, HCD法, TiN, ステンレス鋼
4150	反応性二成分スパッタリングによる(Ti, Al)N膜の作製	高谷松文, 松永正久	41	5	530	1990	5:原著論文	A01	TiN, AlN, 反応性2成分スパッタリング, 硬化, PVD
4151	RuO ₂ - SiO ₂ スパッタ膜の電気的性質	竹内学, 三輪田和雄, 長坂秀雄	41	5	534	1990	5:原著論文	A01	RuO ₂ , SiO ₂ スパッタリング, 薄膜抵抗体, 抵抗の温度係数 (TCR)
4152	粉末へのスパッタリング法によるアルミナ粒子分散強化型複合材料の開発	竹島鋭機, 五井薫, 藤井孝浩, 坂倉 昭	41	5	538	1990	5:原著論文	A01	粉末, スパッタリング, 焼結, アルミナ, 複合材料
4153	プラズマCVDにより作製した非晶質C膜の光学的性質	杉村博之	41	5	545	1990	5:原著論文	B01	プラズマ-CVD, 非晶質炭素膜, 屈折率, 光学的バンドギャップ
4154	CVD法による軟鋼板上へのZrB ₂ 及びTiB ₂ - ZrB ₂ 皮膜の生成	佐藤忠夫, 西野宇太郎, 宮川俊三, 嶋影和宣	41	5	549	1990	5:原著論文	B01	CVD, ZrB ₂ , TiB ₂ -ZrB ₂ , 複合膜
4155	気相合成ダイヤモンドのカソードミネッセンスによる評価	陳 家富, 黄 燕清, 西村一仁, 細見 暁	41	5	555	1990	5:原著論文	B01	プラズマCVD, ダイヤモンド薄膜, カソードルミネッセンス, ラマン分光分析
4156	族遷移金属への窒素イオン注入による表面薄膜組成と着色性	寺島慶一, 松坂菊生, 峯岸知弘	41	5	560	1990	5:原著論文	A08	窒素イオン注入, 遷移金属, 窒化物, 深さ方向元素分布, 着色
4157	Mo, Nb, V及びCrを含む低炭素合金鋼のイオン窒化	浦尾亮一, 中川清三, 北川和成, 稻見隆, 諏訪正輝	41	5	566	1990	5:原著論文	A08	イオン窒化, 表面硬化, 表面改質, 低炭素合金鋼
4158	SUS304基材上に被覆したTiC皮膜及びNi - TiC複合皮膜の密着性	石田 章, 武井 厚	41	5	570	1990	7:速報論文	A08	イオンプレーティング, TiC, Ni-TiC, 複合皮膜, 密着性
4159	レーザー誘起放電PVD法による硬質C膜の形成	小椋茂樹, 峰田進栄, 安永暢男	41	5	572	1990	7:速報論文	A01	CO ₂ レーザー, レーザー誘起放電, 硬質炭素膜
4160	C ₂ H ₂ - O ₂ 系燃焼炎によるダイヤモンド合成における基板の影響	高谷松文, 三浦 毅, 坂本幸弘	41	5	574	1990	7:速報論文	B09	ダイヤモンド合成, 燃焼炎法, 硬質被覆
4161	純クロムの電気化学的性質に及ぼす窒素またはアルゴン注入の影響	寺島慶一, 松坂菊生, 峯岸知弘	41	5	576	1990	7:速報論文	A08	イオン注入, 電気化学的特性, CrN, 照射損傷
4162	セラミックファイバ - 製マイクロばねの引張り試験法	岩永 浩, 岩崎 武, 元島栖二	41	5	578	1990	7:速報論文	B01	引張り試験法, マイクロばね, セラミックファイバー
4163	日華機能性ドライブロセンシングシンボジウム報告	高井 治	41	5	580	1990	15:リポート	A10	ドライブロセンシング, 機能化, シンボジウム報告, 日華
4164	巻頭言: 協調と競合	田畑三郎	41	6	593	1990	1:巻頭言		
4165	金型の体質改善処理と表面改質処理	大和久重雄	41	6	594	1990	2:総説	B05	熱処理, 表面改質, 金型
4166	金型の熱処理と表面処理	山中久彦	41	6	603	1990	3:解説	B05	熱処理, 表面改質, 金型
4167	PVDによる金型の表面処理	山田保之	41	6	609	1990	3:解説	A01	PVD, イオンプレーティング, 金型
4168	CVDによる金型の表面処理	平原民雄	41	6	615	1990	3:解説	B01	CVD, 炭化, 窒化, 金型
4169	プラスチック用表面加飾成形型の開発	野口裕之, 魏 杰, 中川威雄, 宮本和彦, 柳沢 章, 今井正人	41	6	624	1990	3:解説	A10	セラミック鑄型, プラスティック成形型
4170	湿式めっきによる金型の表面処理	岡田義夫	41	6	630	1990	3:解説	B02	金型, めっき, 無電解めっき, 複合めっき
4171	金型用アルミニウム合金の特性と硬質アルマイト処理	白井克夫	41	6	637	1990	3:解説	B02	金型, 硬質アルマイト, アルミニウム合金
4172	金型表面の電解加工仕上げ	桑原陽平	41	6	646	1990	3:解説	C05	金型, 電解加工
4173	めっき厚さ増加に伴う組成及び構造変化	渡辺 徹	41	6	652	1990	3:解説	B02	めっき, 組成, 構造, 非晶質, 炭化
4174	シリーズ/表面物性評価技術 - 表面状態の解析(9) - ラザフォード後方散乱分析法	木曾義之	41	6	659	1990	9:シリーズ-2	A10	RBS, 表面分析
4175	マイクロ波プラズマCVD法によるダイヤモンド合成における基板材質の影響	伊藤 滋	41	6	664	1990	10:比べてみよう	A10	分解温度
4176	マイクロ波プラズマCVD法によるダイヤモンド合成における基板材質の影響	陳 家富, 黄 燕清, 細見 暁, 吉田勇夫	41	6	665	1990	5:原著論文	B01	プラズマCVD, ダイヤモンド, 基板材質
4177	アルキルベンゼン蒸気吸着による微小面積の測定法	野中 昭	41	6	670	1990	5:原著論文	A04	表面積測定, 吸着, アルキルベンゼン蒸気
4178	PR電析によるエレクトロロミックなイリジウム酸化物薄膜の生成	吉野隆子, 新井賢二, 馬場宣良	41	6	676	1990	5:原著論文	B09	イリジウム酸化物薄膜, エレクトロロミズム, PR電析
4179	Cu - Ni及びCu - Ni - M系合金の内部ホウ化	藤田浩紀, 高田保夫, 新井 透	41	6	684	1990	5:原著論文	B06	内部硼化, 銅合金
4180	アルミニウムアノード酸化皮膜の電解着色挙動	川口朋子, 小野幸子, 佐藤敏彦, 増子	41	6	690	1990	5:原著論文	B07	アノード酸化皮膜, アルミニウム, 電解着色
4181	ハライド系溶融塩法によるクロムめっき鋼上へのホウ化物皮膜形成	沖 猛雄, 兼松秀行	41	6	695	1990	5:原著論文	A09	硼化, クロムめっき鋼, 溶融塩, 不均化反応
4182	超微小硬度計による無電解Ni - Co - B合金皮膜の硬さ	斉藤哲男, 佐藤栄一	41	6	700	1990	5:原著論文	B02	無電解Ni-Co-B合金めっき, 超微小硬度計, ダイナミック硬度
4183	HCl溶液中の交流エッチングで生ずるアルミニウム上の皮膜の2重構造	菅沼栄一, 丹野裕司	41	6	702	1990	7:速報論文	C02	アルミニウム, 交流エッチング, 皮膜, 2層構造, SEM
4184	アミノ基を有する高分子被覆剤を用いた無電解Niめっき	浜谷健生	41	6	704	1990	7:速報論文	B02	無電解ニッケルめっき, 被覆剤, 含アミノ高分子, プラズマイニ-P合金, 水素透過性, 非晶質構造
4185	無電解ニッケルめっき皮膜の水素透過性	松岡政夫, 前川 諭, 岩倉千秋	41	6	706	1990	7:速報論文	B03	
4186	巻頭言: 先進工業国としての今後のあり方	西田滋三	41	7	713	1990	1:巻頭言		
4187	立体配線基板特集よせて	沢山一平	41	7	714	1990	4:技術解説	A10	プリント基板, 立体配線基板, MCB
4188	高性能エンブラによる射出成形回路部品 - PCK-Technologyを中心として	山崎 学	41	7	715	1990	3:解説	A10	エンブラ, 射出成形, 回路基板, 無電解めっき, MCB
4189	2ショット法によるMID	湯本哲男	41	7	721	1990	3:解説	A10	プリント基板, 射出成形デバイス, 2ショット法, フルアディティブ
4190	へこみ配線法	岡田義夫, 安藤 隆, 西城信吾	41	7	728	1990	3:解説	A10	プリント基板, エンブラ, へこみ配線法, 射出成形基板
4191	成形転写法によるMCB	大森和光	41	7	733	1990	3:解説	A10	射出成形, 成形転写法, プリント配線基板
4192	KONECプロセス	高松一也	41	7	741	1990	3:解説	A10	プリント基板, 立体配線基板, スクリーン印刷, KONECプロセス, 金属・セラミック接合, 接合界面, 拡散接合, 残留応力
4193	金属・セラミック接合における課題	諸住正太郎	41	7	745	1990	3:解説	A10	

4194	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(10) - フーリエ変換赤外分光法(FIT-IR)による表面状態の解析	大木貞嗣	41	7	750	1990	9:シリーズ-2	A10	表面分析, FT-IR(フーリエ変換赤外分光)
4195	シリーズ / 表面物性評価技術 - 11(1) HIF法によるFe, Ni基板上へW, Mo板の接合	澤井秀夫, 高井 治, 伊藤 滋, 宮崎邦彰, 森 和美, 小浦延幸, 米田 登	41	7	756	1990	10:比べてみよう	A10	仕事関数
4196	電気化学的手法による電解脱脂中の表面変化測定	市野良一, 興戸正純, 沖 猛雄	41	7	757	1990	5:原著論文	B01	接合, CVD, HIF, W, Mo
4197	アルミニウム合金ダイカストのアルノード酸化挙動に及ぼす合金元素の影響	三田郁夫, 福田一彦	41	7	761	1990	5:原著論文	C06	インピーダンス, 電解脱脂, 表面均一性, モニタリング
4198	アルミニウム合金の孔食に及ぼす有機系食品添加物の影響	加藤 彰, 高木章嘉, 吉原佐知雄, 糸井康彦, 神戸 哲, 佐藤米本, 間英夫, 藤波知之, 高木啓明	41	7	772	1990	5:原著論文	B07	アルミニウム合金, ダイカスト, アルノード酸化, 電流波形, 硫酸アルミニウム合金, 孔食, 有機インヒビター, 光音響分光法, 食品添加物
4199	電解併用無電解銅めっき - プリント配線板への応用	南 達郎, 佐藤 登	41	7	777	1990	7:速報論文	C07	無電解めっき, 銅めっき, 電解併用, プリント配線基板, 機械的
4200	トライボロジー系のスティックスリップに関する表面解析	橋本 哲	41	7	779	1990	7:速報論文	B03	トライボロジー, スティックスリップ, 表面解析, XPS
4201	巻頭言:豊かな生活を引き継ぐために	橋本功二	41	8	795	1990	1:巻頭言	A10	元磁気メモリ, 磁気薄膜, ハット
4202	光磁気メモリ用磁性薄膜の作製	前野仁典, 小林政信	41	8	796	1990	3:解説	A10	スバツタ膜, 垂直磁気異方性, ア
4203	希土類 - 遷移金属アルモルファス合金スバツタ膜の垂直磁気異方性	山本 寛	41	8	803	1990	3:解説	A10	アルモルファス合金, 希土類 - 遷移
4204	アルミニウム電解コンデンサにおける寿命命化とバリアー皮膜	神崎信義, 島谷涼一, 高橋 寛, 徳村弘	41	8	808	1990	3:解説	B07	アルミニウム電解酸化皮膜, アルミニウム電解コンデンサ
4205	アルミニウム陽極酸化皮膜多孔質構造をベ - スとするサブミクロン多孔質電導材料の作製 - 構造転写法による微細規則構造	益田秀樹, 馬場直良	41	8	813	1990	3:解説	B07	アルミニウム陽極酸化皮膜, 多孔質材料, マイクロファブリケーション
4206	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(11) - 2次イオン質量分析法(SIMS)シリーズ / くらべてみよう物性値 - 密度	橋本 哲	41	8	817	1990	9:シリーズ-2	C07	SIMS, 深さ方向分布, イオン像
4207	PVD法による金属薄膜の結晶配向性とモルフォロジー	渡辺 徹	41	8	822	1990	10:比べてみよう	A10	密度
4208	マイクロ波プラズマCVD法によるダイヤモンド合成における反応ガスの影響	王 東冬, 沖 猛雄	41	8	823	1990	5:原著論文	A01	PVD, 金属薄膜, 結晶配向性
4209	(K+, Na+) - フェライト薄膜の感湿特性	陳 家富, 黄 燕清, 細見 暁, 吉田勇夫, 伊藤 滋, 川瀬裕史, 成木伸也, 小浦延幸, 米田 登	41	8	829	1990	5:原著論文	B01	CVD, マイクロ波プラズマ, ダイヤモンド
4210	連続焼鈍によるTi添加鋼板のリン酸塩処理性	羽田隆司, 増井 昇, 米野 実	41	8	834	1990	5:原著論文	A05	湿度センサー, フェライト, 薄膜, イオン交換
4211	片面表面処理鋼板における非処理面のリン酸塩処理性	羽田隆司, 内藤 茂, 安藤公一, 米野 実	41	8	839	1990	5:原著論文	A05	リン酸塩処理性, 連続焼鈍, Ti添加鋼板
4212	銅(II) - EDTA浴からのCu電析の初期過程に及ぼす超音波照射の影響	呉 文昌, 千葉 淳	41	8	844	1990	7:速報論文	A05	リン酸塩処理性, 非処理面, 表面処理鋼板, 酸化物層
4213	電着によるSn-Pb合金C/N砥石の製作	萩生田善明, 高谷松文, 松永正久, 安永暢男	41	8	850	1990	7:速報論文	B02	電気めっき, 核成長, 超音波攪拌, 銅-EDTA
4214	電着によるSn-Pb合金C/N砥石の製作	文 松永正久, 安永暢男	41	8	852	1990	7:速報論文	B02	電析, 分散めっき, ずず, C/N砥石
4215	巻頭言:精神的風土	福本幸男	41	9	861	1990	1:巻頭言		
4216	ECRプラズマ技術の現状	松尾誠太郎	41	9	862	1990	3:解説	B01	電子サイクロトロン共鳴(ECR)プラズマ, 析出, エッチング
4217	ECRプラズマエッチングの現状	鈴木康浩, 鶴飼勝三	41	9	866	1990	3:解説	C04	電子サイクロトロン共鳴(ECR)プラズマ, 反応性イオンビームエッチング, ULSI
4218	ECRスプラズマCVDの現状	赤堀 孝, 尾崎成則, 中山 了	41	9	871	1990	3:解説	B01	電子サイクロトロン共鳴(ECR), プラズマ, CVD
4219	ECRスバツタの現状	小野俊郎, 五十嵐賢, 片山祐三	41	9	877	1990	3:解説	B01	電子サイクロトロン共鳴(ECR), プラズマ, スバツタ
4220	イオンビーム源としてECR	高木憲一	41	9	882	1990	3:解説	B01	電子サイクロトロン共鳴(ECR), イオンビーム源
4221	亜鉛イオン存在下における第2元素の電析挙動	福島久哲, 秋山徹也	41	9	888	1990	3:解説	B02	亜鉛, 電析, 平衡電位
4222	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(12) - ラマン分光法による表面吸着種の解析	大澤雅俊	41	9	894	1990	9:シリーズ-2	B02	ラマン分光法, SERS, 共鳴ラマン効果, 時間分解ラマン
4223	シリーズ / 色 - 自動車の色彩と技術・市場の変化	袴田浩司	41	9	900	1990	9:シリーズ-2	B09	自動車, 色彩, 市場動向
4224	シリーズ / くらべてみよう物性値 - バンドギャップ(1)	澤井秀夫	41	9	905	1990	10:比べてみよう	A10	バンドギャップ
4225	無電解銅めっき浴における化学平衡	水本省三, 縄舟秀美, 松本邦勝	41	9	907	1990	5:原著論文	A10	無電解銅めっき, 化学平衡, 混合錯体
4226	EDTAを錯化剤とする無電解Cuめっきにおける分極特性	水本省三, 縄舟秀美, 松本邦勝, 川崎元雄, 木下朱美, 荒藤原 裕, 榎本英彦	41	9	912	1990	5:原著論文	B03	無電解銅めっき, 混成電位理論, EDTA-Cu()錯体
4227	ピロリン酸浴からのCu-Zn合金めっきにおけるヒステジンの作用機構	園田 司, 杉本 護, 西羅正芳, 縄舟秀美, 水本省三	41	9	917	1990	5:原著論文	B02	Cu-Znめっき, ピロリン酸浴, ヒステジン, 交流インピーダンス
4228	鋼板のリン酸塩処理性に対するリン酸塩処理条件の影響	羽田隆司, 増井 昇, 安藤公一, 米野 実	41	9	922	1990	5:原著論文	B02	リン酸塩処理, Ti添加鋼板
4229	熱拡散表面処理における濃度 - 距離曲線の解析について	桑山健太, 村田康浩, 大西正巳	41	9	927	1990	5:原著論文	B08	熱拡散, 表面処理, 相互拡散係数
4230	Ti合金の引張り強度特性に及ぼすアルミナイジング処理の影響	武井 厚, 石田 章, 小野寺秀博	41	9	931	1990	7:速報論文	B06	Ti合金, 拡散浸透法, アルミナイジング, 引張り強度, 延性
4231	コバルトナフタロシアニン薄膜のカソード・エレクトロクロミズム	志村美知子, 佐藤 潔, 出沼 剛, 志村幸	41	9	936	1990	7:速報論文	A09	コバルトナフタロシアニン, エレクトロクロミズム, 酸素還元
4232	孔食萌芽の生存時間に与える電位と塩化物イオン濃度の影響	坂入正敏, 水流 徹	41	9	938	1990	7:速報論文	B10	孔食, ワイブルプロット, 電流振動
4233	巻頭言:創造とセレンディビティー	本間英夫	41	9	940	1990	7:速報論文	B09	溶射, 防錆, 防食, 封孔
4234	プラズマ溶射の基礎 - 粉粒の加速と加熱	丸尾 大	41	10	949	1990	1:巻頭言	A02	プラズマ溶射, 加熱, 加速
4235	溶射方式	北原 繁	41	10	951	1990	3:解説	A02	溶射方式, フレーム溶射, 爆発溶射, アーク溶射, プラズマ溶射
4236	粉末溶射材料	白井勝之	41	10	957	1990	3:解説	A02	粉末溶射, 溶射材料
4237	溶射皮膜の特性 - 機械的, 化学的, 物理的	清水保雄	41	10	962	1990	3:解説	A02	溶射皮膜, 機械特性, 耐摩耗性, 電気特性
4238	防錆, 防食被覆	石川量大	41	10	968	1990	3:解説	A02	溶射, 防錆, 防食, 封孔
4239			41	10	974	1990	3:解説	A02	

4241	耐摩耗性被覆	原田良夫	41	10	980	1990	3:解説	A02	溶射, 耐摩耗性被覆, 高速ガス炎溶射, 減圧プラズマ溶射, WCプラズマ溶射, ガスタービン, 断熱被覆, シルコニア, 高温腐食, プラズマ溶射, ガスタービン
4242	耐熱性・断熱性被覆	鈴木隆夫・竹田博光	41	10	984	1990	3:解説	A02	傾斜機能材料, 減圧プラズマ溶射
4243	高温耐食被覆	児島慶亨	41	10	988	1990	3:解説	A02	傾斜機能材料, 減圧プラズマ溶射
4244	傾斜機能材料	斉藤 亨・北田三郎・下田信之・古賀正実・知 滝川 浩・大野吉弘・加賀保男・門場昭彦・塚本幸一・内山 太	41	10	992	1990	3:解説	A02	傾斜機能材料, 減圧プラズマ溶射
4245	発電用電極材料	寺本富彦・小野英彦	41	10	996	1990	3:解説	A02	固体酸化物燃料電池, 溶射層, ペロブスカイト酸化物, 機能デバイス
4246	電磁波反応皮膜	堀江 譲	41	10	1000	1990	3:解説	A02	プラズマ溶射, 蛍光発光機能, X線クロミック機能
4247	半導体材料	大森 明・朴 景采	41	10	1004	1990	3:解説	A02	プラズマ溶射, TiO ₂ 皮膜, 電子伝導性, 半導体, 光電気化学的微生物, 光半導体, 殺菌, TiO ₂ , 低温溶射法
4248	光半導体布による微生物の殺菌	桜田 司	41	10	1008	1990	3:解説	A02	減圧プラズマ溶射, 非晶質磁性膜, トルクセンサ
4249	減圧プラズマ溶射によるアモルファス磁性膜の生成	寺本富彦・小野英彦	41	10	1012	1990	3:解説	A02	超伝導皮膜, Y-Ba-Cu酸化物, 溶射
4250	超伝導皮膜	北原 繁	41	10	1017	1990	3:解説	A02	拡散係数, 表面処理, 熱拡散処理
4251	拡散による表面処理と拡散係数	大西正巳・桑山健太・下崎敏唯・若松	41	10	1020	1990	3:解説	A02	XPS, 化学シフト, サテライトピーク, オージェパラメーター
4252	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(13) - X線光電子分光法(XPS)	金野英隆	41	10	1026	1990	9:シリーズ-2	A10	色彩管理, 測色機器, 色差計
4253	シリーズ / 色 - 測色機器による色彩管理	森本晃夫	41	10	1033	1990	9:シリーズ-2	A10	色彩管理, 測色機器, 色差計
4254	シリーズ / くらべてみよう物性値 - バンドギャップ(2)	澤井秀夫	41	10	1038	1990	10:比べてみよう	A10	バンドギャップ
4255	EDTA錯体浴からの無電解Cuめっきの析出機構	水本省三・縄舟秀美・松本邦勝・川崎	41	10	1039	1990	5:原著論文	B03	無電解銅めっき, EDTA-銅()錯体, 析出機構
4256	電析法によるFe-W合金皮膜の非晶質機構の考察	阮永 豊・小若正倫・姚 素薇	41	10	1044	1990	5:原著論文	B02	電気めっき, Fe-W, 非晶質, メカニズム
4257	HCl溶液中の交流エッチングで生ずるアルミニウム表面皮膜の検討	菅沼栄一・丹野裕司・伊藤 武・船越明・松木健三	41	10	1049	1990	5:原著論文	C03	アルミニウム, 交流エッチング, アノード皮膜, エッチ皮膜
4258	アルミニウム陽極酸化皮膜の青色電解着色	石田慎一・伊藤征司・郎	41	10	1054	1990	5:原著論文	B07	アルミニウム, アノード酸化皮膜, 電解着色, 青色着色
4259	屋内汚染物質の測定法の検討	福田芳雄・福島敏郎・夕・フェン・吉原一弘・藤原 純	41	10	1059	1990	5:原著論文	C07	屋内汚染物質, 蓄積速度, 風速, 屋内腐食, 測定法
4260	プリント配線板作製工程における銅めっき過程の光音響的手法によるその場測定	吉原佐知雄・高橋亮二・佐藤栄一	41	10	1065	1990	7:速報論文	B02	銅めっき, 光音響法, プリント配線基板, その場測定
4261	巻頭言: 技術と環境	山田俊幸	41	11	1073	1990	1:巻頭言		
4262	表面処理による耐摩耗性の改善	高谷松文	41	11	1074	1990	3:解説	A10	硬質皮膜, 耐摩耗性
4263	アルミニウムアノード酸化による硬質皮膜の諸特性	富田節夫	41	11	1081	1990	3:解説	B07	アノード酸化皮膜, 硬質陽極酸化, 絶縁破壊電圧, 耐摩耗性
4264	硬質アルミニウムめっきによる耐摩耗性皮膜の形成	興水 勲	41	11	1087	1990	3:解説	B02	硬質アルミニウムめっき, 耐摩耗性, コンポジットめっき
4265	コンポジットめっきによる耐摩耗性皮膜の形成	黒澤一吉	41	11	1094	1990	3:解説	B02	コンポジットめっき, 耐摩耗性, 密着性
4266	無電解コンポジットめっきの耐摩耗性	豊田 稔	41	11	1101	1990	3:解説	B03	無電解ニッケルめっき, コンポジットめっき, 耐摩耗性
4267	塗膜の硬度と耐摩耗性	田中正一	41	11	1105	1990	3:解説	A05	塗膜, 硬度, 耐摩耗性
4268	溶射による耐摩耗性皮膜	工藤唯輔	41	11	1117	1990	3:解説	A02	溶射, 耐摩耗性被覆, 高速ガス炎溶射, 減圧プラズマ溶射, WCイオン注入, TiN, PVD, イオンレーティング, 硬質皮膜
4269	PVDによる耐摩耗性皮膜の形成	大石政治	41	11	1125	1990	3:解説	A01	溶射, 耐摩耗性被覆, 高速ガス炎溶射, 減圧プラズマ溶射, WCイオン注入, TiN, PVD, イオンレーティング, 硬質皮膜
4270	CVDコーティングによる硬質膜の形成とその用途	佐々木恒	41	11	1133	1990	3:解説	B01	CVD, 硬質膜, 切削工具
4271	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(14) - 超音波スペクトロスコピーによる材料表面の評価	成田敏夫	41	11	1141	1990	9:シリーズ-2	A10	超音波スペクトロスコピー, 材料表面評価
4272	めっきによる黒色化	古賀孝昭	41	11	1148	1990	9:シリーズ-2	B02	めっき, 黒色化
4273	プラズマ・イオンプロセス技術と新素材 - 新しいFeS ₂ 非晶質合金	松原覚衛	41	11	1150	1990	12:武井記念シリーズ	A01	Pl - プラズマ, クラスタイオンビーム, 薄膜, 非晶質合金
4274	シリーズ / くらべてみよう物性値 - 超伝導	井手本康	41	11	1157	1990	10:比べてみよう	A10	超伝導体, 臨界温度
4275	アミノシラン処理ガラス上への無電解Niめっき - 次亜リン酸ソーダによる前処理の対極に金属モリブデンを使用した非水溶媒中からの硫化モリブデンの電析	浜谷健生・熊谷八百三	41	11	1159	1990	5:原著論文	B03	無電解めっき, ガラスベース, パラジウム, 次亜リン酸
4276	La-Ni系合金スパッタ膜の構造・水素吸蔵特性	中村豊久	41	11	1163	1990	5:原著論文	B02	非水溶媒, 硫化モリブデン, 電析, DMF
4277	アルカリ溶液中におけるガリウム - ヒ素合金電着	釜崎清治・亀井 健・那須勇樹	41	11	1168	1990	5:原著論文	A01	La-Ni合金, スパッタ膜, 水素吸蔵合金
4278	非シアン銀浴の可能性に関する研究	張 時性・沼田博雄・大野 潔・春山志郎	41	11	1174	1990	5:原著論文	B02	電析, ガリウム-ヒ素合金, アルカリ溶液
4279	高分解能電子顕微鏡によるアルミアノード酸化皮膜の構造と電子線照射による結晶化過程の観察	井上博之・山川宏二・近藤哲也・正木小野幸子・市野瀬英喜・川口朋子・増子昇	41	11	1178	1990	5:原著論文	B02	銀めっき, 置換析出, 部分分極曲線, 非シアン銀めっき浴
4280	熱交換器用塗装アルミフィンの親水性と耐食性	喜川口朋子・増子昇	41	11	1181	1990	5:原著論文	B07	アルミニウム, アノード酸化皮膜, 結晶化, 電子照射, 高分解能TEM
4281	Ni部分めっきのインライン同期化	広前義孝・倉田正裕・小林美智男・斉大見裕司・小倉 健・山田信彦・山本 守・竹中 修	41	11	1187	1990	5:原著論文	A05	アルミニウム, 塗装, フィン, 耐食性, 親水性
4282	乾式物理現象におけるAg核の活性	藤原真人・川尻和広	41	11	1192	1990	6:技術論文	B02	同期化, インラインめっき, 部分めっき, 高速めっき, Niめっき
4283	Al-Mn系合金の陽極酸化皮膜の遠赤外線放射特性	藤原真人・川尻和広	41	11	1197	1990	13:研究ノート	A10	銀核, 乾式物理現象
4284	各種C化合物及びダイヤモンドと溶融Cu-Sn合金との濡れ性	前嶋正受・松尾 守・猿渡光一・石禾和夫・島上誠司・福田洋一・久田栄一・沖 猛・戸嶋茂郎・水流 徹・春山志郎・中川善隆・広瀬祐輔	41	11	1200	1990	7:速報論文	B07	Al-Mn系合金, アノード酸化, 多孔質構造, 遠赤外線放射特性
4285	モデルセルを用いたメタノール溶液中での鉄の局部腐食の研究	猿渡光一・石禾和夫・島上誠司・福田洋一・久田栄一・沖 猛・戸嶋茂郎・水流 徹・春山志郎・中川善隆・広瀬祐輔	41	11	1202	1990	7:速報論文	B01	濡れ性, 炭化物, CVDダイヤモンド, 溶融Cu-Sn合金
4286	巻頭言: 40周年記念号発刊にあたって	増子 昇	41	12	1215	1990	1:巻頭言	*	局部腐食, 鉄, メタノール, モデルセル
4287	創立40周年に寄せて	浅原照三・川崎元雄	41	12	1216	1990	1:巻頭言	*	

4289	座談会 - (1)協会の創立から現在まで - 協会の歴史を語る	武井 武, 今井 昇, 川崎元雄, 岸 松平, 長坂秀雄, 岸 富也, 尾形幹夫, 二瓶公志, 岡村寿郎, 海老原延郎, 後藤文男, 澤井秀夫, 新藤芳雄	41	12	1218	1990	21:座談会	*	*
4290	座談会 - (2)エレクトロニクスと表面処理	尾形幹夫, 二瓶公志, 岡村寿郎, 海老原延郎, 後藤文男, 澤井秀夫, 新藤芳雄	41	12	1232	1990	21:座談会	*	*
4291	表面技術のパラダイム - 今後の表面技術はいかにあるべきか	村川享男	41	12	1244	1990	20:随想	*	*
4292	表面科学における最近の進歩	本間禎一	41	12	1250	1990	20:随想	*	*
4293	表面技術協会に期待する	兼松秀行, 小岩一郎, 佐倉康男, 佐藤登, 松岡政夫	41	12	1255	1990	20:随想	*	*
4294	表面技術協会創立40周年記念報告	増子 昇	41	12	1259	1990	20:随想	*	*
4295	(金属)表面技術協会の歩み - 年表と解説	鈴木六郎	41	12	1260	1990	20:随想	*	*
4296	表面技術協会の40年を顧みる	今井 昇	41	12	1263	1990	20:随想	*	*
4297	成膜技術 - 電気めっき - Cu, Ni, Crめっき	広瀬祐輔	41	12	1265	1990	4:技術解説	*	銅, ニッケル, クロムめっき
4298	成膜技術 - 電気めっき - Zn, Cd, Sn, Pbめっき	安谷屋武志	41	12	1266	1990	4:技術解説	*	亜鉛, カドミウム, ずす, 鉛めっき
4299	成膜技術 - 電気めっき - 貴金属めっき	斉藤いほえ	41	12	1268	1990	4:技術解説	*	貴金属めっき
4300	成膜技術 - 電気めっき - 合金めっき	渡辺 徹	41	12	1270	1990	4:技術解説	*	合金めっき
4301	成膜技術 - 電気めっき - 複合めっき	古川直治	41	12	1272	1990	4:技術解説	*	複合めっき
4302	成膜技術 - 電気めっき - 機能めっき	尾形幹夫	41	12	1274	1990	4:技術解説	*	機能めっき
4303	成膜技術 - 電気めっき - 特殊めっき	山下嗣人	41	12	1276	1990	4:技術解説	*	特殊めっき
4304	成膜技術 - 電気めっき - 非水, その他	武井たつ子	41	12	1278	1990	4:技術解説	*	非水めっき
4305	無電解めっき - 無電解銅めっき	松岡政夫	41	12	1280	1990	4:技術解説	*	無電解めっき, 銅めっき
4306	無電解めっき - Ni系及びCo系めっき	澤井秀夫, 小岩一郎	41	12	1282	1990	4:技術解説	*	無電解めっき, ニッケル, コバルトめっき
4307	無電解めっき - 異金属及び他のめっき	縄舟秀美	41	12	1283	1990	4:技術解説	*	無電解めっき, 貴金属めっき
4308	溶融めっき	杉本正威	41	12	1284	1990	4:技術解説	*	溶融めっき
4309	PVD(物理的蒸着法) - 真空蒸着	大工原茂樹	41	12	1286	1990	4:技術解説	*	PVD, 真空蒸着
4310	PVD(物理的蒸着法) - イオンプレーティング	稲川幸之助	41	12	1287	1990	4:技術解説	*	PVD, イオンプレーティング
4311	PVD(物理的蒸着法) - スパッタリング	細川直吉	41	12	1287	1990	4:技術解説	*	PVD, スパッタリング
4312	PVD(物理的蒸着法) - 金属MBE	山本良一	41	12	1289	1990	4:技術解説	*	PVD, 金属, MBA
4313	PVD(物理的蒸着法) - 半導体MBE	吉田貞史	41	12	1289	1990	4:技術解説	*	PVD, 半導体, MBA
4314	CVD(化学的蒸着法) - 熱CVD	伊藤 滋	41	12	1290	1990	4:技術解説	*	熱, CVD
4315	CVD(化学的蒸着法) - プラズマCVD	高井 治	41	12	1291	1990	4:技術解説	*	プラズマ, CVD
4316	CVD(化学的蒸着法) - 光CVD	鹿田順生	41	12	1292	1990	4:技術解説	*	光, CVD
4317	CVD(化学的蒸着法) - MOCVD	徳田博邦	41	12	1293	1990	4:技術解説	*	MOCVD
4318	CVD(化学的蒸着法) - プラズマ重合	山内 健, 長田義仁	41	12	1294	1990	4:技術解説	*	プラズマ重合
4319	溶射 - RFプラズマ溶射	朝日直達	41	12	1295	1990	4:技術解説	*	溶射, RFプラズマ溶射
4320	溶射 - 減圧雰囲気プラズマ溶射	朝日直達	41	12	1295	1990	4:技術解説	*	減圧, プラズマ溶射
4321	溶射 - 超高速フレーム溶射	朝日直達	41	12	1295	1990	4:技術解説	*	超高速, プラズマ溶射
4322	溶射 - 一般溶射	朝日直達	41	12	1295	1990	4:技術解説	*	溶射
4323	陽極酸化, 化成処理 - 陽極酸化 - アルミニウム陽極酸化	平山良夫	41	12	1297	1990	4:技術解説	*	陽極酸化, アルミニウム
4324	陽極酸化, 化成処理 - 陽極酸化 - チタン, その他陽極酸化	伊藤征司郎	41	12	1299	1990	4:技術解説	*	陽極酸化, チタン
4325	陽極酸化, 化成処理 - 着色処理	斉藤勝士	41	12	1300	1990	4:技術解説	*	陽極酸化, 着色処理
4326	陽極酸化, 化成処理 - 化成処理	斉藤ともみ	41	12	1301	1990	4:技術解説	*	化成処理
4327	陽極酸化, 化成処理 - 電解クロメート処理	近藤嘉一	41	12	1302	1990	4:技術解説	*	電解クロメート処理
4328	有機質被覆 - 粉体塗装	岩城拓也	41	12	1303	1990	4:技術解説	*	粉体塗装
4329	有機質被覆 - 電着塗装	土谷義治	41	12	1305	1990	4:技術解説	*	電着塗装
4330	有機質被覆 - 高密度エネルギービームによる有機皮膜の硬化システム	後藤弘明	41	12	1306	1990	4:技術解説	*	エネルギービーム, 有機皮膜, 硬化
4331	有機質被覆 - 重防食塗覆法(一般的ライニングを含む)	吉田耕太郎	41	12	1307	1990	4:技術解説	*	防食塗膜, ライニング
4332	表面改質 - イオン注入	寺島慶一	41	12	1308	1990	4:技術解説	*	表面改質, イオン注入
4333	表面改質 - ダイナミックミキシング	佐藤 守	41	12	1309	1990	4:技術解説	*	表面改質, ダイナミックミキシング
4334	表面改質 - レーザー	佐藤卓蔵	41	12	1310	1990	4:技術解説	*	表面改質, レーザー
4335	表面改質 - 表面硬化 - 窒化	浦尾亮一	41	12	1311	1990	4:技術解説	*	表面硬化, 窒化
4336	表面改質 - 表面硬化 - 炭化	寺門一佳	41	12	1313	1990	4:技術解説	*	表面硬化, 炭化
4337	表面改質 - 表面硬化 - 浸炭	寺門一佳	41	12	1313	1990	4:技術解説	*	表面硬化
4338	表面改質 - 拡散浸透処理	武井 厚	41	12	1314	1990	4:技術解説	*	表面改質, 拡散浸透処理
4339	エッチング - ウェットエッチング	加藤凡典	41	12	1315	1990	4:技術解説	*	湿式エッチング
4340	エッチング - ドライエッチング	阿部東彦, 米田昌弘	41	12	1316	1990	4:技術解説	*	乾式エッチング
4341	研磨 - 機械的表面仕上げ	植木正義	41	12	1318	1990	4:技術解説	*	研磨, 機械的
4342	研磨 - 電解表面仕上げ	松本誠臣	41	12	1319	1990	4:技術解説	*	研磨, 電解仕上げ
4343	表面処理材の耐食性, 評価技術 - 表面処理材の耐食性	今井八郎	41	12	1320	1990	4:技術解説	*	表面処理剤, 耐食性
4344	表面処理材の耐食性, 評価技術 - 評価技術	福本幸男	41	12	1321	1990	4:技術解説	*	評価技術
4345	表面分析	前田重義	41	12	1322	1990	4:技術解説	*	表面分析
4346	FA化による表面処理技術の自動化	松村宗順	41	12	1324	1990	4:技術解説	*	FA化, 表面処理技術, 自動化
4347	トピックス - 超伝導膜 - 湿式超伝導膜	小浦延幸	41	12	1327	1990	4:技術解説	*	湿式, 超伝導膜
4348	トピックス - 超伝導膜 - 乾式超伝導膜	舘沢 朗	41	12	1328	1990	4:技術解説	*	乾式, 超伝導膜
4349	トピックス - ダイヤモンド膜	佐藤洋一郎	41	12	1329	1990	4:技術解説	*	ダイヤモンド膜
4350	トピックス - 選択透過膜	黒田孝一	41	12	1329	1990	4:技術解説	*	選択透過膜
4351	トピックス - 機能分子による電極表面修飾	渡辺 正	41	12	1330	1990	4:技術解説	*	電極表面修飾, 機能分子
4352	トピックス - ホットスタンピング	佐藤英明	41	12	1330	1990	4:技術解説	*	ホットスタンピング
4353	トピックス - 表面析出	吉原一紘	41	12	1331	1990	4:技術解説	*	表面析出
4354	トピックス - ソルゲルコーティング	和田健二	41	12	1331	1990	4:技術解説	*	ソルゲルコーティング
4355	トピックス - 乾式着色処理	柏木邦彦	41	12	1332	1990	4:技術解説	*	乾式着色
4356	トピックス - 生体材料(生体適合材料)	箕浦憲彦	41	12	1332	1990	4:技術解説	*	生体材料
4357	トピックス - 超微粒子	大野 悟	41	12	1333	1990	4:技術解説	*	超微粒子
4358	トピックス - 表示材料 - ルミネッセンス, エレクトロクロミック	馬場宣良, 吉野隆子	41	12	1334	1990	4:技術解説	*	表示材料, EL, EC
4359	トピックス - 電極材料 - 表面処理に用いられるアノード材料	川嶋幸雄, 大江一英	41	12	1335	1990	4:技術解説	*	電極材料, アノード材料
4360	トピックス - アート	黒田孝一	41	12	1335	1990	4:技術解説	*	アート

4361	トピックス - 磁気メモリー	後藤文男	41	12	1336	1990	4:技術解説	*	磁気メモリー
4362	トピックス - 電子材料	山田啓作	41	12	1336	1990	4:技術解説	*	電子材料
4363	トピックス - In-Situ-STM	板谷謹悟	41	12	1337	1990	4:技術解説	*	STM, その場測定
4364	巻頭言: 材料開発の社会性	山本維行	42	1	1	1991	1:巻頭言	その他	リサイクル、環境
4365	電磁波ノイズの影響と規制の現状	大津 陽	42	1	2	1991	2:総説	その他	電磁波シールド、電磁遮蔽
4366	ビルディングの電磁波シールド対策	岩井善弘	42	1	13	1991	2:総説	その他	電磁波シールド
4367	導電性塗料による電磁波シールド	板野俊明	42	1	22	1991	3:解説	塗布、塗装	電磁波シールド、電磁遮蔽、塗 装、塗布、塗膜
4368	真空蒸着による電磁波シールド	元木 詮	42	1	29	1991	3:解説	物理蒸着	電磁波シールド、電磁遮蔽、蒸 着、アルミニウム
4369	無電解めっき法による電磁波シールド	中村憲二	42	1	33	1991	3:解説	無電解めっき	電磁波シールド、電磁遮蔽、無 電解めっき、ニッケル、銅
4370	片面無電解めっき法による電磁波シールド	斉藤 誠	42	1	39	1991	3:解説	無電解めっき	電磁波シールド、電磁遮蔽、無 電解めっき、ニッケル、銅
4371	複合磁性材料による磁気シールド	岡本昌文	42	1	44	1991	3:解説	その他	電磁遮蔽、電磁波シールド、電 磁鋼板、非晶質
4372	磁気シールド材としての電解鉄箔の用途	鴨井新生	42	1	50	1991	3:解説	その他	電磁遮蔽、電磁波シールド、Fe、 電解鉄箔
4373	低温プラズマプロセスによるイオン導電性 薄膜層の形成	小久見善八内本喜 晴竹原善一郎	42	1	57	1991	3:解説	物理蒸着	導電膜、プラズマ
4374	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態 の解析(15) - アトムプローブFIM	植森龍治 森川博文	42	1	62	1991	4:技術解説	その他	アトムプローブ電解イオン顕微鏡
4375	シリーズ / 色 - 化成処理による黒色化	小泉宗栄	42	1	68	1991	17:講座	化成処理	化成処理、クロメート処理
4376	シリーズ / めっき工場の経営管理技術(1) - 人材育成の原点 - 先ずは納得と感動を	佐藤光治 岡田義 夫 小山 登 三好重	42	1	73	1991	17:講座	その他	改善(改良)、管理、環境
4377	シリーズ / くらべてみよう物性値 - 超伝導 Ni - P - SiC: Ni - P - Diamond複合皮膜	井手本康 恩田時伯 岡安憲 之 吉原佐知雄 佐	42	1	78	1991	10:比べてみよう	その他	超伝導体、臨界温度、酸化物 複合皮膜、無電解めっき、イン ピーダンス解析、ニッケル、SiC
4378	の無電解めっきに対するインピーダンス解 析の非晶質Cr - C皮膜の作製	西羅正芳 山岸憲 史 杉本 護	42	1	79	1991	5:原著論文	無電解めっき	複合皮膜、SiC、磨耗
4379	SiC複合めっきの磨耗特性におけるマト リックスの効果	蘇 建堂 興戸正純 冲 猛雄	42	1	84	1991	5:原著論文	電気めっき	塗装鋼板、劣化挙動、インピーダ ンス測定、塗装ふくれ
4380	定電位分極下における塗装鋼板の劣化挙 動とインピーダンス特性	森河 務 横井昌幸 江口晴一郎 福本幸	42	1	89	1991	5:原著論文	塗布、塗装	クロム、ESCA、カーボン、カルボ ン酸塩
4381	硫酸クロム(III) - カルボン酸塩浴からのCr - C合金めっき皮膜の作製	森河 務 横井昌幸 江口晴一郎 福本幸	42	1	95	1991	5:原著論文	電気めっき	クロム、カーボン、非晶質、結晶 構造、析出機構
4382	硫酸クロム(III) - シュウ酸アンモニウム浴 からの非晶質Cr - C皮膜の作製	津留 豊田代修一 田中辰臣 細川邦典	42	1	100	1991	5:原著論文	電気めっき	電気めっき、電流 密度曲線
4383	ニッケル合金めっき皮膜の組成に 及ぼす電極電位の影響	老田昌弘 本城克彦	42	1	105	1991	5:原著論文	無電解めっき	銅、分極曲線、電子線回折、混 成電位論
4384	無電解銅めっき液の分極挙動と析出物の 電子線解析	藤田浩紀 新井 透	42	1	111	1991	5:原著論文	熱処理	炭化皮膜、バナジウム、ニオブ、 クロム、表面改質
4385	V、NbまたはCrを含む溶融ホウ砂浴中へ の二回浸せきで鋼に形成された2層炭化	清水健一 小林賢 三 G.E.Thompson G C.Wood	42	1	116	1991	5:原著論文	無電解めっき	透過電子顕微鏡、無電解めっ き、ニッケル、リン、アモルファス
4386	高分解能透過電子顕微鏡によるNi - P めっき膜の観察	松田好晴 藤井俊 茂 吉本信子 森田 昌行 芳賀正記	42	1	122	1991	5:原著論文	電気めっき	ジスプロシウム、鉄、有機電解、 パルス、アモルファス
4387	有機電解浴からのDy - Fe電析挙動	入江晃士 竹林恭 志 三浦育子 吉原 佐知雄 佐藤栄一 滝沢貴久 男 中山住 則 小平隆志 黒河 圭子	42	1	127	1991	7:速報論文	無電解めっき	光、音響分光法、無電解めっき、 ニッケル、硼素
4388	無電解めっき過程のPASによるIn-Situ観 測	小野幸子 馬場宣 良 増子 昇 浦尾亮一 近藤隆明 金丸辰也 保母芳彦 橋高敏晴	42	1	129	1991	7:速報論文	拡散皮膜	ステンレス鋼、応力腐食割れ、塩 化物、硫化マンガン、溶体化処 理
4389	クロム拡散被覆ステンレス鋼の耐孔食性	小野幸子 馬場宣 良 増子 昇	42	1	131	1991	7:速報論文	アノード酸化	アルミニウム、陽極酸化法、孔 径、セル径、電子顕微鏡
4390	アルミニウムアノード酸化皮膜の孔径とセル 径	近藤隆明 金丸辰也 保母芳彦 橋高敏晴	42	1	133	1991	7:速報論文	その他	表面物性評価技術 - 表面状態 の解析(16) - 走査型内部光電子放出 シリーズ / くらべてみよう物性値 - イオン 半径(1)
4391	巻頭言: 表団協に思う	麻川健一 吉田 誠	42	2	143	1991	1:巻頭言	その他	表団協セミナー
4392	溶融めっきの現状と動向	中村 一郎	42	2	144	1991	3:解説	溶融めっき	防錆鋼板
4393	溶融亜鉛めっき鋼板	金野英隆 古市隆三 郎	42	2	152	1991	3:解説	溶融めっき	合金化反応、耐食性、溶接性
4394	溶融Zn - Al合金めっき鋼板	内田淳一 渋谷敦 義 津田哲明 山本 康博 瀬戸宏久	42	2	160	1991	3:解説	溶融めっき	鋼板、大気暴露性、合金状態図
4395	溶融Alめっき鋼板	大澤伸夫 福岡 潔 田部善一 近藤哲也 政木征 史 井上博之 山川 松岡秀樹 橋本 哲 影 近 博	42	2	169	1991	3:解説	溶融めっき	鋼板、マフラー、耐候性、耐熱性
4396	ターンめっき鋼板	麻川健一 吉田 誠	42	2	178	1991	3:解説	溶融めっき	ターンめっき、プレニッケルめっ き、ガソリタンク
4397	構造物溶融亜鉛めっき	中村 一郎	42	2	186	1991	3:解説	溶融めっき	鋼板、機械的性質、脆性、建材、 工程
4398	活性元素を用いた表面処理による合金の 耐高温酸化性の向上	金野英隆 古市隆三 郎	42	2	193	1991	2:総説	電気めっき	活性元素、高温酸化、酸化物 層、カソード皮膜
4399	溶融塩電解法によるAl - Mn合金めっき	内田淳一 渋谷敦 義 津田哲明 山本 康博 瀬戸宏久	42	2	200	1991	3:解説	溶融めっき	溶融塩めっき、アモルファス、非 水浴
4400	シリーズ / 色 - 塗装による黒色化	武田一宏	42	2	206	1991	9:シリーズ-2	塗装	黒色化、電着塗装、静電塗装、 ロールコート塗装
4401	シリーズ / めっき工場の経営管理技術(2) - めっきの原価計算	秦 暢幸	42	2	208	1991	9:シリーズ-2	電気めっき	原価管理、治具、不良
4402	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態 の解析(16) - 走査型内部光電子放出 シリーズ / くらべてみよう物性値 - イオン 半径(1)	奥村次徳 塩島謙次	42	2	215	1991	9:シリーズ-2	その他	内部光電子、半導体界面、顕微 鏡
4403	アノード定電流電解エッチングによる粗面 化形態に及ぼすアルミニウム中の銅元素	伊藤 滋	42	2	220	1991	10:比べてみよう	その他	イオン半径、配位数、低スピン状 態、高スピン状態
4404	オキシンを含むリン酸塩溶液中でのアノ ード酸化によるアルミニウムの防食効果	世利修美	42	2	221	1991	6:技術論文	電解エッチング	P S版用アルミ、Cu、分極曲線、 ピット
4405	アノード酸化アルミナメンブレンの等電点 前後のイオン透過	箕輪恵美子 小林史 郎 伊藤雅彦 泉谷 雅清	42	2	226	1991	5:原著論文	アノード酸化	リン酸塩溶液、酸化溶解特性、p H
4406	エッチング開始直後のエッチピットの成長 挙動	黒田孝一	42	2	232	1991	5:原著論文	アノード酸化	等電点、染料、イオン透過
4407	メタンスルホン酸銀 - ヨウ化カリウム浴か らの銀めっき	大澤伸夫 福岡 潔 田部善一 近藤哲也 政木征 史 井上博之 山川 松岡秀樹 橋本 哲 影 近 博	42	2	236	1991	5:原著論文	電解エッチング	コンデンサ、Al、定電流電解、定 電位電解
4408	アルモルファスW03 - TiO3薄膜を用いたE C素子の寿命	松岡秀樹 橋本 哲 影 近 博	42	2	241	1991	5:原著論文	その他	銀、電気めっき、非シアン浴、は んだ付け性、HBPSA
4409	不溶性アノードを用いたFeめっきにおけ るFe3+の還元反応の高速化	松岡秀樹 橋本 哲 影 近 博	42	2	246	1991	5:原著論文	化学蒸着	アモルファス、エレクトロクロミ ム、発色特性、X線回折、SEM
4410	不溶性アノードを用いたFeめっきにおけ るFe3+の還元反応の高速化	松原茂雄 小見 崇	42	2	253	1991	5:原著論文	電気めっき	鉄、電気めっき、アニオン交換 膜、隔膜電解、高速化
4411	有機電解液からのイットリウムの電析挙動	松田好晴 今橋健 二 吉本信子 森田 昌行 芳賀正記	42	2	258	1991	7:速報論文	電気めっき	電気めっき、非晶質、ニッケル、 モリブデン、熱処理

4412	コバルト・ナフタロシアニンのエレクトロクロミズムを利用した微量酸素の定量	志村美知子・奥村次徳・小沢欣一・志村幸雄	42	2	260	1991	7:速報論文	電気めっき	エレクトロクロミズム、溶存酸素計
4413	無電解Pd-P合金めっき皮膜のはんだ付け性及び接触抵抗	芳賀正記・内田 衛・水本省三・縄舟秀美	42	2	262	1991	7:速報論文	無電解めっき	次亜リン酸塩、還元剤、はんだ付け性、接触抵抗、無電解めっき
4414	巻頭言:特集「湿式法による磁気記録媒体」に寄せて	逢坂哲彌	42	3	271	1991	1:巻頭言	その他	湿式法、小型薄膜ディスク
4415	無電解めっき磁気記録媒体開発秘話	永尾守正	42	3	273	1991	3:解説	無電解めっき	磁気ディスク、磁気ディスク媒体、薄膜ディスク、無電解めっきコバルト、無電解めっき、めっき速度、磁気特性
4416	無電解Co長手記録媒体	鷹野 修	42	3	278	1991	3:解説	無電解めっき	コバルト、無電解めっき、垂直記録媒体、合金
4417	無電解Co合金めっき垂直磁気記録媒体	逢坂哲彌・本間敬之	42	3	283	1991	3:解説	無電解めっき	電解析出、アルマイト、磁気記録媒体、ポア径、充てん率
4418	アルマイト垂直磁気記録媒体	荒井賢一・姜 熙雨・石山和志	42	3	291	1991	3:解説	アノード酸化	ニッケル、無電解めっき、非晶質構造、非磁性皮膜、錯体
4419	ハードディスク基板の下地処理 - 無電解ニッケル-リンめっき浴	沼沢 潔・武居義政・渡辺賢治	42	3	297	1991	3:解説	無電解めっき	ハードディスク装置、無電解めっき、Ni、製造システム
4420	めっきディスク製造システム - 下地めっき装置を中心に	中山郁雄	42	3	303	1991	3:解説	無電解めっき	ニッケル、無電解めっき、磁気ハードディスク、Al、前処理
4421	磁気ディスク用無電解ニッケル-リン皮膜に及ぼす前処理の効果	米光 誠・池田 洋	42	3	323	1991	5:原著論文	無電解めっき	無電解めっき、ハードディスク
4422	無電解めっき小型磁気ディスクの高密度化	長坂英昭・道盛 徹・竹野 博	42	3	328	1991	5:原著論文	無電解めっき	無電解めっき、Co、P、テクスチャー処理、磁気特性、微細構造
4423	テクスチャー処理基板上に成膜した無電解CoP薄膜媒体の磁気特性と微細構造	逢坂哲彌・本間敬之・井上克己・浅井弘紀・飯塚博夫・吉野 浩・後藤文男	42	3	334	1991	5:原著論文	無電解めっき	磁気記録、無電解めっき、媒体ノイズ
4424	めっき型磁気ディスクの微細構造と媒体ノイズ	松永俊樹・金子 衛・宮本幸博・田上 満・富田 猛	42	3	339	1991	5:原著論文	無電解めっき	磁気特性、無電解めっき、コバルト、合金、薄膜媒体
4425	力性アルカリ性無電解コバルト合金めっき浴の吸収特性と皮膜磁性	後藤文男・山本武彦・増田則男・逢坂	42	3	345	1991	5:原著論文	無電解めっき	無電解めっき、粉体、伝導体、顔料
4426	無電解めっき法による金属被覆粉体の製造技術の開発	川上 浩・竹下淳一	42	3	308	1991	3:解説	無電解めっき	人手不足、省力化、OJT、外国人労働者
4427	シリーズ/めっき工場の経営管理技術(3) - 人手不足とその対策	吉川弘二	42	3	314	1991	9:シリーズ-2	その他	イオン半径、イオン価数、置換、機能性改善
4428	シリーズ/くらべてみよう物性値 - イオン半径(2)	伊藤 滋	42	3	319	1991	10:比べてみよう	その他	アルミニウム、黒色化、電解着色法、有機染色、含浸
4429	シリーズ/色 - 陽極酸化による黒色化	平山良夫	42	3	320	1991	9:シリーズ-2	アノード酸化	複合化、融合化、複合材料、機能材料
4430	巻頭言:技術の複合化と融合化	大久保敬吾	42	4	363	1991	1:巻頭言	その他	洗浄、環境、溶剤、界面活性剤、フロン
4431	脱脂洗浄の動向	辻 薦	42	4	364	1991	2:総説	洗浄	有機溶剤、フロン、塩素系洗浄剤、PAFT
4432	有機溶剤系洗浄剤	北村健郎	42	4	369	1991	3:解説	洗浄	水系洗浄剤、エマルジョン洗浄剤、酸性洗浄剤、アルカリ性洗浄剤
4433	水系洗浄剤	天田 徹	42	4	375	1991	3:解説	洗浄	電解洗浄、陰極電解洗浄、PR電解洗浄、電解酸洗い、水素せい
4434	電解洗浄技術	斎藤 斉	42	4	380	1991	3:解説	洗浄	超音波洗浄、精密洗浄、ガラス、超純水、周波数
4435	超音波洗浄技術	佐藤昭八郎	42	4	384	1991	3:解説	洗浄	溶剤洗浄、真空式洗浄法、溶剤積層板、耐熱性、耐久性、ビニル系樹脂
4436	真空式洗浄技術	野寺克巳	42	4	389	1991	3:解説	洗浄	走査型トンネル顕微鏡
4437	プラスチック・金属積層材における金属・樹脂相互作用	松坂菊生	42	4	394	1991	3:解説	その他	東南アジア、めっき技術、環境管理、品質管理
4438	シリーズ/表面物性評価技術 - 表面状態の解析(17) - SXMによる表面・表層の評	金子礼三	42	4	400	1991	9:シリーズ-2	表面分析	ドライブプロセス、着色、イオンレーティング、PVD
4439	シリーズ/めっき工場の経営管理技術(4) - 最近の東南アジアのめっき技術	矢部 賢	42	4	404	1991	9:シリーズ-2	電気めっき	イオン半径
4440	シリーズ/色 - ドライブプロセスによる黒色化	*	42	4	410	1991	9:シリーズ-2	その他	塗膜、インピーダンス特性、劣化挙動、コイル・コイル線図
4441	シリーズ/くらべてみよう物性値 - イオン半径(3)	伊藤 滋	42	4	411	1991	10:比べてみよう	その他	一次電流分布、連続めっき、縦型槽、電流密度分布
4442	定電流分極下における塗装鋼板の劣化挙動とインピーダンス特性	蘇 建堂・興戸正純・沖 猛雄	42	4	413	1991	5:原著論文	塗装	無電解めっき、銅、ジビリジル、混成電位、電子線解析
4443	縦型連続電気めっき層における1次電流分布	津田哲明・水本雅也・矢川敦久	42	4	419	1991	5:原著論文	電気めっき	陽極酸化、イオンレーティング、アルミニウム、チタン、鋼板
4444	無電解銅めっきの分極特性と析出物に対するジビリジルの影響	老田昌弘・本城克彦	42	4	425	1991	5:原著論文	無電解めっき	アルミニウム、エッチング、ビット発生数、ビット成長速度、ビットサ
4445	Al/Ti二層めっき鋼板の陽極酸化特性	安江良彦・影近 博	42	4	431	1991	5:原著論文	アノード酸化	電気めっき、非晶質、ニッケル、モリブデン、熱処理
4446	直流エッチング時のエッチピットの成長挙動	大澤伸夫・福岡 潔・田部善一	42	4	437	1991	5:原著論文	電解エッチング	超伝導、エレクトロニクス、マイクサナー効果
4447	電解Ni-Mo非晶質合金皮膜の熱処理による結晶化に伴う物性の変化	袁 宝林・小若正倫	42	4	441	1991	7:速報論文	電気めっき	分子線エビタキシー、エビタキシャル膜、XPS、RHEED
4448	巻頭言:「ナ」への誘い	河村敏孝	42	5	463	1991	1:巻頭言	その他	超伝導、Y、Bi、線材、デバイス
4449	超伝導薄膜に何が期待できか	岡部洋一	42	5	464	1991	3:解説	その他	レーザアブリケーション、超伝導
4450	MBE法による超伝導薄膜の作製とキャラクタリゼーション	鯉沼秀臣・永田裕俊	42	5	467	1991	3:解説	その他	スパッタ蒸着、超伝導、Y系超光子膜
4451	CVD法による超伝導薄膜の作製	青木伸哉・山口太一・河野 幸	42	5	473	1991	3:解説	化学蒸着	ECRマイクロ波プラズマ、
4452	レーザーアブリケーション法による超伝導薄膜の作製	松本卓也・川合知二・河合七雄	42	5	479	1991	3:解説	その他	蒸発、反応、堆積、酸化物超伝導
4453	スパッター法による酸化物超伝導薄膜の作製	中村恵吉	42	5	486	1991	3:解説	その他	Y、Bi、塗布熱分解法、超伝導
4454	バイアス印加ECRプラズマ酸化法による超伝導薄膜の処理技術	作田 健・小林 猛	42	5	491	1991	3:解説	その他	電着機構、酸化物超伝導、各種形状、各種素材
4455	熱プラズマフラッシュ蒸発法による超伝導薄膜の作製	寺嶋和夫・吉田豊信	42	5	496	1991	3:解説	その他	高温超伝導膜、YBa ₂ Cu ₃ O _{7-x} 膜、溶射
4456	塗布熱分解法による超伝導膜の作製	熊谷俊弥・真部高明・水田 進	42	5	500	1991	3:解説	塗布	
4457	泳動電着法を応用した各種形状の各種基材上への酸化物超伝導体の作製	小浦延幸・荘司浩雅	42	5	508	1991	3:解説	泳動電着	
4458	溶射による高温超伝導薄膜の作製	真保幸雄	42	5	514	1991	3:解説	溶射	

4459	シリーズ/表面物性評価技術 - 表面状態の解析(18) - 電子EXAFS	藤川高志	42	5	519	1991	9:シリーズ-2	電気めっき	EXAFS, EELS, 表面構造解析
4460	シリーズ/めっき工場の経営管理技術(5) - めっきの自動化の考え方	高木誠治	42	5	524	1991	9:シリーズ-2	電気めっき	液管理, FA化, 治具
4461	シリーズ/色 - めっき金色化	小林道雄	42	5	528	1991	9:シリーズ-2	電気めっき	電気めっき, 金, 銅, 合金めっき, 浴組成
4462	新たに制定された無電解Cuめっき規格	豊永 実	42	5	531	1991	14:データ	無電解めっき	規格, プリント基板, アディティブ
4463	シリーズ/くらべてみよう物性値 - 格子常反磁性イオンプレーティングによる配向性AIN薄膜の形成	渡辺 徹	42	5	534	1991	10:比べてみよう	その他	格子定数
4464	低温ラミネ - ト可能なPVC被覆鋼板用ポリエステル樹脂系接着剤の開発	大竹輝徳, 真野 毅, 桑野三郎, 沖 猛雄	42	5	535	1991	5:原著論文	イオン注入	窒化アルミニウム, C軸配向性, 音響材料, イオンプレーティング
4465	低温ラミネ - ト可能なPVC被覆鋼板用ポリエステル樹脂系接着剤の開発	林 芳夫, 中本哲男, 神田勝美	42	5	541	1991	5:原著論文	電気めっき	PVC被覆鋼板, ポリエステル, 接着, 密着性
4466	金 - 銅 - Ni - 合金皮膜の微細化について	渡辺公秀, 入江晃士, 吉原佐知雄, 佐藤昌伸, 榎本英彦, 小見 崇	42	5	548	1991	5:原著論文	電気めっき	微細化, Au, パルスめっき
4467	Ni - 金属Sn複合めっき皮膜の作製とそのはんだ付け性	伊藤昌伸, 榎本英彦, 小見 崇	42	5	553	1991	5:原著論文	電気めっき	Ni, Sn, 合金めっき, はんだ付け性, 表面形態
4468	電析法によるNi - S合金の析出過程と非晶質の形成	成田 彰, 渡辺 徹	42	5	559	1991	5:原著論文	電気めっき	非晶質, Ni, S, 合金めっき, 構造
4469	HCD法によるTiNコーティング鋼の耐食性に及ぼす成膜条件の影響	滝沢貴久男, 福島 誠, 今井八郎	42	5	564	1991	5:原著論文	その他	イオンプレーティング, TiN, バイアス電圧, ステンレス鋼
4470	非晶質Ni - Co - B合金皮膜の熱処理による影響	齋藤哲男, 佐藤栄一	42	5	571	1991	7:速報論文	無電解めっき	非晶質, Ni, Co, B, 合金, 焼入れ
4471	クロムの多硫化ナトリウム中での腐食挙動	下屋敷重広, 高橋和雄, 床井博見	42	5	573	1991	7:速報論文	その他	Cr, 硫化皮膜, 腐食
4472	巻頭言: 材料開発に思う	木村達也	42	6	583	1991	1:巻頭言	その他	金属, リサイクル, 合金化技術, 表面処理技術
4473	小特集「印刷・コピー」に寄せて	加藤凡典	42	6	584	1991	3:解説	その他	印刷, コピー, 半導体, 表面処理
4474	オフセット印刷機械	縄田卓生	42	6	585	1991	3:解説	その他	オフセット印刷機械, 枚様印刷機, 輪転印刷機
4475	カラースキャナ -	宇佐見良徳	42	6	589	1991	3:解説	その他	カラースキャナー, 平面型スキャナー, 色補正, 網点発生
4476	製版における表面処理	江頭靖郎	42	6	594	1991	3:解説	その他	表面処理, 製版, オフセット, グラビア
4477	新聞印刷	柿崎謙介	42	6	599	1991	3:解説	その他	新聞, オフセット印刷, カラースキャナー, 印刷インキ, 印刷素材, 固着, 乾燥と硬化, 樹脂
4478	インキと素材	佐野節也	42	6	603	1991	3:解説	その他	印刷技術, エッチング技術, フォトファブリケーション, 精密電子部品, 金属処理
4479	エレクトロニクスへの応用	山村 康	42	6	607	1991	3:解説	その他	カード, 光記憶カード, ICカード
4480	ホログラム印刷	和田 隆	42	6	610	1991	3:解説	その他	ホログラム
4481	光カ - ド:ICカ - ド	倉持 涉, 西川誠一	42	6	614	1991	3:解説	その他	カード, 光記憶カード, ICカード
4482	シリーズ/めっき工場の経営管理技術(6) - 都市型工場における技術開発	石川進造	42	6	619	1991	9:シリーズ-2	その他	都市工場, 経営, 技術開発
4483	シリーズ/色 - めっきによる金色化(2)	小林道雄	42	6	625	1991	9:シリーズ-2	電気めっき	金色めっき, 銅, 亜鉛, すず, 合金めっき
4484	シリーズ/くらべてみよう物性値 - 電気伝導	伊藤 滋	42	6	626	1991	10:比べてみよう	その他	電気抵抗率
4485	Zn - Ni合金電析挙動に及ぼすパルス電解の効果	西村一実, 菊池郁夫, 小田島壽男	42	6	627	1991	5:原著論文	電気めっき	パルスめっき, Zn, Ni, 合金電析, 表面形態
4486	弱アルカリ溶液中におけるコバルトアノード酸化反応に及ぼすアンモニアの効果	小林和夫, 宮田雅之, 若山宏明, 宮林 毅, 大塚俊明, 日根 袁, 宝林 劉, 克里, 小若正倫	42	6	633	1991	5:原著論文	アノード酸化	コバルト, アンモニア, アノード酸化, 酸化皮膜
4487	アンモニア・クエン酸塩浴による電析Ni - Mo非晶質合金の作製と耐食性	清水健一, 小林賢三, G.E.Thompson, G.C.Wood	42	6	639	1991	5:原著論文	電気めっき	Ni, Mo, 合金, 非晶質, 腐食
4488	バリアー形アノード酸化皮膜の成長に伴うアルミニウム表面の平滑化について	清水健一, 小林賢三, G.E.Thompson, G.C.Wood	42	6	645	1991	5:原著論文	アノード酸化	アルミニウム, アノード酸化, バリアー酸化
4489	18 - 8ステンレス鋼の耐孔食性に及ぼすMnS介在物と定電位電解処理の影響	滝沢貴久男, 中山住則	42	6	649	1991	5:原著論文	その他	ステンレス鋼, 孔食, 介在物, 活性態溶解, 孔食電位
4490	巻頭言: 自然との対話	小林賢三	42	7	661	1991	1:巻頭言	その他	自然, 対話
4491	印刷技術の原理と動向	山岡亜夫	42	7	662	1991	2:総説	その他	印刷, 転写, 製版, カラーブルー, インキ
4492	フルカラー複写機の原理と技術要素	高瀬克明	42	7	675	1991	2:総説	その他	フルカラー, 電子写真, 高画質, デジタル化, 複写機
4493	トナ - と素材 - トナ - と紙の定着性	今田俊治	42	7	681	1991	3:解説	その他	紙, トナー, 複写, 樹脂, 顔料, ワックス
4494	スクリーン印刷によるフィンパタン形成	植田豊一, 池上 昭	42	7	685	1991	3:解説	その他	半田印刷, スクリーンマスク, スクリーン印刷, ファインパタン, 厚膜印刷
4495	金属上への印刷技術	町井昭彦	42	7	691	1991	3:解説	その他	金属, オフセット印刷, 3ピース印刷, 2ピース印刷, UV印刷
4496	バット印刷	清水久吾	42	7	697	1991	3:解説	その他	印刷, バット印刷, シリコンゴム, マーキング処理, 立体物
4497	3次元立体成型品への加飾方法	樽谷隆至	42	7	703	1991	3:解説	その他	加飾, 三次元立体, ホットスタンブ, インモールド転写, サーマ
4498	バイオセンサ -	軽部征夫	42	7	710	1991	3:解説	その他	センサー, バイオセンサー, 酵素センサー
4499	マーキングフィアルムの印刷	橋本定明	42	7	715	1991	3:解説	その他	マーキングフィルム
4500	電気通信用屋外設備の腐食と対策	高沢壽佳	42	7	719	1991	3:解説	その他	腐食, 防食, 有機被覆, 電気通信, 腐食診断技術
4501	シリーズ/色 - 塗装による金色化	吉原一郎	42	7	726	1991	9:シリーズ-2	塗装	塗装, 金色, 顔料, アルミナ粉末, 黄色顔料
4502	シリーズ/くらべてみよう物性値 - 単体のアスコルビン酸を還元剤とする無電解めっき浴の電気化学的挙動	平山良夫	42	7	728	1991	10:比べてみよう	その他	比熱
4503	無電解銅めっきの均一析出性	加藤 勝, 新倉恵子, 星野重孝, 大野 涼	42	7	729	1991	5:原著論文	無電解めっき	無電解めっき, 金, シアンフリー浴, アスコルビン酸, 錯化剤
4504	無電解銅めっきの均一析出性	本間英夫, 藤波知之	42	7	736	1991	5:原著論文	無電解めっき	無電解めっき, 銅, 均一析出性, アスペクト比, 溶存酸素
4505	電解鉄箔を支持体としたPS版の特性	神田勝美, 山根啓二, 近藤嘉一	42	7	740	1991	5:原著論文	その他	PS版, 平版印刷, 電解鉄箔, 鉄めっき
4506	テルミット法で合成したZnO微粉体の電気泳動電着回収	小林秀彦, 加藤巳幸, 三田村孝	42	7	746	1991	5:原著論文	泳動電着	電気泳動電着, ジルコン, 窒素, 酸洗い, 回収
4507	Siウエハー上への無電解Niめっきにおける紫外線照射効果	石川 豊, 中道一郎	42	7	751	1991	7:速報論文	無電解めっき	紫外線光, 無電解めっき, Ni, Siウエハー
4508	無電解銅めっき過程における析出速度の変化	松岡政夫, 岩本和也, 林 忠夫	42	7	753	1991	7:速報論文	無電解めっき	無電解めっき, 銅, 混成電位, 添加剤, 析出速度
4509	巻頭言: 中小企業生き残り作戦	笹野不二夫	42	8	765	1991	1:巻頭言	電気めっき	中小企業
4510	小特集「電解用電極の進展と表面処理」企画にあたって	虫明克彦	42	8	766	1991	2:総説	電気めっき	電気めっき

4511	表面処理プロセスにおける不溶性アノード	岸 富也	42	8	767	1991	3:解説	アノード析出	不溶性アノード、アノード、触媒
4512	鉛電極の特性とその応用	太田健一郎、鈴木匠、神谷信行	42	8	773	1991	3:解説	電気めっき	Pd、二酸化鉛電極、オゾン生成
4513	フェライト電極の現状	大江一英	42	8	778	1991	4:技術解説	電気めっき	フェライト
4514	DSE	島宗孝之、中島保夫、中松秀司	42	8	783	1991	4:技術解説	化成処理	DSE、銅箔、アルミ箔
4515	白金被覆チタン電極	松澤繁光	42	8	788	1991	4:技術解説	電気めっき	白金、チタン
4516	IVa ~ VIa族遷移金属非酸化物のセラミック	三田村孝、小林秀彦	42	8	793	1991	3:解説	電気めっき	B、C、N、分極曲線
4517	ガス拡散電極	古屋長一	42	8	800	1991	3:解説	拡散皮膜	ガス拡散電極、アノード、水素
4518	溶射法で作製したマグネタイトコート電極の性質	虫明克彦、井上英雄、玉田興史	42	8	848	1991	7:速報論文	溶射	Mg、溶射、アノード特性
4519	ガラス被覆チタン基体を用いた酸素発生用電極	虫明克彦、増子昇	42	8	850	1991	7:速報論文	塗布・塗装	ガラスコート、触媒被覆、硫酸浴、シリサイド
4520	FA化による表面処理技術の自動化	松村宗順	42	8	805	1991	3:解説	電気めっき	FA化、通信手段、CIM、ソフトウェア、ハードウェア
4521	衛星搭載用マグネシウム合金の表面処理技術	三野正人	42	8	811	1991	3:解説	電気めっき	Mg、航空宇宙搭載器、イオンプレーティング
4522	シリーズノ表面物性評価技術 - 表面状態の解析(19) - 昇温脱離法による吸着・脱離過程の解明	藤田大介	42	8	815	1991	9:シリーズ-2	吸着	化学吸着、物理吸着、昇温脱離法
4523	シリーズノくらべてみよう物性値 - 融解熱	平山良夫	42	8	821	1991	10:比べてみよう	熱分解	融解熱
4524	DC型カラープラズマディスプレイパネル厚膜陰極へのめっき効果	小岩一郎、藤井浩三、小林広美、澤井秀夫、寺尾芳孝	42	8	823	1991	5:原著論文	電気めっき	カラーPDP、水銀浸漬法、陰極作製法
4525	酸化Zr粉末上へのPdの無電解めっきとめっき物の熱的挙動	佐藤祐一、藤橋勝治、齋藤学、関野修二、小早川紘一、早	42	8	827	1991	5:原著論文	無電解めっき	Zr、Pd、燃焼触媒
4526	無電解銅めっきにおけるフェナントロン添加剤の作用機構	老田昌弘、本城克彦	42	8	833	1991	5:原著論文	無電解めっき	無電解めっき、添加剤、作用機構
4527	無電解Ni-P-PTFE複合めっき浴における界面活性剤の作用	老田昌弘、本城克彦	42	8	833	1991	5:原著論文	無電解めっき	界面活性剤、懸濁性測定、析出速度、共析量測定、複合めっき
4528	エッチングしたアルミニウム箔表面に生成するバリアー型アノード酸化皮膜の構造	清水健一、小林賢三	42	8	844	1991	5:原著論文	アノード酸化	縦断面超薄切片、TEM、超ミクローム
4529	無電解ニッケルめっき過程における応力割れの検出: 光音響的手法によるアプローチ	入江晃士、竹林恭志、三浦育子、吉原佐知雄、佐藤栄一、久米道之、小野さとみ、大澤松夫	42	8	852	1991	7:速報論文	無電解めっき	Ni、B、合金、クラック、応力
4530	TiO ₂ 粉末光触媒を用いる有機窒素化合物の分解処理	久米道之、小野さとみ、大澤松夫	42	8	854	1991	7:速報論文	その他	光触媒分解、酸化チタン、N置換化合物
4531	H ₂ - H ₂ S雰囲気中におけるアルミニウム拡散被覆の高温硫化	百瀬 治、吉田 薫、河上 護	42	8	856	1991	7:速報論文	拡散皮膜	硫化量、アルミ拡散層、高温硫化
4532	巻頭言: 気になること	諏訪正輝	42	9	867	1991	1:巻頭言	その他	材料、プロセス、先端技術、先端材料、後端材料
4533	熱拡散法による合金めっき鋼板の製造方法の特性	和氣亮介	42	9	868	1991	3:解説	熱処理	熱拡散、合金めっき、電気めっき
4534	金属超微粒子担持電極の接触特性	松田好晴、高須芳雄	42	9	873	1991	3:解説	電析応用	金属超微粒子、電気触媒特性、メタノールの陽極酸化
4535	耐熱めっきの構成と機能	小見 崇	42	9	881	1991	3:解説	その他	合成材料、電着、トライボロジー、熱応力、耐熱性
4536	電子部品への無電解ニッケル合金めっきの応用	澤井秀夫、逢坂哲彌	42	9	888	1991	3:解説	無電解めっき	無電解めっき、ニッケル、合金、サーマルヘッド、電子機器
4537	高温超伝導酸化物の酸素ストイキオメリー - 超伝導体における酸素の問題	井手本康、笛木和雄	42	9	896	1991	3:解説	その他	酸素ストイキオメリー、超伝導酸化物、欠陥、酸素の拡散、Cu
4538	シリーズノめっき工場の経営管理技術(7) - めっき工場の排水・廃棄物処理における取り組むべき問題	石井 博	42	9	904	1991	9:シリーズ-2	その他	排水、廃棄物、COD
4539	シリーズノ色 - ドライブプロセスによる金色化	*	42	9	911	1991	9:シリーズ-2	その他	金色化、イオンプレーティング、TiN、膜特性
4540	シリーズノくらべてみよう物性値 - 縦弾性率	平山良夫	42	9	912	1991	10:比べてみよう	その他	縦弾性率、ヤング率、フックの法則、弾性変形
4541	グリオキシル酸を還元剤とする無電解銅めっき	本間英夫、小松素明、藤波知之	42	9	913	1991	5:原著論文	無電解めっき	銅、無電解めっき、グリオキシル酸、均一析出性、機械的性質
4542	次亜リン酸を還元剤とする低温タイプの無電解ニッケルめっき浴の開発	松岡政夫、小川哲司、岩倉千秋	42	9	918	1991	5:原著論文	無電解めっき	低温、Ni、P、合金、引張強さ、耐食性
4543	ダイナミックミキシング法により形成したTiN膜の構造と磨耗	中島昌一、近崎充夫	42	9	923	1991	5:原著論文	イオン注入	TiN、イオン注入、蒸着、反応性蒸着、磨耗
4544	アルミの交流エッチングにおけるボ - ラス層の生成に及ぼす諸因子の影響	菅沼啓一、丹野裕司、梅津 勇、船越明、松木健三	42	9	928	1991	5:原著論文	電解エッチング	アルミニウム、ACエッチング、静電容量、アノード皮膜
4545	ADC12Alダイカスト合金の硫酸溶液中における多孔質アノード酸化の生成挙動に及ぼす加熱処理の影響	渡辺啓一、高橋英明、古市隆三郎、瀬尾真浩	42	9	933	1991	5:原著論文	アノード酸化	アルミニウム、合金、アノード酸化処理、ダイカスト
4546	アルミニウム複合酸化物皮膜の構造観察手法に関する1考察	清水健一、小林賢三	42	9	941	1991	6:技術論文	アノード酸化	アルミニウム、アノード酸化、TEM、SEM、電解
4547	爆発溶射法によるAl ₂ O ₃ - TiO ₂ セラミック皮膜の特性	山田勝弘、中島弘幸、森本純司、山口瀬高信雄	42	9	945	1991	7:速報論文	溶射	セラミックコーティング、ガス爆発溶射法、耐磨耗性、マイクロ硬度
4548	巻頭言: CVD技術への期待	瀬高信雄	42	10	963	1991	1:巻頭言	その他	CVD
4549	界面・接着・複合材料	中尾一宗	42	10	964	1991	2:総説	その他	界面、接着、複合材料、ガラス繊維強化プラスチック、シランカップリング
4550	宇宙機器における複合材料	田中長博	42	10	976	1991	3:解説	その他	先端複合材料、炭素繊維強化プラスチック、繊維強化金属、アラミド繊維強化プラスチック
4551	航空機における複合材料の応用	南雲 隆	42	10	984	1991	3:解説	その他	航空材、複合材料、材料開発、加工技術開発
4552	自動車部品と複合材料	蓮見 茂	42	10	991	1991	3:解説	その他	自動車、複合材料
4553	スポ - ツ用品と複合材料	小塚興治	42	10	997	1991	3:解説	その他	複合材料、ガラス繊維強化プラスチック、ゴルフクラブ、つり竿、テニスラケット
4554	住宅資材と複合材料	阿部義孝	42	10	1004	1991	3:解説	その他	繊維強化プラスチック、住宅資材、バスタブ、下水浄化槽、人造
4555	シリーズノ色 - 陽極酸化による金色化	岡 安夫、平山良夫	42	10	1011	1991	9:シリーズ-2	その他	陽極酸化皮膜、電解発色、染色
4556	シリーズノくらべてみよう物性値 - 熱伝導	平山良夫	42	10	1012	1991	10:比べてみよう	その他	熱伝導率
4557	電析Ni-P合金めっきの熱処理による皮膜構造変化と硬さとの関係	来間清志、山田克美、佐藤馨、影近 博	42	10	1013	1991	5:原著論文	電気めっき	ニッケル、リン、電気めっき、硬度、結晶構造、熱処理
4558	VとCrまたはNbとCrを含む溶融水ウ砂浴中で鋼に形成された複合炭化物	藤田浩紀、新井 透	42	10	1019	1991	5:原著論文	拡散皮膜	炭化物、複合炭化層、クロム、バナジウム、ニオブ

4559	リン青銅スズめっき材の熱はく離について	深町一彦, 川内 進	42	10	1026	1991	5:原著論文	電気めっき	銅、スズ、リン、層間拡散、熱はく離、カーケンドルポイド
4560	リン青銅スズめっき材のはく離に及ぼす合金元素及び下地銅めっきの影響	深町一彦, 小倉次夫, 荒木田泰弘	42	10	1033	1991	5:原著論文	電気めっき	銅、スズ、リン、熱はく離、電気めっき
4561	クロムを含有する亜鉛合金の析出	秋山徹也, 福島久哲, 浦川隆之	42	10	1039	1991	5:原著論文	電気めっき	電気めっき、亜鉛合金、クロム、鉄
4562	単結晶銀上への鉛のUnderpotential-Deposition過程のIn-Situ観測 - 光音響的手法によるAFMローチ	吉原佐智雄, 高橋亮二, 岡本三永子, 佐藤栄一	42	10	1044	1991	5:原著論文	その他	銀、単結晶、鉛、in-situ観測、光音響
4563	巻頭言:自動車と表面処理	長田征夫	42	11	1057	1991	1:巻頭言	その他	自動車、表面処理、リサイクル
4564	無電解めっきの原理 - 析出機構を中心として	松岡政夫	42	11	1058	1991	2:総説	無電解めっき	無電解めっき、混成電位論、半反応、副反応、浴の安定性
4565	無電解銅めっきの現状と将来	藤波知之	42	11	1068	1991	3:解説	無電解めっき	銅、無電解めっき、均一析出性、高速化、ホルマリンフリー
4566	無電解金めっきの歴史と現状	沖中 裕	42	11	1077	1991	3:解説	無電解めっき	金、無電解めっき
4567	無電解ニッケル(Ni - P, Ni - B)めっきの現状と展開	田村忠義	42	11	1087	1991	3:解説	無電解めっき	ニッケル、無電解めっき、特性の応用
4568	無電解パラジウムめっきの現状と将来	縄舟秀美	42	11	1093	1991	3:解説	無電解めっき	無電解めっき、パラジウム、合金皮膜、接触抵抗、はんだ付け性
4569	無電解白金めっき	高橋健二	42	11	1100	1991	3:解説	無電解めっき	白金、無電解めっき、ヒドラジン
4570	無電解複合めっきの現状と将来	松村宗順	42	11	1104	1991	3:解説	無電解めっき	無電解めっき、複合めっき
4571	無電解めっき工程と設備の実際	矢部 賢	42	11	1110	1991	3:解説	無電解めっき	無電解めっき、工程のデザイン、前処理装置、浴管理、設備管理
4572	無電解めっきの廃液処理	加藤清治, 藤田 繁	42	11	1118	1991	3:解説	無電解めっき	銅、無電解めっき、廃水処理、COD除去、電気透析
4573	無電解ニッケルめっき廃液の処理	木村輝三	42	11	1123	1991	3:解説	無電解めっき	ニッケル、無電解めっき、排水
4574	無電解めっきの自動管理システム	吉田 正	42	11	1129	1991	3:解説	無電解めっき	溶液管理、無電解めっき
4575	鉄族金属を含む合金の電析挙動	東 敬	42	11	1134	1991	12:武井記念シリーズ	電気めっき	共析、鉄族金属、亜鉛、モリブデン、分極
4576	シリーズ/くらべてみよう物性値 - 熱膨張	平山良夫	42	11	1140	1991	10:比べてみよう	その他	膨張、熱膨張率、線膨張率
4577	PET素地上の無電解Co - Ni - Pめっき膜の磁気特性に及ぼす前処理の影響	松田 均, 廣野 修, 池内隆啓	42	11	1141	1991	5:原著論文	無電解めっき	無電解めっき、アクチベータ処理、保磁力
4578	亜リン酸塩を還元剤とする無電解Pd - P合金めっき及びその析出機構	芳賀正記, 内田 衛, 水本省三, 縄舟秀美, 滝沢貴久, 福島誠, 黒河圭子, 岡田英敏, 今井八郎	42	11	1146	1991	5:原著論文	無電解めっき	無電解めっき、Pd、P、合金、亜リン酸塩、結晶構造
4579	TiN被覆したステンレス鋼の硫酸水溶液中での耐食性	山崎 晃, 名倉英明, 横沢真観, 上浦宏明, 両角宏喜, 加藤凡典, 上田重朋	42	11	1152	1991	5:原著論文	その他	腐食、イオンブレーディング、HCDプロセス、窒化チタン、ステンレス鋼
4580	SiとAuGeSb / Cr / NiCr / Ni層の接触抵抗	山崎 晃, 名倉英明, 横沢真観, 上浦宏明, 両角宏喜, 加藤凡典, 上田重朋	42	11	1158	1991	6:技術論文	物理蒸着	接触抵抗、Si - AuGeSb、粉末サイクルテスト
4581	リードフレーム用Cu合金におけるマイグレーション性の評価	両角宏喜, 加藤凡典, 上田重朋	42	11	1163	1991	6:技術論文	その他	マイグレーション、銅、リードフレーム、デンドライト成長
4582	ジビリジル添加の無電解銅めっき低温浴の分極特性と析出物	老田昌弘, 本城克彦	42	11	1169	1991	7:速報論文	無電解めっき	銅、無電解めっき、ジビリジル、混成電位、分極曲線、エチレンジアミンテトラ酢酸
4583	紙上の無電解Ni - Bめっき皮膜のシールド効果	三浦育子, 入江晃士, 小林美紀, 斎藤哲男, 佐藤栄一	42	11	1171	1991	7:速報論文	無電解めっき	EMIシールド、無電解めっき、Ni、B、合金、活性化時間
4584	高純度アルミニウムの陽極酸化皮膜の多孔質層の観察	前嶋正史, 石禾和夫, 猿渡光一, 平田西山諒行	42	11	1173	1991	7:速報論文	アノード酸化	高純度アルミニウム、陽極処理、多孔質層、ウェアー現象、生成効
4585	巻頭言:表面技術と表面科学雑感	西山諒行	42	12	1183	1991	1:巻頭言	その他	科学、技術、表面
4586	「小特集/ダイヤモンド薄膜の生膜技術・評価及び応用」に寄せて	広瀬洋一, 高井 治	42	12	1184	1991	1:巻頭言	その他	ダイヤモンド、合成、評価
4587	熱フィラメントCVD法及び電子衝撃CVD法によるダイヤモンド薄膜の作製	澤辺厚仁	42	12	1185	1991	3:解説	化学蒸着	熱フィラメントCVD、EACVD、ダイヤモンド薄膜
4588	有磁場マイクロ波プラズマCVD法及びマイクロ波プラズマCVD法によるダイヤモンド薄膜の作製	鈴木準一, 川原田洋, 平木昭夫	42	12	1189	1991	3:解説	化学蒸着	ダイヤモンド薄膜、CVD、ECR
4589	直流プラズマCVD法によるダイヤモンド合成	鈴木一博, 犬塚直夫	42	12	1196	1991	3:解説	化学蒸着	ダイヤモンド、CVD、直流、薄膜、プラズマ
4590	DCプラズマジェットCVD法によるダイヤモンド合成	栗原和明, 河原田元信, 佐々木謙一	42	12	1199	1991	3:解説	化学蒸着	ダイヤモンド薄膜、プラズマジェット、傾斜機能物質、熱プラズマ、プラズマCVD
4591	アーク放電プラズマジェットCVD法によるダイヤモンド合成	吉川昌範	42	12	1205	1991	3:解説	化学蒸着	アーク放電、プラズマジェット、セパレートプラズマトーチ、ダイヤモンド薄膜、成長過程
4592	燃焼炎を用いたダイヤモンド合金	広瀬洋一	42	12	1212	1991	3:解説	化学蒸着	ダイヤモンド、薄膜、燃焼点、CV
4593	ラマン分光法によるダイヤモンド薄膜の評価	吉川正信	42	12	1217	1991	3:解説	化学蒸着	ラマン、応力、ダイヤモンド、グラフィット、C - BN
4594	ダイヤモンドコーティングの切削工具への応用	菊池則文	42	12	1223	1991	3:解説	化学蒸着	CVD、ダイヤモンド、コーティング、切削工具
4595	CVDダイヤモンド薄膜の電子デバイスへの応用	岡野 健, 黒須楯生, 飯田昌盛	42	12	1230	1991	3:解説	化学蒸着	半導体ダイヤモンド、p-n接合ダイオード、FET
4596	ダイヤモンド薄膜のエレクトロニクスへの応用	馬場和宏	42	12	1235	1991	3:解説	化学蒸着	ダイヤモンド薄膜、ヒートシンク、多層配線基板、X線マスク
4597	シリーズ/表面物性評価技術 - 表面状態の解析(20) - 全反射蛍光X線分析法	青木貞雄	42	12	1240	1991	9:シリーズ-2	その他	全反射、蛍光X線、侵入深さ、微量元素分析
4598	シリーズ/くらべてみよう物性値 - 標準電極電位(単体)	虫明克彦	42	12	1243	1991	10:比べてみよう	その他	標準電極電位
4599	ニッケル電析の配向性モルフォロジーと界面インピーダンスに及ぼすクマリンの影響	周 延伶, 市野良一, 興戸正純, 沖 猛雄	42	12	1245	1991	5:原著論文	電気めっき	ニッケル、電気めっき、モルフォロジー、配向性、インピーダンス
4600	TiN及びTiCコーティング膜の配向性	内山休羽, 羽根雅之, 森 尚武, 松竹寛	42	12	1250	1991	5:原著論文	化学蒸着	TiNコーティング、TiCコーティング、配向性、組成、パッキング密度
4601	TiN被覆したステンレス鋼の耐食性に及ぼすMnS介在物の影響	滝沢貴久, 福島誠, 岡田英敏, 今井須田 新, 荻野陸雄, 田中成夫	42	12	1255	1991	5:原著論文	化学蒸着	窒化チタン、腐食、MnS、介在物、ステンレス鋼
4602	クロメート皮膜を構成するクロム化合物の熱的性質	須田 新, 荻野陸雄, 田中成夫	42	12	1262	1991	7:速報論文	化成処理	塗布型クロメート、熱分析、乾燥温度、クロム化合物
4603	巻頭言:生物に学ぶ表面と表面皮膜	馬場宣良	43	1	1	1992	1:巻頭言	A10.その他	生物、表面、表面皮膜、エレクトロクロミズム
4604	多孔質A陽極酸化皮膜を隔膜とする光励起電子のベクトル輸送とエネルギー貯蔵	魚崎浩平, 岡崎賢太郎, 上田讓司	43	1	2	1992	3:解説	B07.アノード酸化	アノード酸化膜、マイクロバ膜、酸化アルミニウム、太陽光エネルギー変換、電子移動反応
4605	光ディスクスタンパー - の製造とその評価技術	川崎 実	43	1	7	1992	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	製造工程、光ディスクスタンパー、スタンパー評価技術
4606	シリーズ/表面物性評価技術 - 表面状態の解析(21) - 粒子励起X線分析法(PIXE)	木曾義之, 広川 健	43	1	14	1992	9:シリーズ/表面状態の解析 21	A10.その他	粒子励起X線分析法(PIXE)
4607	NIオン注入により生成するTiNとZrNのXPSによる解析	寺島慶一, 松坂菊生, 峯岸知弘	43	1	19	1992	5:原著論文	A08.イオン注入	窒素イオン注入、Ti窒化物、Zr窒化物、結合エネルギー、ケミカルシ

4608	金属の電析に及ぼすジェット流の理論的考察	吳 文昌, 千葉 淳, 中西和美	43	1	24	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	超音波, キャピテーション, ジェット流, 電析
4609	LaNi ₅ MY合金膜の電気化学的水素吸蔵特性	釜崎清治, 亀井 健, 那須勇樹	43	1	30	1992	5:原著論文	A01.物理蒸着	金属水素化物薄膜, La-Ni合金膜, 電気化学的水素吸蔵
4610	有機電解液からマズプロシウム - 鉄電析に関する研究	松田好晴, 藤井俊茂, 吉本信子, 森田昌行, 芳賀正記	43	1	36	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Dy-Fe-Co電析, パルスめっき, 有機電解液
4611	シアン化銀浴からの銀めっきの硬度	右田泰治, 中島 清, 齋藤昭夫	43	1	41	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	銀の硬度変化, 煮沸, パーキング, 時効, X線回折, バターン
4612	13M及び1.5M硫酸溶液中のアルミニウムダイカスト合金ADC12のアノード酸化	福田 豊, 福田芳雄, 福島敏郎	43	1	48	1992	5:原著論文	B07.アノード酸化	アルミニウム, ダイカスト合金, アノード酸化, 硫酸
4613	リン青銅スズめっき材の耐熱はく離性に及ぼす下地銅浴種の影響	深町一彦	43	1	55	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	リン青銅, スズめっき, 銅下地, 熱剥離
4614	Zn-Ni合金めっき組成の傾斜化	日野 実, 西田典秀, 平松 実, 川崎仁士, 須田 新, 萩野陸雄, 田中成夫	43	1	61	1992	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	Zn-Ni電析, 傾斜化組成, 腐食
4615	塗布型クロメート皮膜の乾燥温度による質量変化	鈴木六郎	43	1	65	1992	20:随想	A05.塗布・塗装	塗布型クロメート, 熱分析, 乾燥温度, SIMS, マススペクトル
4616	随想 - 褒め方としかり方の原理(7:3の法	鈴木六郎	43	2	73	1992	1:巻頭言	A10.その他	ほめ方, しかり方, 7:3の法則
4617	巻頭言: 環境・資源・表面処理	高井 治	43	2	74	1992	2:総説	A01.物理蒸着	環境, 資源, 表面処理
4618	透明導電膜概論	大工原茂樹	43	2	82	1992	3:解説	A01.物理蒸着	透明導電膜, ITO(酸化インジウム・スズ), 膜作製
4619	真空蒸着及びRFイオンプレーティングによるITO膜の作製	堀口青史	43	2	87	1992	3:解説	A01.物理蒸着	ITO膜, 真空蒸着, RFイオンプレーティング
4620	スパッタリングによるITO膜の作製	名手達夫, 岸 俊人	43	2	92	1992	3:解説	A01.物理蒸着	ITO, マグネトロンスパッタリング, ターゲット密度, LCD
4621	ITOスパッターゲットの製造方法とその	中西功次	43	2	98	1992	3:解説	A01.物理蒸着	ITO, スパッターゲット
4622	スパッタ法によるITOキャリア生成機構	樋口 靖	43	2	103	1992	3:解説	A01.物理蒸着	ITO, 酸化インジウム膜, 伝導機構, DCスパッタリング
4623	スパッタ法による低抵抗ITO膜の作製	水野谷清	43	2	107	1992	3:解説	A01.物理蒸着	ITO, DCマグネトロンスパッタリング, 透明伝導膜, 抵抗率
4624	LCD用透明電膜	北原洋明	43	2	110	1992	3:解説	A01.物理蒸着	液晶ディスプレイ, 透明電極, 基板アクティブマトリックス型LCD, 酸化インジウム - スズ, TFT/LCD, スパッタリング, エッチング
4625	アクティブマトリックス型LCD	野中寿夫	43	2	115	1992	9:シリーズ/表面状態の解析 22	A10.その他	材料物性評価, 超音波計測, 超音波顕微鏡
4626	シリーズ/表面物性評価技術 - 表面状態の解析(22) - 超音波による材料物性評価	上田龍二, 朝倉祝治, 土岐荘太郎, 杉石田 章, 武井 厚, 辻裕一郎, 今井八郎	43	2	121	1992	5:原著論文	A01.物理蒸着	塩化第二鉄, エッチング, 電気化学, 分極, 腐食
4627	分極挙動	寺島慶一, 松坂節生, 峯岸弘, 関根小野田元伸, 土屋武司, 清水一夫, 渡辺	43	2	126	1992	5:原著論文	A08.イオン注入	イオン注入, Ni-TiC複合皮膜, 酸化
4628	反応性イオンプレーティング法によって作製したNi-TiC複合皮膜の耐酸化性	野口駿雄, 吉村長威	43	2	131	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Ni-B, 合金, 電析, 非晶質
4629	金属バナジウムへの窒素イオン注入により生成する表面窒化薄膜層の特性	野口駿雄, 吉村長威	43	2	131	1992	5:原著論文	B07.アノード酸化	アルミニウムのアノード酸化, アンモニウム塩アルカリ性溶液, フッ化物浴, 炭酸浴, 酸アミド浴
4630	電析Ni-B非晶質合金の熱処理による構造及び硬さの変化	益田秀樹, 馬場宣良	43	2	138	1992	5:原著論文	B01.化学蒸着, B07.アノード酸化	CVD, アルミニウムアノード酸化, IR反応容器, アルミニウムトリイソプロポキシド
4631	含フッ化物アンモニウム塩混合アルカリ性浴によるアルミニウムの陽極酸化における炭酸誘導体・酸アミドの添加効果	金山信幸, 堀江 謹, 田辺俊夫	43	2	144	1992	5:原著論文	B06.熱処理	浸炭法, タングステン, グロー放電, 表面硬化, WC
4632	シュウ酸浴中で生成したAl陽極酸化多孔質皮膜へのCVDアルミナ層形成挙動	近藤和夫	43	2	154	1992	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	亜鉛 - 鉄合金, パルス電析, モルホロジー, 腐食
4633	Wのプラズマ浸炭	入江晃士, 小林美紀, 三浦育子, 吉原佐知雄, 佐藤栄一, 高 学, 鎌 傳, 燕雲, 小若正倫, 橋本康彦	43	2	154	1992	7:速報論文	B03.無電解めっき	無電解めっき, 光音響分光法, Ni, B in situ観察, STM
4634	パルス電着した亜鉛 - 鉄合金の耐食性	小野幸子, 増子 昇	43	2	156	1992	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	電析, Co-W合金, 錯化
4635	走査型光音響分光法による無電解めっき過程のIn-Situ観測	富田正吾	43	3	169	1992	7:速報論文	A10.その他	助成金, 大学
4636	1-ヒドロキシエタン - 1,1-ジホスホン酸浴からのCo-W合金の電析	若木政利	43	3	170	1992	7:速報論文	B07.アノード酸化	アルミニウム, アノード酸化皮膜, 格子像, 結晶, 高分解能TEM
4637	巻頭言: 研究に助成金を	若木政利	43	3	170	1992	2:総説	A10.その他	レーザー, アルミニウム合金, 合金シンクロトロン放射光, EXAFS, SR-EXAFS, 全反射EXAFS, 表面EXAFS
4638	高分解能電子顕微鏡によるアルミニウムアノード酸化皮膜の構造	若木政利	43	3	170	1992	3:解説	A10.その他	Ni-P合金, 合金めっき, 誘起共析
4639	レーザーによるアルミニウムの表面合金	増井寛二, 野村 毅, 権 植浩, 張 道淵, 周 延伶, 市野良一, 興戸正純, 沖 猛雄	43	3	181	1992	3:解説	B03.無電解めっき	界面ACインピーダンス, 混成電位, 無電解めっき, 添加剤
4640	シリーズ/表面物性評価技術 - 表面状態の解析(23) - シンクロトロン放射光利用広域X線吸収微細構造(SR-EXAFS)解	小浦延幸, 関口 攻	43	3	188	1992	9:シリーズ/表面状態の解析 23	A10.その他	アルミニウム, 化学エッチング, 酸性浴, ACインピーダンス
4641	電析Ni-P合金の析出機構について	須田 新, 萩野陸雄, 田中成夫, 前田重義	43	3	195	1992	5:原著論文	A05.塗布・塗装	塗布型クロメート, 熱分析, 乾燥温度, X線光電子分光法(XPS)
4642	交流界面インピーダンス法による無電解銅めっき浴中への添加剤の効果測定	深町一彦, 小倉次夫	43	3	200	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	リン青銅, スズめっき, はんだめっき, 熱剥離, めっき条件
4643	ACインピーダンス法を用いた酸性浴中のアルミニウムの化学エッチング機構の解析	水木一成, 森崎重喜, 馬場宣良, 多田吉野隆子, 森 正澄, 森崎重喜, 馬場宣良, 水木一成, 多田増井孝宏, 辻裕一郎, 石田 章, 武井 厚	43	3	205	1992	5:原著論文	B07.アノード酸化	エレクトロロミネッセンス, Eu3+付加, アノードAl ₂ O ₃ 膜
4644	XPSによる塗布型クロメートの乾燥温度による組成変化の解析	若木政利	43	3	211	1992	5:原著論文	B05.熱分解, ソル-ゲル法	ゾル - ゲル法, アルミニウム, 分散型ACEL
4645	リン青銅スズ, はんだめっき材の熱はく離に及ぼすめっき条件の影響	若木政利	43	3	216	1992	5:原著論文	A01.物理蒸着	組成変化, Ni-TiC複合皮膜, イオンプレーティング
4646	アルミニウムの含Eu ³⁺ イオン水溶液での交流陽極酸化中の桃色発光	日野 実, 西田典秀, 平松 実, 米田理史, 勝村宗英, 津留 豊, 中村吉博, 細川邦典	43	3	221	1992	13:研究ノート	A10.その他, B02.電気めっき・電鍍	CO ₂ レーザー, 合金, めっき, Zn-Ni
4647	ゾル-ゲル法によって生成したアルミナ層を誘導体に用いた分散型ACEL素子の作製	若木政利	43	3	227	1992	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	残留応力, ニッケル電析, ワット浴, ひずみゲージ, 銅素地基板
4648	単一蒸発源のイオンプレーティングによって作製したNi-TiC複合皮膜の組成変化	辻野文三, 沖 猛雄	43	3	229	1992	7:速報論文	B09.その他, C07.その他	NaNO ₃ -KNO ₃ 溶融塩, ステンレス鋼, ガルバニックカップル法, 腐食速度, 着色(カラー化)
4649	CO ₂ レーザーによるZn/Ni二層めっき皮膜の表層合金化処理	牧野英司, 矢島宇生, 柴田隆行, 池田正幸, 丹野裕司, 菅 山川宏二, 田辺幸男, 上池 育	43	3	229	1992	7:速報論文	C03.化学エッチング/電解エッチング	アルミニウム, トンネルエッチング, その場観察(in situ観察)
4650	ニッケル膜の残留応力測定に関する研究	菅 山川宏二, 田辺幸男, 上池 育	43	3	231	1992	7:速報論文	A10.その他, B09.その他, A05.塗布・塗装	表面改質技術, 総合化学
4651	硝酸塩系溶融塩中におけるステンレス鋼の溶出挙動	菅 山川宏二, 田辺幸男, 上池 育	43	3	233	1992	7:速報論文	A05.塗布・塗装	VOC
4652	アルミニウムのトンネルエッチングのその場観察	菅 山川宏二, 田辺幸男, 上池 育	43	3	233	1992	7:速報論文	A05.塗布・塗装	塗料, VOC
4653	巻頭言: 総合科学としての表面改質技術		43	4	249	1992	1:巻頭言		
4654	揮発性有機化合物(VOC)排出規制の動向		43	4	250	1992	2:総説		
4655	生産統計から見たVOC削減と塗料の展		43	4	254	1992	3:解説		

4656	対応塗料の最近の進歩 - 環境保全と電着塗料の動向	福島 豊	43	4	259	1992	3:解説	A06.泳動電着	電着塗料,自動車,環境保全
4657	対応塗料の最近の進歩 - 水系塗料の最近の進歩	根津嗣男	43	4	267	1992	3:解説	A05.塗布・塗装	水系塗料,VOC,自動車用塗料,ペースコート
4658	対応塗料の最近の進歩 - ハイソリッド塗料の新しい展開	塩見一喜	43	4	273	1992	3:解説	A05.塗布・塗装	ハイソリッド塗料
4659	対応塗料の最近の進歩 - 粉体塗料の新しい展開	池田俊和	43	4	279	1992	3:解説	A05.塗布・塗装	VOC,粉体塗料
4660	塗装処理工程の対応 - 自動車塗装処理からの環境汚染に対する具体策	田辺幸男	43	4	285	1992	3:解説		VOC,自動車塗料処理
4661	塗装処理工程の対応 - 製缶用塗料の地球環境保全対策	堀田久志	43	4	299	1992	3:解説	A05.塗料・塗布,A06.泳動電着	製缶用塗料,水系塗料,粉体塗料,電着,フミネート
4662	塗装設備での対応 - 最近の塗装設備と公害対策	庄司 麟	43	4	306	1992	3:解説	A05.塗布・塗装	公害対策,塗料ミスト, VOC
4663	塗装前処理としての塗布型クロメート	三代沢良明	43	4	311	1992	3:解説	A05.塗布・塗装	前処理,塗装,耐食性,クロメート,シ
4664	BCI2 - NH3ガスを用いたプラズマCVD法による鋼表面でのホウ素化合物の生成	宮下文彬,野中弘樹,市井一男,藤村千田厚生,中川卓二,高野良比古,笠小林繁夫,旭野 肇,津留壽昭,柳ヶ瀬勉,柚賢正光,赤沢 昇,山崎 珠,大山昌憲	43	4	319	1992	5:原著論文	B01.化学蒸着,B07.アノード酸化	アノード酸化, - Si,H,カレントインフラクター,容量,活性化エネルギー,超伝導,泳動電着法,ステンレス鋼
4665	無電解めっきによる鉛皮膜の形成	千田厚生,中川卓二,高野良比古,笠小林繁夫,旭野 肇,津留壽昭,柳ヶ瀬勉,柚賢正光,赤沢 昇,山崎 珠,大山昌憲	43	4	324	1992	5:原著論文	B03.無電解めっき	Pt-Mo合金,電析,非晶質, DSC,ESCA
4666	電析法による Pt - Mo合金	小林繁夫,旭野 肇,津留壽昭,柳ヶ瀬勉,柚賢正光,赤沢 昇,山崎 珠,大山昌憲	43	4	330	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	アノード酸化, - Si,H,カレントインフラクター,容量,活性化エネルギー,超伝導,泳動電着法,ステンレス鋼
4667	電流遮断法を応用したエチレンジアミン系の中の水素化アモルファスシリコン陽極酸化泳動電着法によるステンレス鋼板上への YBCO超伝導体の作製	南 直孝,小浦延幸	43	4	340	1992	5:原著論文	A06.泳動電着	金メッキ,ピンホール,メッキ, 応力,ひずみ
4668	金めっきのピンホール発生に及ぼすニッケル素材の応力の影響	齋藤いほえ,吉田裕道	43	4	346	1992	13:研究ノート	B02.電気めっき・電鍍	濃炭法,プラズマ溶射,タングステン,表面硬化, WC
4670	減圧プラズマ溶射によるタングステン皮膜のプラズマ浸炭	金山信幸,堀江 謙,田辺俊夫	43	4	349	1992	7:速報論文	A02.溶射	ガス溶射法,クロムカーバイト皮膜,自己融着
4671	クロムカーバイト基ガス溶射皮膜の液体Na中における自己融着機構	下屋敷重広,山形保男,伊藤守男,公文将人,福田祐治,森河 務,横井昌幸,城間成信,江口晴一郎,香西英治	43	4	351	1992	7:速報論文	A02.溶射	
4672	クエン酸浴からの電気Ni - P合金めっき	城間成信,江口晴一郎,香西英治	43	4	353	1992	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	Ni-P合金,電析,Ni-クエン酸浴
4673	ジビリジル添加浴における無電解銅の曲げ強度と色	老田昌弘,本城克彦	43	4	355	1992	7:速報論文	B03.無電解めっき	曲げ強度,無電解銅めっき,ジビリジル, エチレンジアミンテトラ酢
4674	SUS316鋼とテフロン球すきまのすきま腐食再不動電位	今井八郎,澤倉一哉,増子 昇	43	4	357	1992	7:速報論文	B09.その他	ステンレス鋼,隙間腐食,再不動電位,テフロン球
4675	巻頭言: 研究と活性化	榎本英彦	43	5	371	1992	1:巻頭言	A10.その他	研究,活性化
4676	電極溶液界面及び電解めっき過程のSTM観察	西谷龍介,粕谷厚生,仁科雄一郎	43	5	373	1992	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	STM, in situ STM,電気めっき,電析
4677	走査トンネル顕微鏡による無電解めっき薄膜析出過程のIn-Situ観察	本間敬之,山崎琢也,逢坂哲彌	43	5	378	1992	3:解説	B03.無電解めっき	走査トンネル顕微鏡, in situ観察,無電解めっき
4678	半導体開発におけるSTM / AFM	徳本洋志	43	5	383	1992	3:解説	A04.吸着,A10.その他	STM, AFM, Si(111)-7*7, Si(001)-2*1, 原子ステップ, マイクロマイグレーション
4679	有機超薄膜のSTM / AFM	原 正彦	43	5	388	1992	3:解説	A04.吸着,A10.その他	STM, AFM, 液晶, タンパク質, スクリーニング効果
4680	吸着物のSTM	関根 功,湯浅 真	43	5	393	1992	3:解説	A04.吸着	STM,吸着物,表面
4681	QCM法による有機及び無機電気活性薄膜における物質移動の研究	直井勝彦	43	5	399	1992	3:解説	B09.その他	QCM法,電解重合,ポリピロール,ドーパント
4682	センシング技術へのSAWデバイスの応用	新井祐子	43	5	404	1992	3:解説	A10.その他	弾性表面波デバイス(SAWデバイス), センサー,周波数
4683	赤外分光法による電極表面のIn-Situ測定	大澤雅俊	43	5	409	1992	3:解説	A04.吸着,B09.その他	赤外分光法,電極表面現象, in situ測定
4684	ラマン分光法による電極表面反応の解析	佐々木芳朗	43	5	414	1992	3:解説	A04.吸着,B09.その他	ラマン分光法,電極反応, SERS
4685	高感度反射赤外分光法による反応ガス存在下での表面反応の観測	近藤淳子,堂免一成	43	5	419	1992	3:解説	A04.吸着,B09.その他	赤外分光法,表面反応吸着分子
4686	CVDプロセスのIn-Situエリブソメトリー	杉本克久	43	5	424	1992	3:解説	B01.化学蒸着	in situエリブソメトリー, CVDプロセス,薄膜
4687	電極表面のエリブソメトリー	大塚俊明	43	5	429	1992	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	エリブソメトリー,電極,光学特性,表面皮膜
4688	光音響分光法 - 固液界面への適用	吉原佐知雄	43	5	434	1992	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	光音響分光法,金属電極,半導体電極, in situ測定
4689	電極表面の紫外可視反射分光法	相樂隆正	43	5	440	1992	3:解説	A04.吸着	紫外可視反射分光法,電位変調
4690	電気化学質量分析法: DEMS法	延与三知夫,渡辺恭一,松田直樹,仁科辰夫,末永智一,内田 勇	43	5	446	1992	3:解説	A04.吸着,B09.その他	紫外可視反射分光法,電位変調
4691	In-SituXRD測定法によるCuの無電解析出過程の検討	延与三知夫,渡辺恭一,松田直樹,仁科辰夫,末永智一,内田 勇	43	5	451	1992	5:原著論文	B03.無電解めっき	電極,質量分析, DEMS
4692	金電極上に吸着した芳香族チオールの高感度反射吸収赤外分光法によるその場観	佐々木健,石川達雄	43	5	457	1992	5:原著論文	A04.吸着	in situ観察,IRRAS,吸着,芳香族チオール,全電極
4693	ミラージュ法及びSTMによる銀上の鉛のUPD現象のIn-Situ検出	吉原佐知雄,岡本三永子,遠藤浩二,佐藤栄一	43	5	462	1992	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	ミラージュ法,STM,銀,鉛, アンダーポテンシャル析出
4694	ダイヤモンド成長過程を電氣的にその場測定する方法	広瀬洋一,亀田常男,飯嶋利彦,木村	43	5	467	1992	5:原著論文	B01.化学蒸着	ダイヤモンド薄膜, CVDダイヤモンド成長,測定, 燃
4695	銀及び銅電極表面におけるメルカプトベンゾチアゾールのIn-Situ吸着構造解析	大澤雅俊,松田直樹,内田 勇	43	5	472	1992	5:原著論文	A04.吸着, B02.電気めっき・電鍍	メルカプトベンゾチアゾール,吸着構造,表面増強ラマン散乱,金属めっき添加剤
4696	銀めっきにおける微分容量の電析形態の関係	井上博之,山川宏二,近藤哲也,正木	43	5	478	1992	13:研究ノート	B02.電気めっき・電鍍	銀メッキ,インヒビター,微分容量,表面モルホロジー(表面形態)
4697	水晶マイクロバランス法による無電解銅めっきにおける局部反応の解析	松岡政夫,村井淳一,岩倉千秋	43	5	481	1992	7:速報論文	B03.無電解めっき	無電解銅,アルカリ金属イオン,混成電位,分極曲線, QCM法
4698	界面活性剤をドーナツとした電解重合ポリピロール膜のインピーダンス特性	前田美知子,中村節子	43	5	483	1992	7:速報論文	B09.その他	電解重合,ポリピロール,イオン移動,拡散,インピーダンススペ
4699	走査型振動電極法による亜鉛めっき電流分布の測定	津留 豊,関谷雅紀,中村淳一,細川邦典	43	5	485	1992	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	電流分布,亜鉛めっき,参照電極, 走査振動電極法
4700	巻頭言: 新素材と希元素	野口駿雄	43	6	507	1992	1:巻頭言	A10.その他	新素材, 希元素
4701	自動車工業における表面処理技術の利用	新井 透	43	6	508	1992	2:総説		表面処理技術の利用,自動車工
4702	防錆鋼板 - Zn - Fe合金めっき鋼板を中心として	深田 新	43	6	516	1992	3:解説	A03.溶融めっき	耐食性,防錆鋼板
4703	化成処理 - 耐スキャブ腐食性とリン酸塩皮膜構造	河上 毅,金丸辰也	43	6	524	1992	3:解説	B08.化成処理	リン酸塩皮膜,リン酸塩処理, フォスフォファイライト, スキップ腐

4704	車体防錆と塗装処理	久米政文	43	6	530	1992	3:解説	A05.塗布・塗装A06.泳動電着B08.化成処理	自動車、防錆、電着塗装
4705	自動車内装部品における表面技術	丸矢一夫	43	6	539	1992	3:解説	A05.塗布・塗装A10.その他	自動車、内装(インテリア)、表面技術
4706	機能部品の表面改質技術の現状	鮎谷清司	43	6	543	1992	3:解説	B08.化成処理	自動車(機能)部品、表面改質、耐摩耗性、ハイブリッド処理
4707	アルミニウムボデイの表面処理	松本 徹,西野俊哉	43	6	550	1992	3:解説	B08.化成処理	アルミニウム、表面処理、クロム酸クロメート(処理)、リン酸亜鉛
4708	自動車の塩害問題と防錆評価技術	竹内寿浩,渡邊弘和,今中 正,白谷敏	43	6	556	1992	3:解説	A02.溶射A05.塗布・塗装A06.泳動電着A10.その他	自動車腐食防錆、ブルーピンググラウンドテスト、融雪剤
4709	有機導電薄膜を用いたアルミニウム電解コンデンサ	工藤康夫	43	6	562	1992	3:解説	B09.その他	アルミニウム電解コンデンサー、ポリピロール、電気伝導性高分子(固体)電解質
4710	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(2.4) - 走査電子顕微鏡の3次元表面形状測定器への応用	大堀真敬	43	6	567	1992	9:シリーズ-2	A10.その他	3D表面粗さ、画像処理、SEM、測定
4711	ダイヤモンド膜合金の現況	瀬高信雄	43	6	573	1992	12:武井記念シリーズ	B01.化学蒸着	ダイヤモンド、CVD、成長過程、マイクロ波プラズマ
4712	TiNイオンプレATING皮膜の配向性に及ぼす基板の影響	松竹寛康,馬場恒明,羽板雅之	43	6	579	1992	5:原著論文	A01.物理吸着	イオンプレATING、TiN皮膜、配向性、XPS、絶縁性基板
4713	反応性スパッタ蒸着による窒化チタン膜特性の窒素ガス分圧依存性	西村生哉,勇田敏夫,斎藤 剛	43	6	584	1992	5:原著論文	A01.物理吸着	窒化チタン、TiN、反応性スパッタ蒸着、微細(結晶)粒構造
4714	無電解めっきによるアンチモン皮膜の形成	千田厚生,高野良比古,中川卓二	43	6	589	1992	5:原著論文	B03.無電解めっき	無電解めっき、アンチモン被膜、TiC13
4715	ポイドフリー無電解銅めっきの前処理について	藤波知之,本間英夫	43	6	595	1992	5:原著論文	B03.無電解めっき	スルホール、無電解銅めっき、促進(処理)、還元剤、ポイドフリー界面ACインピーダンス、モルホロジー、添加剤、ニッケル電析、攪拌
4716	交流界面インピーダンス法によるワット浴からのニッケルめっきに及ぼすかく拌と添加剤の影響に関する研究	周 延倫,市野良一,興戸正純,沖 猛雄	43	6	601	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Ni-Al合金、構造、硬度、複合物
4717	複合電析膜加熱法によるNi-Al合金膜の組織と硬度	伊崎昌伸,榎本英彦,小見 崇,中山竹林恭志,熊谷和彦,吉原佐知雄,佐藤栄一,千葉 淳	43	6	607	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Ni-Al合金、構造、硬度、複合物
4718	ニッケル初期電析に及ぼす磁場の影響; 走査型トンネル顕微鏡による観察	藤栄一,千葉 淳,高上僚一,古賀正太郎,平田和洋,松永守央,細川邦典	43	6	612	1992	13:研究ノート	B02.電気めっき・電鍍	ニッケル、磁場効果、初期電析、走査型トンネル顕微鏡(STM)
4719	光熱硬化を用いた金属電析物の熱波像	高上僚一,古賀正太郎,平田和洋,松永守央,細川邦典	43	6	614	1992	7:速報論文	A10.その他,B02.電気めっき・電鍍	光熱分光法、熱波
4720	水素吸蔵合金を用いた水素透過膜電極の試作と特性	釜崎清治,那須勇樹	43	6	616	1992	7:速報論文	A01.物理吸着	水素透過電極、金属水素化物、水素拡散
4721	巻頭言: 3.5歳を迎える北海道支部	古市隆三郎	43	7	623	1992	1:巻頭言	A10.その他	北海道支部、3.5歳、支部活動
4722	表面処理層の内部応力	田中啓介	43	7	624	1992	2:総説	A01.物理蒸着A02.溶射,B01.化学蒸着	内部応力、表面処理、X線回折、(表面)被覆
4723	イオンプレATING法により形成された皮膜の内部応力	遠藤隆士	43	7	630	1992	3:解説	A01.物理蒸着	イオンプレATING、薄膜、内部応力
4724	スパッタリングにより形成された薄膜の内部応力	馬来国粥	43	7	635	1992	3:解説	A01.物理蒸着	スパッタリング、内部応力、薄膜成長
4725	熱CVD法により形成された硬質膜の内部	木幡 護	43	7	641	1992	3:解説	B01.化学蒸着	内部応力、硬質被覆、熱CVD
4726	溶射皮膜の内部応力	戸部省吾	43	7	650	1992	3:解説	A02.溶射	溶射皮膜、残留応力、X線回折、ラメラ構造、不均一ひずみ
4727	無電解めっき皮膜の内部応力	岩松克茂,大塚邦顕,内藤 薫	43	7	656	1992	3:解説	B03.無電解めっき	内部応力、無電解めっき、ニッケル、パラジウム、銅
4728	電気めっきにより形成された皮膜の内部	金尾嘉徳	43	7	667	1992	3:解説	B02.電気めっき	内部応力、電気めっき
4729	塗膜の内部応力	佐藤忠明	43	7	671	1992	3:解説	A05.塗布・塗装	有機塗膜、内部応力、付着、熱収縮力、ガラス転移温度
4730	公衆表示用電気泳動表示素子の開発	外山二郎	43	7	679	1992	3:解説	A06.泳動電着	電気泳動表示素子、染料変色、パネル構造、非発光表示素子
4731	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(2.5) - 走査型電子顕微鏡によるシリコン表面の電子ステップ構造観察	本間芳和	43	7	683	1992	3:解説	A10.その他	走査型電子顕微鏡、原子ステップ
4732	レーザープレATINGによる金の微細パターン形成	牧野英司,矢崎 建,石井 遊,柴田隆行,池田正幸,天日勝也,千田厚生,高野良比古,中川卓二	43	7	689	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍,B09.その他	レーザープレATING、金、微細パターン、アルゴンイオンレーザー
4733	無電解めっきによるインジウム皮膜の形成	千田厚生,高野良比古,中川卓二	43	7	694	1992	5:原著論文	B03.無電解めっき	無電解めっき、インジウム皮膜、イリジウム合金皮膜、三塩化チタ
4734	アルミニウムめっき鋼板の耐食性・耐熱性改善に及ぼすTi中間層の効果	影近 博,木部 洋	43	7	700	1992	5:原著論文	A01.物理蒸着	耐食性、高温酸化、アルミニウムめっき鋼板、チタン被覆、二層被
4735	n-ブチルベンゼン蒸気とクリプトンガス吸着による多孔質アルミニウム陽極酸化皮膜孔径の決定	野中 昭	43	7	706	1992	5:原著論文	A04.吸着,B07.アノード酸化	多孔質アルミニウムメンブレン、イオン構造、電気透析、タンニン酸、プラス電荷
4736	定電位電解法による硫酸塩浴からのZn-Co合金電析	田淵 誠,津留 豊,松永守央,細川邦典	43	7	712	1992	7:速報論文	B02.電気めっき	Zn-Co合金、定電位電解法、アノード溶解法、結晶構造
4737	プラス電荷を中和したアノード酸化アルミナメンブレンによるイオンの透過	黒田孝一	43	7	714	1992	7:速報論文	B07.アノード酸化	多孔質アルミニウムメンブレン、イオン構造、電気透析、タンニン酸、プラス電荷
4738	マイクロ波プラズマCVD法による遷移金属基板へのダイヤモンド合成	高谷松文,金 曾孫,鈴 裏司,入江晃士,小林美紀,中澤育子,吉原佐知雄,斎藤哲男,佐藤栄一	43	7	716	1992	7:速報論文	B01.化学蒸着	ダイヤモンド合成、MWCVD、遷移金属基板
4739	アコースティックミッション法による無電解Ni-Bめっき皮膜の密着性の評価	金野英隆,潮川里奈,佐伯 功,古市隆松,坂菊生,市島真司,竹内 学,榎井正	43	7	718	1992	7:速報論文	B03.無電解めっき	無電解めっき、Ni-B、アコースティックミッション、密着性
4740	電解析出法によるAl-Yb混合酸化物皮膜の形成	金野英隆,潮川里奈,佐伯 功,古市隆松,坂菊生,市島真司,竹内 学,榎井正	43	7	720	1992	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍,B09.その他	カソード析出、硝酸塩還元、酸化物被覆、活性元素、高温酸化
4741	GDS放電発光分光法による塗装鋼板表面の深さ方向元素迅速分析	松坂菊生,市島真司,竹内 学,榎井正	43	7	722	1992	7:速報論文	A05.塗布・塗装	GDS、有機塗膜、亜鉛、プレーコート金属
4742	巻頭言: 先の先を広く読み取ろう	松本誠臣	43	8	733	1992	1:巻頭言	A10.その他	日本経済、理工系大学、先の先を読む
4743	心臓代用弁材料の表面処理	勇田敏夫,菊田幸明	43	8	734	1992	3:解説	C01.機械研削B01.化学蒸着,A01.物理蒸着	心臓代用弁、バイロライトカーボン
4744	生体用金属材料の表面処理とその効果	埴 隆夫	43	8	739	1992	3:解説	A10.その他	生体適合性、生体適合材料、生体用金属材料、表面処理、生体適合性
4745	歯科用接着性レジンの貴金属合金の接着を強固にするための金属表面改質法	大野弘機,松田浩一,日景 盛	43	8	744	1992	3:解説	A10.その他	表面改質、貴金属合金、歯科用接着性レジン
4746	医療分野に応用する炭酸ガスレーザー光用細径伝送路の製作	加藤祐次,宮城光信	43	8	750	1992	3:解説	A05.塗布・塗装	炭酸ガスレーザー(CO2)、中空伝送路(中空動波路)、医療応用
4747	人工心臓の表面処理	山家智之,仁田新一	43	8	755	1992	3:解説	A05.塗布・塗装	人工心臓、補助人工心臓、表面処理、血栓生成
4748	マイクロバイオセンサ	末永智一	43	8	759	1992	3:解説	A10.その他,B08.化成処理,C04.電気メッキ,C02.その他	マイクロバイオセンサ、マイクロ電極、細胞内測定、マイクロマシン技

4749	神経細胞の成長方向制御	川名明夫	43	8	764	1992	3:解説	A10.その他	細胞培養,成長方向制御,神経回
4750	歯科材料の表面とその評価	堀内 孝,橋本弘一	43	8	769	1992	3:解説	A10.その他	歯科材料,メタルボンドホーセレン,表面処理,結合機構,接着機構
4751	放射光による材料の評価分析技術	飯田厚夫	43	8	774	1992	3:解説	A10.その他	シンクロトロン放射,材料評価分析,X線分析,X線分光,X線回折
4752	Zn - Fe系合金の投射によるメカニカルブレーティング	逢坂智博,長野泰久,渡辺正次	43	8	779	1992	6:技術論文	C01.機械研磨,C07.その他	Zn-Fe系合金,熱処理,附着量
4753	フッ化水素ガスセンサ用Pt - O薄膜電極の作製	中野信夫,石地 徹,岡本昭夫,鈴木義彦,小川倉一	43	8	785	1992	5:原著論文	A01.物理蒸着	Pt-O薄膜,反応性パツタ法,HFガスセンサ
4754	回転円筒電極による銅めっきの研究	アプライティ,アブリミティ,松永守央,津留 豊,細川邦典	43	8	789	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	銅電析,回転円筒電極,攪拌,モルホロジー,優先配向
4755	アルミニウムのアノード酸化によるコバルトブルー - 皮膜	三田郁夫,小玉英俊,山崎 猛	43	8	794	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	アルミニウム,アノード酸化,電析,コバルトブルー皮膜
4756	陽極酸化多孔質アルミナを母型とする高分子多孔性薄膜の作成	益田秀樹,西尾和之,馬場宣良	43	8	798	1992	7:速報論文	A05.塗布・塗装	A04.アノード析出
4757	巻頭言:公設試(Kohsetushi)の役割	巻頭言:久米道之	43	9	805	1992	1:巻頭言	A10.その他	公設試,役割
4758	B系酸化物高温伝導材料	前田 弘	43	9	806	1992	3:解説	A10.その他	酸化物高温超伝導体,Bi-Sr-Ca-Cu-O,高Tc
4759	斜め蒸着媒体	篠原統一	43	9	813	1992	3:解説	A01.物理蒸着	MEテーパー,B析出,磁気記録
4760	STMによる微小腐食量の定量化	升田博之	43	9	818	1992	11:アカデミック研究会シリーズ	B02.電気めっき・電鍍	B09.その他
4761	シリコン気相成長に関するコンピュータ解	高田俊和	43	9	823	1992	11:アカデミック研究会シリーズ	A01.物理蒸着	A04.吸着
4762	投射メカニカルブレーティングの鉄核を有する鉄 - 亜鉛系投射材料の寿命	逢坂智博,長野泰久,渡辺正次	43	9	829	1992	6:技術論文	A10.その他	公設試,役割,酸化物高温超伝導体,Bi-Sr-Ca-Cu-O,高Tc
4763	無電解Ni-Cr合金めっき浴の検討	中山郁雄,府川 真,本間敬之,逢坂哲彌	43	9	835	1992	6:技術論文	B03.無電解めっき	MeV,イオン注入,Cr,熱処理,深さ分布
4764	化学蒸着法によって形成したガスタービン翼用高温耐食性NiAlコーティング	児島慶享,山口 静	43	9	839	1992	5:原著論文	B01.化学蒸着	NiAlコーティング,高温耐食性,化学蒸着,ガスタービン
4765	金属クロムにイオン注入された窒素の深さ分布に及ぼす熱処理の影響	寺島慶一,西山文隆,坂本浩基,広川健,木曾義之,松坂桑野三郎,真野 毅,沖 猛雄	43	9	844	1992	5:原著論文	B08.化成処理	Ti(C,N),イオンブレーティング,固溶体皮膜
4766	反応性イオンブレーティングによるTi(C,N)複合皮膜の形成について	青木公二,福田元保,鷹野 修	43	9	852	1992	5:原著論文	A01.物理蒸着	A10.その他
4767	無電解Co - Ni - P合金めっきの防食特性	小野田元伸,清水一夫,土屋武司,渡辺平平和政,不破章雄	43	9	857	1992	5:原著論文	B03.無電解めっき	無電解めっき,Co - Ni - P合金,防食
4768	電析法によるNi - Co - B非晶質合金の作成及び物性	日野 実,平松賢吾,西田典秀,平松 実,川崎仁士	43	9	862	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Ni - Co - B合金,電析,非晶質
4769	金めっき膜にタイする素地ニッケル結晶面の影響	日野 実,平松賢吾,西田典秀,平松 実,川崎仁士	43	9	868	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	金めっき,素地ニッケル,成長面,配向率
4770	硫酸浴からのZn - Co合金めっきの組成と耐食性	日野 実,平松賢吾,西田典秀,平松 実,川崎仁士	43	9	873	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Zn-Co合金電析,耐食性,硫酸溶液
4771	エチレンジアミン浴からのパラジウム - ニッケル合金めっきに関する研究(1) - 定電位電解法による研究	松永守央,原利久,アブリティ,津留 豊,細川邦典	43	9	878	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	パラジウム-ニッケル合金,定電位電析,エチレンジアミン,水素発生
4772	巻頭言:研究できる環境を	近江俊樹	43	10	899	1992	1:巻頭言	A10.その他	海洋構造物,表面技術
4773	"小特集/海洋構造物と表面技術"に寄せて	伊藤 叡	43	10	900	1992	1:巻頭言	A05.塗布・塗装	A07.ライニング
4774	チタンクラッド鋼による海洋構造物の防食技術	田所 裕,本間安二,長谷泰治	43	10	901	1992	3:解説	A05.塗布・塗装	A10.その他
4775	海洋構造物の防食ライニングの現状	若松富夫	43	10	907	1992	3:解説	A07.ライニング	ライニング,鋼構造物,重防食,塗装鋼板,溶融アルミニウムめっき鋼板
4776	塗装鋼板	福本博光	43	10	913	1992	3:解説	A03.溶融めっき	A05.塗布・塗装
4777	海洋構造物の防食システム	藤田正敏	43	10	921	1992	3:解説	A05.塗布・塗装	重防食塗装,耐候性塗装,飛沫帯,長橋梁
4778	ステンレス鋼の海洋構造物に対する重クロム酸塩系電解処理の適用	金子 智,佐藤義和	43	10	929	1992	3:解説	B08.化成処理	B09.その他
4779	酸性雨の生成 影響,監視及び対策	溝口次夫	43	10	937	1992	3:解説	C07.その他	ステンレス鋼,電解処理,重クロム酸(塩)溶液,耐食性,海水酸性雨,反応過程,長距離輸送,モニタリングネットワーク,塩化第二鉄,エッチング,スプレー,物質移動,速度論
4780	塩化第二鉄溶液のスプレーエッチング速度の解析	上田龍二,朝倉祝治,田野崎芳夫,杉日野 実,西田典秀,平松 実,米田理史,勝村宗英	43	10	946	1992	5:原著論文	C03.化学エッチング	電解エッチング
4781	Zn/Ni二層めっき皮膜の表層合金化に及ぼすCO2レーザー処理の影響	勝村宗英,篠田真人,西出利一,志智雄之,有田池田正樹,早川 林,西野 敦	43	10	952	1992	5:原著論文	A10.その他	B02.電気めっき・電鍍
4782	透明樹脂基板上へ形成したシリカ膜の密着性	篠田真人,西出利一,志智雄之,有田池田正樹,早川 林,西野 敦	43	10	957	1992	5:原著論文	B01.化学蒸着	硬質膜,プラズマCVD,透明樹脂,シリカ膜
4783	食塩水中のAl合金の耐食性に及ぼすフッ素樹脂アングラ - コート材のAl2O3 - TiO2及びNi - Crプラズマ溶射層の効果	千田厚生,高野良比古,中川卓二,本間英夫,加賀谷康永	43	10	962	1992	5:原著論文	A02.溶射	プラズマ溶射,耐食性,Al2O3-TiO2, Ni - Cr合金,PTFE樹脂
4784	無電解めっきによるカドミウム皮膜の形成	千田厚生,高野良比古,中川卓二,本間英夫,加賀谷康永	43	10	967	1992	5:原著論文	B03.無電解めっき	無電解めっき,カドミウム皮膜,硫化カドミウム皮膜,三塩化チタ
4785	電解併用無電解銅めっきの電流波形と均一析出性	水本省三,縄舟秀美,廣尾敬雄,張 蘊珊,芳賀正記	43	10	973	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	B03.無電解めっき
4786	エチレンジアミン錯体浴からの銅電析及び皮膜特性	水本省三,縄舟秀美,廣尾敬雄,張 蘊珊,芳賀正記	43	10	978	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	銅電析,エチレンジアミン錯体浴,Zn - ホールめっき力,機械的性質,結晶構造
4787	銅(II) - EDTA溶液からの銅電析に及ぼす静水圧の影響	吳 文昌,千葉 淳,中西和美	43	10	983	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	超音波,キャビテーション,静水圧,電析
4788	エチレンジアミン浴からのパラジウム - ニッケル合金めっきに関する研究(2) - 定電流パルス電解法による研究	松永守央,原利久,アブリティ,津留 豊,細川邦典	43	10	987	1992	13:研究ノート	B02.電気めっき・電鍍	パラジウム-ニッケル合金,定電流パルス電析,エチレンジアミン
4789	TiN被覆ステンレス鋼の耐食性	福島 誠,高沢貴久,男,岡田英敏,今井	43	10	990	1992	7:速報論文	A01.物理蒸着	ARE法,ステンレス鋼,TiN,窒素ガス流,耐食性
4790	アルミニウムの多孔質型/バリアー型複合アノード酸化皮膜の超薄切片観察	小野幸子,増子 昇	43	10	992	1992	7:速報論文	B07.アノード酸化	アルミニウム,アノード酸化皮膜,電解コンデンサー,TEM
4791	巻頭言:表面技術とコンピュータシミュレーション	小浦延幸	43	11	999	1992	1:巻頭言	A10.その他	B02.電気めっき・電鍍
4792	建物を演出する金属材料	櫻野紀元	43	11	1000	1992	2:総説	A05.塗布・塗装	A10.その他
4793	金属建材とアート	黒田孝一	43	11	1004	1992	2:総説	A05.塗布・塗装	A10.その他
4794	ステンレス鋼建材とその表面処理	中田潮雄	43	11	1009	1992	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	A10.その他
4795	チタン建材とその表面処理	佐藤廣士	43	11	1014	1992	3:解説	A01.物理蒸着	B07.アノード酸化

4796	アルミニウム建材の装飾的表面処理	山口 裕	43	11	1020	1992	3:解説		アルミニウム、アノード酸化、前処理、アノード酸化皮膜着色、立体的処理、局部的二重エッチング
4797	木目アルミニウム建材	川端 清	43	11	1031	1992	3:解説		アルミニウム、アノード酸化、建
4798	人工緑青銅板	玉野井英雄.杉山	43	11	1035	1992	3:解説		自然・人工緑青、色調制御、結晶
4799	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(26) - 多重内部反射赤外吸収法(MIR)によるシリコン表面の分析	長沢佳克	43	11	1040	1992	9:シリーズ-2	A10.その他	MIR,ATR,シリコン、シリコンの酸化物
4800	高周波マグネトロンスパッタリング法を用いたFe基板上への純Zn皮膜の結晶成長	兼松秀行.沖 猛雄	43	11	1047	1992	5:原著論文	A01.物理蒸着	スパッタリング、亜鉛皮膜、結晶配向性、モルホロジー、吸着抑制
4801	高濃度シアン化銀浴からの厚付け銀めっき	齋藤明夫.右田泰治	43	11	1053	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	炭酸カリウム、厚付け銀めっき、シアン浴、配向性、水素化カリウム
4802	酢酸エステル / 硫酸亜鉛水溶液界面に電析した亜鉛葉の形態	阪原 久.金児純征.泰松 育	43	11	1059	1992	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	金属葉、電析、界面成長、亜鉛、薄膜
4803	塩化第二鉄溶液によるスプレーエッチングの電気化学的計測	上田龍二.朝倉祝治.丁 志強.田野崎芳夫.杉浦猛雄.吉原佐知雄.武田香里.佐藤栄一.米盛隆一.内山郁夫.佐伯俊一	43	11	1065	1992	5:原著論文	C03.化学エッチング・電解エッチング	塩化第二鉄、エッチング、スプレー、限界電流、電気化学的測定
4804	アルミニウムの電解エッチング過程の光音響的手法による検討	阪原 久.金児純征.泰松 育	43	11	1070	1992	5:原著論文	C03.化学エッチング・電解エッチング	アルミニウム、DC、光音響
4805	アルミニウムのアルカリ性浴陽極酸化における塩素ならびに塩素酸イオンの影響	吉村長威.吉田 正	43	11	1073	1992	5:原著論文	B07.アノード酸化	アルカリ性浴アノード酸化、塩素イオン、塩素酸イオン、アノード酸化コーティング
4806	RFスパッタリング法によるTi-Ni水素吸蔵合金膜の作成	釜崎清治.岡島健一	43	11	1077	1992	7:速報論文	A01.物理蒸着	RFスパッタリング法、水素吸蔵膜、Ti-Ni合金
4807	水素チャージしたニッケル及び銅のはんだ付け性	新井 進	43	11	1079	1992	7:速報論文	B09.その他	電解水素チャージ、はんだ付性、メニスコグラフ、ニッケル、銅
4808	海外からのたより - アルゴン国立研究所に派遣されて	高橋節子	43	11	1081	1992	22:技術資料	A10.その他	コラム、海外からのたより、アルゴン国立研究所
4809	巻頭言:表面改質とイオン	沖 猛雄	43	12	1089	1992	1:巻頭言	A10.その他,B09.その他	イオンビーム、表面改質、パッシベーション
4810	特集"イオンビームによる表面改質とパッシベーション"に寄せて	沖 猛雄	43	12	1090	1992	22:技術資料	A01.物理蒸着A08.イオン注入A10.その他	特集によせて、イオンビーム、表面改質、パッシベーション
4811	表面改質と表面特性	本間禎一	43	12	1091	1992	3:解説		表面改質、表面特性、ドライプロ
4812	表面改質とイオンビーム技術	岩木正哉	43	12	1097	1992	3:解説	A01.物理蒸着A08.イオン注入A10.その他	表面改質、表面処理、イオンビーム、イオン注入、ミキシング
4813	金属窒化物層の組成及び耐食性	寺島慶一.松坂菊生	43	12	1103	1992	3:解説	A08.イオン注入	窒素イオン注入、銅、金属窒化物、耐食性、プリスター
4814	金属イオン注入による鉄鋼材料の表面改質	杉山賢司.佐々木純.林 和範.古市修身.荒木 純.札軒富	43	12	1109	1992	3:解説	A08.イオン注入	金属イオン注入、摩擦と摩耗、防食
4815	イオン注入した金属層の電気化学的性質 - サイクリックボルタンメトリーによる	高橋勝緒	43	12	1114	1992	3:解説	A08.イオン注入	イオン注入金属、電気化学的性質、サイクリックボルタンメトリー
4816	イオンビームスパッタ法薄膜によるパッシベーション	上條栄治	43	12	1119	1992	3:解説	A01.物理蒸着A08.イオン注入A10.その他	デュアルイオンビームスパッタリング、イオンビーム促進蒸着法、薄膜、表面改質
4817	ダイナミックミキシングによる耐熱性傾斜組成コーティング	児島慶享	43	12	1126	1992	3:解説	A01.物理蒸着A08.イオン注入A10.その他	ダイナミックイオンミキシング、傾斜機能材、耐熱性コーティング
4818	イオン注入とイオンビームミキシングによる摩擦特性の改善	平野元久	43	12	1132	1992	3:解説	A01.物理蒸着A08.イオン注入A10.その他	イオン注入、イオンビームミキシング、トライボロジー
4819	チタンの分極挙動に及ぼすTa,Ni複合イオン注入の影響	杉崎康昭.安永龍弘.佐藤廣士	43	12	1139	1992	5:原著論文	A08.イオン注入	イオン注入、Taイオン、Niイオン、チタン、分極挙動
4820	鉄表面の電気化学的性質に及ぼすO注入効果	藤花隆宣.岡部芳雄.高橋勝緒.岩木三尾.淳.棚木敏幸.岩木正哉	43	12	1146	1992	5:原著論文	A08.イオン注入	鉄表面、酸素イオン注入、電気化学的性質、微視的特徴
4821	Alイオン注入したNi基合金の高温酸化特性	戴 義生.川口年安.鈴木巧一.鈴木すすむ.山本 清	43	12	1151	1992	5:原著論文	A08.イオン注入	アルミニウム、イオン注入、Ni基合金、熱的酸化
4822	酸素イオン注入による重金属フッ化物ガラス耐水性の改善	戴 義生.川口年安.鈴木巧一.鈴木すすむ.山本 清	43	12	1155	1992	5:原著論文	A08.イオン注入	フッ化物ガラス、耐水性、イオン注入
4823	IVa及びVIa族遷移金属の水素吸収に及ぼす窒素イオン注入の影響	寺島慶一.関根一夫.鈴木博則.峰岸知弘.松坂菊生	43	12	1159	1992	5:原著論文	A08.イオン注入,B09.拡散皮膜	イオン注入、遷移金属、水素吸収、陰極水素チャージ、GDS
4824	窒化チタン / 窒化クロム多層膜の形成とその耐孔食性	大谷三郎.高木俊宣.柳 千裕	43	12	1168	1992	5:原著論文	A01.物理蒸着A08.イオン注入A10.その他	窒素イオン、多層、イオンビームミキシング、孔食、ステンレス鋼
4825	Ti蒸着膜に対するAr+イオンビームアシスト効果	鷹野一朗.松井和明.磯部昭二.野村	43	12	1172	1992	5:原著論文	A01.物理蒸着A08.イオン注入A10.その他	イオンビーム、アシスト蒸着、附着、Ti膜、ACイオンビーム
4826	イオンビームスパッタ法で作成したアモルファスNi-Ta-P膜の低濃度塩水電解での電極特性と膜質へのイオン照射効果	黒澤 進.飛田修司.林 常昭	43	12	1178	1992	5:原著論文	A01.物理蒸着A08.イオン注入A10.その他	イオンビームスパッタ法、イオン照射、イオン注入、非晶質Ni-Ta-P合金、薄膜
4827	イオンビームミキシングによる歯科インプラント用Ti-Ni形状記憶合金へのTiパッシベーション膜の作製	千田中成.藤沼明子.松浦正道.石川仁.吉成正雄.住井俊夫.井上 孝.下野伊藤由彦.伊藤明生.東 博純.日置辰中島昌一.小室勝博.近藤充夫	43	12	1184	1992	5:原著論文	A01.物理蒸着A08.イオン注入A10.その他	歯科インプラント、イオン注入、Ti-Ni合金、パッシベーション膜
4828	イオン注入によるAl合金の耐摩耗性改善	伊藤由彦.伊藤明生.東 博純.日置辰中島昌一.小室勝博.近藤充夫	43	12	1190	1992	5:原著論文	A08.イオン注入	イオン注入、Al合金、硬さ、摩耗
4829	イオン注入したAlNセラミックスの摺動摩擦特性	中島昌一.小室勝博.近藤充夫	43	12	1194	1992	5:原著論文	A01.物理蒸着A08.イオン注入A10.その他	AlN、イオンビームスパッタリング、イオン注入、摩耗
4830	Nイオン注入による切削工具材料の表層改質	金沢憲一	43	12	1199	1992	5:原著論文	A08.イオン注入	Nイオン注入、切削工具、高速度鋼、工具摩耗、超微小硬度計
4831	Heイオンビーム加工による表面粗さの改善	井上徳之.志真俊夫	43	12	1205	1992	5:原著論文	A10.その他	イオンビーム加工、表面粗さ、ブロッグゲ-ジ、Heイオン、表面処
4832	Cr板へのMeV窒素イオン多重注入(1) - 改質層の結晶性に対する注入基板温度の影響	西山文隆.吉田 智.坂本浩基.広川 健.木曾義之.寺島慶一.松坂菊生	43	12	1209	1992	5:原著論文	A08.イオン注入	MeVイオン注入、基板温度、深さ方向分析、RDS
4833	Cr板へのMeV窒素イオン多重注入(2) - N濃度プロファイルに対する熱処理効果	西山文隆.吉田 智.坂本浩基.広川 健.木曾義之.寺島慶一.松坂菊生	43	12	1216	1992	5:原著論文	A08.イオン注入	MeVイオン注入、クロム板熱処理、深さ方向分析、RBS
4834	IBED法によるC-BN膜形成におけるArイオンボンバードメントの効果	田辺信夫.飯島康裕.高山輝之.岩木宮川草児.池山雅美.斎藤和雄.中尾節男.丹羽博昭.種村誠太.宮川圭子	43	12	1223	1992	5:原著論文	A01.物理蒸着A10.その他	C-BN、薄膜、イオンビーム、析出ボンバードメント
4835	窒素イオン注入によるZrN層の形成と熱処理効果	美 斎藤和雄.中尾節男.丹羽博昭.種村誠太.宮川圭子	43	12	1230	1992	5:原著論文	A08.イオン注入	窒素イオン注入、ZrN、共鳴核反応法、微小硬度

4836	窒素イオン注入による固体表面の濡れ性の制御	上出雅男, 樋下田和也	43	12	1235	1992	13:研究ノート	A08.イオン注入	窒素イオン、濡れ性、接触角
4837	窒化チタンイオン薄膜の耐エロージョン特性	木内正人, 茶谷原昭義, 堀野裕治, 木野村淳, 空野由明, 藤井兼栄, 長坂浩志, 土屋直樹, 南吉夫, 三浦毅, 入江和隆, 渡喜久雄, 越智尚宏, 山本普一	43	12	1237	1992	7:速報論文	A01.物理蒸着, A10.その他	エロージョン、窒化チタン、イオンプレATING、ダイナミックイオンビームミキシング
4838	デュアルイオンビームミキシング装置の開発それを用いた炭素膜の作製	黒澤進, 寺門一佳, 松坂菊生	43	12	1239	1992	7:速報論文	A01.物理蒸着, A08.イオン注入, A10.その他	ダイナミックイオンミキシング、デュアルイオンビームミキシング装置、ダイヤモンドカーボン、イオンビーム、イオンビーム応用技術、イオン注入、イオンビームミキシング、特許
4839	特許情報よりみたイオンビーム応用に関する技術動向	里見豊	44	1	1	1993	1:巻頭言	A01.物理蒸着, A08.イオン注入, A10.その他	
4840	巻頭言: 1993年を迎えて	前田重義	44	1	2	1993	3:解説	B08.	アルミニウム、表面、界面、塗装、化成処理
4841	塗装性からみたアルミニウムの表面と界面	Prof. Dr. Ch. J. RAUB(訳)村横利弘	44	1	7	1993	9:シリーズ-2	B02.	電気めっきの歴史、電鍍
4842	電気めっきの歴史-19世紀におけるインターナショナルな展開の例	高橋忠昭, 阿部一浩, 吉原佐知雄, 佐	44	1	13	1993	5:原著論文	B02.	分散めっき膜、ニッケル、二酸化チタン、光電気化学
4843	Ni-TiO ₂ 分散めっき皮膜の光電気化学的挙動	前川英明, 明石和夫	44	1	17	1993	5:原著論文	A10.	プラズマ窒化、チタン、表面硬化、熱窒化、バイアス電位
4844	チタンの高周波プラズマ窒化	児嶋佳世子, 斎藤いばえ, 古澤寛子	44	1	22	1993	5:原著論文	B02.	等速電気泳動法、金属シアン化物イオン、金めっき液、銀めっき液、銅めっき液
4845	等速電気泳動法によるシアン化物めっき液の分析	倉内利春, 稲川幸之助	44	1	28	1993	5:原著論文	A10.	ZrC膜、カーバイドエミッター、活性化反応性蒸着
4846	活性化反応性蒸着によるZrC膜の形成	魏大維, 市野良一, 興戸正純, 沖猛雄, 津留豊, 高松亮太, 細川邦典	44	1	33	1993	5:原著論文	A03.	チタン薄膜、電析、熔融塩、パルス法、配向性、モルフォロジー
4847	熔融塩中のパルス法によるチタン薄膜の電析とその特性	伊崎昌伸, 片山順一, 榎本英彦, 小見崇, 中山豊	44	1	39	1993	5:原著論文	B02.	ホウ酸、ニッケル析出、ワット浴、pH緩衝、生成膜抵抗
4848	ワット浴からのニッケルめっきに及ぼすホウ酸の影響	新井進, 竹本正, 水谷正海, 征矢隆	44	1	44	1993	5:原著論文	B02.	Ni-Al複合膜、加熱、相構造、Ni3Al
4849	Ni-16mol% Al複合電析膜の組織に及ぼす加熱の影響	井上博之, 山川宏二, 正木征史	44	1	50	1993	5:原著論文	B02.	はんだ付性、メニスコグラフ、ニッケル電析、過剰電流密度、ニッケル中の水素含有率
4850	過剰電流密度で形成したニッケルめっきのはんだ付性	本間英夫, 高井英次, 小林健	44	1	55	1993	5:原著論文	B02.	銀めっき、銀-ヨウ化カリウム浴、HBPSA、回ディスク電極、非無電解はんだめっき、置換めっき、はんだ付性
4851	ヨウ化カリウム浴からの銀の電析機構	竹林恭志, 熊谷和彦, 吉原佐知雄, 佐藤栄一, 千葉淳日野実, 平松賢吾, 平松実, 川崎仁士, 小谷勇	44	1	60	1993	4:技術解説	B03.	ニッケル、磁場効果、初期電析、光音響分光法
4852	無電解はんだめっきの皮膜特性	Zn-Co合金めっき皮膜の耐亜硫酸ガス腐食特性	44	1	67	1993	7:速報論文	B02.	Zr-Co電析、腐食抵抗、SO ₂ ガステスト
4853	ニッケル初期電析に及ぼす磁場の影響-光音響的手法による観察	中山鶴雄, 山崎典宗	44	1	69	1993	7:速報論文	B03.	樹脂粉末、金属被覆、前処理、高速気流中衝撃
4854	Zn-Co合金めっき皮膜の耐亜硫酸ガス腐食特性	佐藤敏彦	44	2	77	1993	1:巻頭言	*	*
4855	樹脂粉末の金属被覆における高速気流中衝撃処理の効果	佐藤敏彦	44	2	78	1993	*	*	*
4856	巻頭言: 貸借対照表を勉強中	松井茂雄	44	2	79	1993	3:解説	C06.	評価方法、洗浄力
4857	"小特集/環境保全と洗浄技術"に寄せて代替洗浄技術の評価項目と評価方法の標準化	鳥居迪明	44	2	85	1993	3:解説	C06.	新ナフテン系金属洗浄剤、プラスチック、フランクロー、半導CFCs、エタン代替、超音波洗浄、キャビテーション、水水系洗浄剤、アルカリ洗浄剤、環境安全性、操業安全性
4858	フロン・トリクロロエタン代替洗浄剤-新ナフテン系炭化水素溶剤を中心に	柴野佳英	44	2	92	1993	3:解説	C06.	CFC代替、HCFC洗浄剤
4859	水を利用した超音波洗浄機	河野武司	44	2	98	1993	3:解説	C06.	無洗浄、フラックス残さ、清浄度、信頼性、PWB
4860	アルカリを使用した洗浄技術-フロン・エタン代替水系洗浄剤について	山辺正顕	44	2	102	1993	3:解説	C06.	電子励起脱離法、ESDシリコン、水素終端、水素吸着、マイクロチャンネルプレート、MCP、飛行時
4861	代替フロンを使用した洗浄技術	山口政義	44	2	108	1993	3:解説	C06.	MeVイオン注入、硬度、固溶度、表面改質
4862	プリント配線板の無洗浄技術	金丸辰也	44	2	115	1993	3:解説	A03.	PVD, アルミニウム膜、配向性、モルフォロジー、吸着インヒビション
4863	二層合金化熔融亜鉛めっき鋼板の開発シリーズ/表面物性評価技術-表面状態の解析(27)-電子励起脱離法による固体表面の動的観察	上田一之	44	2	120	1993	9:シリーズ-2	B07.	スズ-ニッケル合金、腐食抵抗、熱拡散処理
4864	Ni-Cu基板に対するCのMeV注入による表面硬化のメカニズム	熊谷正夫, 齋藤英純, 佐藤学, 樋下田和也, 本並義弘, 吉田云一, 佐藤守	44	2	125	1993	5:原著論文	A08.	電気めっき、サージェント浴、水素共析、内部応力、ひずみゲージ
4865	PVD法によるAl薄膜の結晶配向性とモルフォロジー	長谷川恭孝, 李明勳, 興戸正純, 沖猛雄, 高谷松文, 鈴裏司, 大川広衛	44	2	131	1993	5:原著論文	A01.	金属アルミニウム洗浄、1,1,1-トリクロロエタン、有機系腐食抑制剤、腐食抑制機構
4866	Pb-Sn-Cuスパッタ膜の摩擦・摩耗	西羅正芳, 山岸憲史, 鷹野修	44	2	136	1993	5:原著論文	A10.	孔食、pH, 腐食電位、皮膜破壊電位
4867	無電解Ni-P-PTFE複合めっき皮膜の摩擦・摩耗特性	千田厚生, 高野良比古, 中川卓二	44	2	140	1993	5:原著論文	B03.	スズ-ニッケル合金、腐食抵抗、熱拡散処理
4868	無電解Ni-P-PTFE複合めっき皮膜の摩擦・摩耗特性	吉村長威, 覚野博司	44	2	151	1993	5:原著論文	B07.	光音響法、複合めっき膜、ニッケル、ダイヤモンド、腐食抵抗
4869	無電解めっきによるピスマス皮膜の形成	野口駿雄, 吉村長威, 谷川精志	44	2	156	1993	5:原著論文	B07.	
4870	反復高電流瞬間通電によるアルミニウムの酸性陽極酸化	津野豊, 河野誠, 細川邦典	44	2	161	1993	5:原著論文	B02.	
4871	有機アルカリ性浴(ヒドラジン-フッ化物基液)中でのアルミニウムの陽極酸化における有機酸塩添加の効果	安川三郎, 安田守宏, 渡部清一	44	2	167	1993	5:原著論文	C03.	
4872	クロムめっき初期の残留ひずみに及ぼす下地金属の影響	山田豊, 世利修美, 田頭孝介, 永田公二, 吉村昭三, 尾崎治一, 縄舟秀美, 水本省三, 園田司	44	2	172	1993	5:原著論文	B09.	
4873	1,1,1-トリクロロエタンによるアルミニウムの溶解反応に対する有機試薬の阻害機構	高橋忠昭, 蓬田秀幸, 吉村俊一, 吉原佐知雄, 佐藤栄一, 渋谷敦義	44	2	179	1993	7:速報論文	B02.	
4874	ホスホン酸系溶液中におけるCuの孔食に及ぼすpHの影響	巻頭言: 泥臭さとスマートさ	44	3	185	1993	1:巻頭言		
4875	熱拡散法により作製したスズ-ニッケル合金皮膜の耐食性								
4876	ニッケル-ダイヤモンド複合めっき皮膜の腐食に伴うカラー変化-光音響的手法による評価								
4877	巻頭言: 泥臭さとスマートさ								

4879	機能性ガラスと表面技術	河原秀夫 大工原茂樹,世田博	44	3	186	1993	2:総説	A10.	新しいガラス、表面改質、薄膜
4880	光学部品への薄膜形成	国,大本 稔	44	3	190	1993	3:解説	A01	光学薄膜、光学部品、真空蒸着
4881	ガラス表面のエッチング/リーチング処理	虎溪久良	44	3	195	1993	3:解説	C03	エッチング、溶出、反射防止、中性溶液
4882	自動車における機能性ガラス	川崎英二	44	3	199	1993	3:解説	B05	窓ガラス、自動車、ガラスの安全性、快適性
4883	フッ酸によるガラスの表面処理	保坂達哉,菊池典生	44	3	205	1993	3:解説	C03	ガラス、ソングレア、フラットパネルディスプレイ、化学処理、フッ着色、ガラス
4884	ガラスへの着色	森津幸和	44	3	209	1993	3:解説	B09	エッチング、ガラス
4885	装飾用エッチングガラス	石井克夫	44	3	214	1993	3:解説	C03	エッチング、ガラス
4886	無電解ニッケル - 鉄合金めっきの浴条件と析出速度	堀口慎一,菅野正治,本間英夫	44	3	217	1993	6:技術論文	B03.	ニッケル - 鉄合金めっき、安定性、錯化剤、還元剤
4887	窒素イオン注入した浸炭焼入れ鋼及び調質鋼のすべり摩耗特性	寺島慶一,香田浩之,竹内栄一	44	3	221	1993	5:原著論文	A10.	窒素イオン注入、浸炭鋼、焼入れ鋼、耐摩耗、窒化鉄
4888	ビニル系単量体による電解重合膜の成長機構と被覆金属の耐食性の相関	湯浅 真,杉本 卓,関根 功	44	3	230	1993	5:原著論文	B09	電解重合、電解重合膜、成長機構、被覆金属、腐食抵抗、ビニル系単量体
4889	めっき法による高性能電磁波シールド紙の作製	斎藤哲男,入江晃土,佐藤栄一,戸室康二,桑名朗久	44	3	237	1993	5:原著論文	B03.	電磁波シールド、無電解Ni-Bめっき、ろ紙、活性化処理、電解銅めっき
4890	エチレンジアミン浴からのパラジウム - ニッケル合金めっきに関する研究(3) - 非対称交流電解法による研究	アフライトイ,アフリティ,松永守央,津留 豊,細川邦典	44	3	242	1993	5:原著論文	B02.	パラジウム-ニッケル合金、非対称交流めっき、クラックフリー、平滑、光沢
4891	高速低シアン銀めっき浴の電気化学的挙動	若林信一,竹内昌子,中沢昌夫,金子紀男,根津弘幸	44	3	247	1993	5:原著論文	B02.	銀電析、セレンシアン酸塩、低シアン浴
4892	高速低シアン銀めっき浴の析出膜特性	若林信一,竹内昌子,中沢昌夫,金子紀男,根津弘幸	44	3	254	1993	5:原著論文	B02.	銀電析、セレンシアン酸塩、ジェットめっき
4893	スプリング用素材の表面処理工程における水素量と遅れ破壊との関係	石島健治,上野晴巳,村上晴久,中嶋和夫,秋沢 勝,佐藤武井 厚	44	3	260	1993	5:原著論文	B02.	酸洗浄、ベーキング、表面処理、熱処理、遅れ破壊
4894	巻頭言: METEC '93 へのお誘い	*	44	4	269	1993	1:巻頭言	*	
4895	[I] 大学・高専・高等学校・中学校など	*	44	4	270	1993	14:データ	*	大学、高専、研究者、研究開発
4896	[II] 国公立研究機関	*	44	4	282	1993	14:データ	*	国立試験研究機関、研究者、研究開発動向
4897	[III] 技術事務所	*	44	4	288	1993	14:データ	*	技術事務所、研究者、研究開発
4898	[IV] 企業	*	44	4	288	1993	14:データ	*	企業、研究者、研究開発動向
4899	駒沢工業(株)	*	44	4	307	1993	14:データ	C06.	スプレー、ブース、ろ過、逆洗、脱液、回収
4900	(株)三進製作所	*	44	4	308	1993	14:データ	B02.	塑性加工、プレス、深絞り板金加工、表面処理、カラスステンレス、カラーチタン
4901	(株)東陽理化学研究所	*	44	4	309	1993	14:データ	C07.	脱脂、水洗、超振動
4902	日本テクノ(株)	*	44	4	310	1993	14:データ	C06.	
4903	(株)ハイテクノ	*	44	4	311	1993	14:データ	*	
4904	メルテックス(株)	*	44	4	312	1993	14:データ	B03.	無電解複合ニッケルめっき、PTFE潤滑性、離型性、非粘着性ろ過器、高温めっき、耐熱性、耐薬品性
4905	(株)山本鍍金試験器	*	44	4	313	1993	14:データ	B02.B03.	硬質クロムめっき、亜鉛合金めっき、電磁波シールドめっき、プラスチックめっき
4906	吉野電化工業(株)	*	44	4	314	1993	14:データ	B02.B03.	チタン合金、窒化、時効処理
4907	Ti - 15Mo - 5Zr - 3Al合金の表面改質 - 溶体化過程におけるイオン窒化	百瀬 治,源馬国恭,岸 和弘,河上 護	44	4	315	1993	5:原著論文	B06.	アルミニウム、イオン窒化、グロー放電
4908	アルミニウムのイオン窒化挙動に及ぼす窒化条件の影響	大刀川英男,新井透	44	4	320	1993	5:原著論文	B06.	微細構造、電気抵抗、無電解ニッケル、アニオン種、pH
4909	無電解Ni皮膜の微細構造及び電気抵抗に及ぼすニッケル塩水溶液のアニオン種及びpHの影響	元根正晴	44	4	326	1993	5:原著論文	B03.	金めっき、非対称正弦波、ピンホール、有孔度
4910	非対称正弦波による金の電析	斎藤いほえ,吉田裕道,上野武司,鶴澤幹夫	44	4	330	1993	5:原著論文	B02.	ニッケル電析、過剰電流密度、硬度、優先配向、水素含有率
4911	過剰電流密度で電析したニッケル皮膜	新井 進	44	4	336	1993	5:原著論文	B02.	水素透過電流、ジンケート浴、塩化亜鉛 - 塩化アンモニウム浴、硫酸亜鉛浴
4912	亜鉛めっきにおける鋼への水素侵入	斎藤明夫,アフィイ,セ介	44	4	341	1993	5:原著論文	B02.	没食子酸、軟鋼、中性溶液、腐食抑制剤
4913	中性水溶液中での没食子酸による軟鋼の腐食抑制	柴田芳昭,城元孝之,湯浅 真,関根功,今濱敏信,和氣山田 豊,世利修美	44	4	347	1993	5:原著論文	C07.	カルシウム硬度、孔食、腐食電位、皮膜破壊電位
4914	ホスホン酸系溶液中における鋼の孔食に及ぼすCa濃度の影響と孔食のモニタリング	田頭孝介,永田公二,近藤一雄,津留 豊	44	4	353	1993	5:原著論文	C07.	複合めっき、分散粒子、拡散層、電解槽
4915	硫酸亜鉛浴からのアルミナ複合めっきにおける拡散層の平均厚み	松野儀三,細川邦典,山田隆裕	44	4	357	1993	5:原著論文	B02.	クロムめっき、水素発生、内部応力、ニッケル基板、電極電位
4916	クロムめっき膜の残留ひずみに及ぼすニッケル基板と水素共析反応の影響	津留 豊,河野 誠,細川邦典	44	4	360	1993	5:原著論文	B02.	ニッケル、無電解めっき、磁場効果、光音響分光法
4917	無電解ニッケルめっきに及ぼす磁場の影響 - 光音響的手法による観察	竹林恭志,金野雄祐,吉村俊一,吉原佐知雄,佐藤栄一	44	4	363	1993	7:速報論文	B03.	無電解めっき、電解、CoP合金、磁気特性、微細構造
4918	軟磁性無電解CoP薄膜の磁気特性と微細構造に及ぼす電解の影響	松原 浩,鶴 - 弘,山田明文	44	4	365	1993	7:速報論文	B03.	無電解銅めっき、トリエタノールアミン、加速剤、加速、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン
4919	TEA無電解銅めっきにおける加速剤 - 水酸基効果	近藤宏司,小島克明,石田信正,入江正浩	44	4	367	1993	7:速報論文	B03.	
4920	巻頭言: 国際交流	後藤安邦	44	5	393	1993	1:巻頭言	*	
4921	電流波形制御の理論と電気めっき及び陽極酸化処理への応用	馬場宣良	44	5	394	1993	9:シリーズ-2	B02.B07.	電流波形、パルス、PRめっき、陽極酸化、着色
4922	非シアン銀めっき浴の開発	井上博之,山川宏二,正木征史	44	5	402	1993	3:解説	B02.	非シアン銀めっき浴、ヨウ化カリウム浴、HBPSA
4923	メカニカルブレイキング用投射材料の粉化特性	逢坂智博,長野泰久,渡部正次	44	5	407	1993	6:技術論文	A10.	粉化特性、磁選分離、粒径分布、析出物の密度
4924	TiNコーティング膜の構造に及ぼす熱処理の影響	内山休男,羽坂雅之,小林和夫,松竹寛康,馬場恒明	44	5	413	1993	5:原著論文	A10.	TiNコーティング、RF - イオンのレーティング、構造、熱処理、配向

4925	無電解NiReP合金皮膜の電気抵抗特性と構造に及ぼす熱処理効果	川口 純, 府川 真, 石井賢哉, 逢坂哲彌	44	5	418	1993	5:原著論文	B03.	無電解, NiRePめっき, 電気抵抗特性, アモルファス膜, 膜構造, 結晶化プロセス	
4926	次亜リン酸塩還元剤とエチレンジアミン錯体浴からの無電解Pd-P合金めっきの物質収支及び析出機構	水木省三, 縄舟秀美, 西川憲以, 芳賀正記, 内田 衛	44	5	425	1993	5:原著論文	B03.	無電解めっき, Pd-P合金, 次亜リン酸塩, 物質収支, 析出機構	
4927	電析法による非晶質Fe-Cr-Ni-P合金膜の作製とその分極挙動	李明, 傅 燕雲, 小若正倫	44	5	430	1993	5:原著論文	B02.	電析, アモルファス, Fe-Cr-Ni-P合金, 分極挙動	
4928	TiNで被覆した軟鋼の食塩水中での腐食摩耗について	棚木敏幸, 湯浅 真, 関根 功	44	5	434	1993	5:原著論文	A10.	イオンプレートイング, TiN, 軟鋼, 腐食摩耗, ガルバニック腐食	
4929	常温型溶融塩浴を用いるCu(I)イオンからのCuの電析	小浦延幸, 岩井正行, 上田耕一郎, 鈴安田守宏, 渡部清一, 石井将和, 安川 三郎	44	5	439	1993	5:原著論文	A03.	銅, 電析, Cu(I)イオン, 常温型溶融	
4930	1.1.1-トリクロロエタンによるアルミニウム溶解の抑制剤に対する誘導期テストとスクラッチテストとの相関分析	石川 豊, 中道一郎	44	5	446	1993	5:原著論文	C06.	金属アルミニウムの洗浄, 1.1.1-トリクロロエタン, 有機系腐食抑制剤, 相関分析	
4931	電析非晶質Ni-Cr-P合金皮膜の耐食性	セラムック上へのZr及びZr合金皮膜の電析形成	石川 豊, 中道一郎	44	5	454	1993	7:速報論文	B03.	アルミニウム基板
4932	セラミック上へのZr及びZr合金皮膜の電析形成	河瀬 誠, 多田正行, 伊藤靖彦	44	5	452	1993	7:速報論文	B02.	Zrフィلم, Zr-Al合金皮膜, 溶融塩化物, セラミック上への電析	
4933	アルミニウム基板への無電解Niめっきにおける紫外線照射の効果	石川 豊, 中道一郎	44	5	454	1993	7:速報論文	B03.	UV光, 無電解めっき, ニッケル, アルミニウム基板	
4934	巻頭言:改善をサルから学ぶ	末武 博	44	6	465	1993	1:巻頭言	*		
4935	光露光微細加工技術の現状と将来	堀内敏行	44	6	466	1993	2:総説	C07.	LSI, 光露光微細加工技術, 光露光加工技術	
4936	ボジ型フォトレジストの高解像度の動向	浅海慎五, 逢坂哲彌	44	6	473	1993	3:解説	C07.	ボジ型フォトレジスト, 高解像, ノボラック樹脂, ナフトキノンジアジド, サブミクロン	
4937	微細加工用多層レジスト技術の現状と将来	生津英夫	44	6	478	1993	3:解説	C07.	レジスト, リソグラフィ, LSI	
4938	化学増幅型レジストの現状と将来	上野 巧	44	6	485	1993	3:解説	C07.	レジスト, 化学増幅, 触媒反応	
4939	パンプめっき用フォトレジストの現状	駒野博司	44	6	490	1993	3:解説	C07.	フォトレジスト, パンプ, めっき, ストレートパンプ, TAB	
4940	遷移金属酸化物薄膜の表面改質と半導体リソグラフィへの応用	馬場 守, 池田俊夫	44	6	495	1993	3:解説	A10.	遷移金属酸化物, 表面改質, リソグラフィ, 無機電子線レジス	
4941	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(28) - 高速原子衝撃二次イオン質	長井一敏	44	6	501	1993	9:シリーズ-2			
4942	Fe-Zn系投射材料によるメカニカルブレーティングに関する二, 三の実験	逢坂智博, 長野泰久, 渡辺正次	44	6	507	1993	6:技術論文	A10.	ダイアモンド膜, マイクロ波プラズマCVD, 光学特性, 透過率	
4943	マイクロ波プラズマCVDにより作製したダイヤモンド膜の光学特性	坂本幸弘, 高谷松文	44	6	513	1993	5:原著論文	B01.	ダイアモンド膜, マイクロ波プラズマCVD, 光学特性, 透過率	
4944	無電解スズめっきに関する研究 - SnCl2-KOH系無電解スズめっきの再生と管理	小谷野英勝	44	6	518	1993	5:原著論文	B03.	無電解めっき, スズ, 再生	
4945	電析法による非晶質Fe-Ni-P合金の作製	李明, 小若正倫	44	6	525	1993	5:原著論文	B02.	電析, Fe-Cr-Ni-P合金, アモルファス	
4946	電析Ni-Mo-W三元系非晶質合金めっき膜の作製と耐食性	松本雄行, 湯浅 真, 関根 功, 吉岡 修, 珍田 聡	44	6	530	1993	5:原著論文	B02.	電析, Ni-Mo-W合金, アモルファス三元系合金, 腐食抵抗	
4947	有機アルカリ性浴(プロピレンジアミン-フッ化物基液)中でのアルミニウムの陽極酸化における有機酸塩の効果	野口駿雄, 吉村長蔵	44	6	537	1993	5:原著論文	B07.	有機アルカリ性浴, アルミニウムの陽極酸化, プロピレンジアミン浴	
4948	ADC12アルミニウムダイカスト合金の硫酸溶液中におけるアノード酸化 - 皮膜生成挙動に及ぼす合金成分及び試料調整	高橋英明, 志賀康太, 渡辺啓一, 瀬尾 真浩	44	6	542	1993	5:原著論文	B07.	アノード酸化, アルミニウムダイカスト合金, 高周波誘導プラズマ発光分析, アノード酸化皮膜	
4949	選択酸化により作製したケイフッ化鉄薄膜の熱電特性	林原光男, 小柳阿佐子, 下屋敷重広	44	6	549	1993	7:速報論文	A01.	ケイ化鉄, 熱電特性	
4950	巻頭言:環境への優しさを考えた研究と教	白石振作	44	7	557	1993	1:巻頭言	*		
4951	プリント配線板の現状と将来	青木正光	44	7	558	1993	2:総説	*	プリント配線板, 銅めっき薄板, 表面実装, 回路の組み立て, 電	
4952	プリント配線板の製造法	上山宏治	44	7	566	1993	3:解説	*	プリント配線板, サブトラクティブ法, アディティブ法, マルチワイ	
4953	プリント配線板におけるめっきの前処理 - ブラックオキサイド処理, デスマア処理	崎辺 均, 木村昌志, 森川佳彦	44	7	573	1993	3:解説	B08.	プリント配線板, サブトラクティブ法, アディティブ法, マルチワイ	
4954	プリント配線板におけるめっき技術 - 無電解めっき	奥野和義	44	7	578	1993	3:解説	B03.	プリント配線板, 無電解めっき	
4955	プリント配線板におけるめっき技術 - 電気銅めっき	筑間光晴	44	7	583	1993	3:解説	B02.	ピロリン酸銅, 硫酸銅, PWB	
4956	プリント配線板におけるめっき技術 - はんだめっき	三浦武之, 清田 優	44	7	589	1993	3:解説	B02.	スズ-鉛, 電気めっき, プリント配線板	
4957	プリント配線板におけるエッチング技術	林 俊男	44	7	594	1993	3:解説	C02.	エッチングマシン, エッチャント, エッチャクター, エッチレート	
4958	無電解めっきを使用しないスルーホールめっき法	豊永 実	44	7	599	1993	3:解説	B03.	プリント配線板, ダイレクトプレートイング, 導電性ポリマー, PdS	
4959	表面実装への対応 - 無電解はんだめっき	三浦武之, 古平 滋	44	7	605	1993	3:解説	B03.	スズ-鉛, 置換めっき, SMT	
4960	プリント配線板における最近のめっき装置	岳村伸敏	44	7	609	1993	3:解説	B02, B03.	プリント配線基板, PLT, EQM	
4961	微粒電池ダイヤモンド砥石の作製及び研削性能	鈴木数夫, 佐藤金司, 横山俊雄	44	7	615	1993	6:技術論文	B02.	ダイヤモンドホイール, 電析, 微粒ダイヤモンド	
4962	MnO2を含むセルフクリーニングホーローの触媒特性に及ぼす水ガラスの添加効果	池田正樹, 木村邦夫, 渡辺善博, 西野小浦延幸, 渡辺邦洋, 山岸 武	44	7	621	1993	5:原著論文	A05.	セルフクリーニングホーロー, MnO2, 比表面積, 触媒特性	
4963	銅電析に及ぼすゼラチン及びCl ⁻ の影響	小浦延幸, 渡辺邦洋, 山岸 武	44	7	626	1993	5:原著論文	B02.	銅, 電析, ゼラチン, 塩化物イオン	
4964	銅電析皮膜の性質に及ぼす超音波照射の影響	千葉 淳, 吳 文呂, 中西和美	44	7	631	1993	5:原著論文	B02.	超音波効果, 銅, 電析, 流れ, 静水圧	
4965	亜硫酸金錯体からの金めっき	加賀谷康永, 本間英俊	44	7	638	1993	5:原著論文	B02.	金めっき, パンプ形成, 不均化反	
4966	電気化学プロセスによるチタンの表面窒化	後藤琢也, 多田正行, 伊藤靖彦	44	7	643	1993	7:速報論文	B09.	電気化学的窒化, 溶融塩, 硝酸イオン, 亜硝酸イオン, 窒化物イ	
4967	巻頭言:学会におけるセミナー - の役割	山下嗣人	44	8	653	1993	1:巻頭言	*		
4968	腐食研究の課題と新しい測定法	水流 徹	44	8	654	1993	11:アカデミック研究会シリーズ	B09.	腐食, その場測定, 水晶振動子	
4969	走査型振動電極による局部腐食のIn-Situ測定	石川雄一	44	8	660	1993	11:アカデミック研究会シリーズ	B09.	マイクロバランス, ケルビン法, インピーダンス, 腐食モニタリング	
4970	潤滑樹脂被覆鋼板のプレス成形性に及ぼすス樹脂物性の影響	鈴木幸子, 尾形浩行, 奥楚計造, 成瀬義弘, 大和康二	44	8	667	1993	6:技術論文	A05.	振動電極, 局部腐食, その場観測, 孔食, 隙間腐食	
4971	電解法による有機電解液からのY2O3膜及びY2O3:Eu()膜の生成	松田好晴, 今橋健二, 吉本信子, 森田昌行, 芳賀正記	44	8	672	1993	5:原著論文	B09.	プレス成形性, 引張強度, 伸び, ガラス転移温度, 摩擦係数	
									Y2O3, Y2O3:Eu(), バルス電解法, 有機電解質, 蛍光	

4972	プラズマ及びアーク溶射アルミニウム層の灯油燃焼特性に及ぼす効果	池田正樹, 鶴田邦弘, 西野 敦	44	8	678	1993	5:原著論文	A02.	プラズマ溶射, アーク溶射, 灯油粒子, 気化速度, 燃焼
4973	C3H8 - H2混合ガスによるTi - 6Al - 4V合金のプラズマ浸炭	金山信幸, 堀江 謙, 田辺俊夫	44	8	683	1993	5:原著論文	A10.	浸炭, チタン合金, グロー放電, 表面硬度, チタンカーバイド
4974	エチレンジアミン錯体浴からの電析銅皮膜の室温軟化	水本省三, 縄丹秀美, 廣尾敬雄, 芳賀	44	8	687	1993	5:原著論文	B02.	銅電析, エチレンジアミン浴, 結晶構造, 再結晶
4975	酸性溶液中における無電解Co - B合金皮膜の水素発生反応	江面郁子, 斎藤哲男, 佐藤栄一	44	8	692	1993	5:原著論文	B03.	無電解Co-Bめっき, カソード分極曲線, 交換電流密度, ターフェル直線の傾き
4976	超高压電子ビームによる金属溶射皮膜の改質	森本純司, 山口昭雄, 富江通雄, 阿部信行, 荒田吉明	44	8	695	1993	7:速報論文	A02.	フレーム溶射, 電子ビーム, マイクロピッカース硬度
4977	クロメート処理皮膜のEPMAによる状態分析	林 洋樹, 瀬上康司, 小泉宗栄	44	8	697	1993	5:原著論文	B08.	EPMA, クロメート皮膜, 状態分析
4978	Tiイオン注入による単結晶SiO2上への高密着性銀皮膜の作製	馬場恒明, 畑田留理子	44	8	699	1993	5:原著論文	A08.	銀, チタン, イオンプレATING, G, 密着, SiO2
4979	巻頭言:産学交流を考える	吉田 誠	44	9	707	1993	1:巻頭言	*	
4980	アーキオンプレATING膜の特性と工業的応用	河野通廣, 池永 勝, 市村博司	44	9	708	1993	3:解説	A10.	イオンプレATING, コーティング, 腐食, 耐磨耗性
4981	水溶液中における不均一金属表面の電位・電流分布	金児絃征	44	9	715	1993	3:解説	B09.	腐食モニタリング, ガルバニ腐食, 電位・電流分布
4982	陰イオン固定化材としての層状複水酸化物の化学	成田栄一	44	9	722	1993	3:解説	B09.	層状複水酸化物, ハイドロタルサイト類似化合物, インターカレーション, 固定化, アニオン
4983	カソード電流印加による電解コンデンサ用アルミニウム電極箔の溶解挙動に及ぼすフーリエ変換赤外全反射(FTIR,ATR)法による無電解Ni - P合金めっき浴のIn-Situ	世利修美	44	9	729	1993	6:技術論文	C05.	アルミニウム, 電解コンデンサ, 局部アルカリ化
4984	還元剤浸透法による無電解ニッケル皮膜析出速度に及ぼす浴条件の影響	水本省三, 縄丹秀美, 西川憲以, 小橋元根, 正晴, 西村橋雄, 水畑 穰, 小黒啓介, 竹中啓示, 恭湯浅 真, 松本雄行, 増田昭裕, 糸内友一, 杉山 卓, 関根功, 吉岡 修, 珍田 李, 明, 小若正倫	44	9	732	1993	5:原著論文	B03.	FTIR, ATR, 無電解めっき浴, Ni-Pめっき, その場モニタリング
4985	還元剤浸透法による無電解ニッケル皮膜析出速度に及ぼす浴条件の影響	山田 豊, 世利修美, 田頭孝介, 永田公二, 沖 猛堆, 山崎陽太郎	44	9	737	1993	5:原著論文	B03.	無電解ニッケル膜, めっき速度, 浴条件, 浸透, 速度パラメーター
4986	有機酸系無電解はんだめっき浴での添加物の影響 - 錯化剤についての検討	増田昭裕, 糸内友一, 杉山 卓, 関根功, 吉岡 修, 珍田 李, 明, 小若正倫	44	9	742	1993	5:原著論文	B03.	はんだめっき, 置換めっき, 有機酸系浴, 添加剤, 錯化剤
4987	有機ホスホン酸浴からのFe - Ni - W合金めっき膜の構造と特性	山田 豊, 世利修美, 田頭孝介, 永田公二, 沖 猛堆, 山崎陽太郎	44	9	748	1993	5:原著論文	B02.	Fe-Ni-W合金, 電析, アモルファス, 硬度
4988	ホスホン酸系溶液中における銅の孔食に及ぼすCl ⁻ の影響	山田 豊, 世利修美, 田頭孝介, 永田公二, 沖 猛堆, 山崎陽太郎	44	9	753	1993	5:原著論文	B09.	孔食, SO4 ²⁻ , Cl ⁻ , 皮膜破壊電位, ATPM+BTA溶液
4989	巻頭言:表面技術と深い技術	山崎陽太郎	44	10	765	1993	1:巻頭言	*	
4990	"磁気記録媒体の現状と将来"に寄せて	山崎陽太郎	44	10	766	1993		*	
4991	めっき垂直記録媒体の高記録密度化	達坂哲彌	44	10	767	1993	3:解説	B03.	無電解めっき, 垂直記録, 磁気ディスク媒体, 磁気特性, 記録再スバツタ法, 記録媒体, 高密度記録, 保磁力, 低ノイズ
4992	スバツタ法による高密度磁気記録媒体	白 忠烈, 谷 典明	44	10	774	1993	3:解説	A01.	光磁気ディスク, MO, DCリアクティブスバツタ, 同時スバツタ
4993	光磁気ディスク用スバツタ装置	高城信二	44	10	780	1993	3:解説	A01.	Co-Cr, 磁気薄膜, 磁気記録媒体, 組成分離, 組成微細構造
4994	Co - Cr磁気記録媒体の組成分離構造	前田 安	44	10	785	1993	3:解説	A01.	トライボロジ, 薄膜ディスク, カーボン, 保護膜
4995	ディスク用カ - ボン保護膜のトライボロジ	山本尚之	44	10	790	1993	3:解説	B01.	めっき鋼板, 電気めっき表面処理, 化成処理, クレーター, 界面
4996	自動車用表面処理鋼板と界面制御技術	佐藤 登	44	10	795	1993	3:解説	A03.	光音響分光法, 光熱偏向法
4997	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(29) - 光熱変換分光法	澤田嗣郎	44	10	800	1993	9:シリーズ-2	A08.	光音響分光法, 光熱偏向法
4998	レーザーフラッシュ法によるZnめっき皮膜のエネルギー吸収率測定	日野 実, 平松 実, 秋山光一, 大森蕃三, 川崎仁士	44	10	807	1993	5:原著論文	B02.	亜鉛電析, レーザーフラッシュ法, 表面形態, エネルギー吸収率
4999	マイクロ波プラズマCVDによるダイヤモンド合成における遷移金属の影響	坂本幸弘, 高谷松文	44	10	811	1993	5:原著論文	B01.	ダイヤモンド, マイクロ波プラズマ, CVD, 遷移金属, 触媒
5000	ブフズマ重合により作製したヘキサメチルジシロキサン及びビニルメトキシシラン重合膜の特性	馬場恒明, 畑田留理子	44	10	817	1993	5:原著論文	B09.	ブフズマ重合, ヘキサメチルジシロキサン, ビニルメトキシシラン, 腐食抵抗
5001	無電解Ni - Sn - B合金めっきについて	青木公二, 鷹野 修, 佐々木由紀	44	10	821	1993	5:原著論文	B03.	無電解めっき, Ni-Sn-B合金
5002	無電解銅めっきの精密ろ過効果	小林 健, 本間英夫	44	10	826	1993	5:原著論文	B03.	無電解銅めっき, 連続精密ろ過, 異常析出, 長寿命化
5003	ガラスと無電解ニッケルめっきの密着性	堀田敏一, 鈴木佳司, 渡辺幹男, 本間	44	10	831	1993	5:原著論文	B03.	ガラス, 無電解ニッケルめっき, 初期皮膜形成, 密着強度
5004	プラズマ溶射で形成したA1203・TiO2及びA12O3 - TiO2系溶射層の表面特性と遠赤外線放射特性	池田正樹, 西野 敦	44	10	836	1993	5:原著論文	A02.	プラズマ溶射, 遠赤外線放射
5005	塗布型クロメートの乾燥温度による皮膜構造変化	須田 新, 荻野陸雄, 宮脇 憲, 前田重義	44	10	841	1993	5:原著論文	B05.	塗布型クロメート, 乾燥温度, 重合, 脱酸素反応
5006	活性金属ろう接によるジルコニアの変質層におけるジルコニウムと酸素の挙動	王 立録, 沖 猛堆	44	10	848	1993	5:原著論文	B09.	ジルコニア, 活性金属ろう接, 変質層, 結合状態
5007	浸炭焼入れ法によるチタン合金の表面硬化	前嶋正受, 猿渡光一, 平田昌範, 石禾和夫, 伊藤六郎, 戸嶋茂郎, 武田恭匡, 大瀧礼美, 山口小林繁夫, 津留壽昭, 柳ヶ瀬勉	44	10	853	1993	5:原著論文	B06.	チタン合金, 耐磨耗性, 表面硬度, 浸炭, 酸化
5008	電析によるNi - Mn / SiC複合金膜の作製	戸嶋茂郎, 武田恭匡, 大瀧礼美, 山口小林繁夫, 津留壽昭, 柳ヶ瀬勉	44	10	856	1993	7:速報論文	B02.	Ni-Mn/SiC, 電析, 複合金, 硬度
5009	電析法による非晶質Cr - Ni合金皮膜の作製	小林繁夫, 津留壽昭, 柳ヶ瀬勉	44	10	858	1993	7:速報論文	B02.	Cr-Ni合金, アモルファス, 異常共析
5010	巻頭言:柔らかな考え方	松田好晴	44	11	865	1993	1:巻頭言	*	
5011	マグネシウムの材料特性	小島 陽	44	11	866	1993	2:総説	*	マグネシウム, 機械的特性, マグネシウム合金
5012	マグネシウムの表面処理	高谷松文	44	11	874	1993	2:総説	B07.B08.	表面処理, ダイキャスト, 塗装, 腐食抵抗
5013	マグネシウム - アルミニウム鑄造合金の耐食性改良	Kemel-NISANCIOGLU-and-Otto-LUNDER(訳)小野幸	44	11	883	1993	2:総説	*	Mg-Al合金, ダイキャスト, 腐食抵抗, 電気化学的挙動, 表面酸化皮膜
5014	ダイキャスト用マグネシウム合金	牧野邦彦	44	11	890	1993	3:解説	*	マグネシウムダイキャスト
5015	SEMで見たマグネシウムの表面処理	斎藤 誠	44	11	895	1993	3:解説	B07.B08.	マグネシウム, 化成処理, 表面形態, SEM
5016	北米と日本におけるマグネシウムの普及と用途展開の相違	細田 耕	44	11	899	1993	3:解説	*	マグネシウムダイキャスト

5017	マグネシウム - その誕生とおいたち	寺島慶一	44	11	903	1993	3:解説	*	マグネシウム、歴史、発見、マグネシウム工業
5018	陽極酸化及びクロメート処理マグネシウム合金の耐食性	佐藤文博, 浅川義彦, 中山武典	44	11	912	1993	3:解説	B07.	マグネシウム合金、ダイキャスト、腐食挙動、表面処理
5019	マグネシウム合金の低公害性前処理	傍田 保, 川崎 功	44	11	915	1993	3:解説	B08.	マグネシウム合金、リン酸亜鉛皮膜処理、クロム非含有
5020	マグネシウム合金の陽極酸化処理とめっき処理	平井英次	44	11	917	1993	3:解説	B02.B07.	マグネシウム合金、陽極酸化処理、耐摩耗性
5021	マグネシウム合金上のめっきあれこれ	船田清孝	44	11	919	1993	3:解説	B02.	マグネシウム、電気めっき
5022	マグネシウムダイキャストの表面処理法	土橋 誠, 鈴木光夫	44	11	922	1993	3:解説	A05.B02.B07.B08.	化成処理、陽極酸化、めっき、マグネシウム
5023	マグネシウムダイキャストの粉体塗装	尾崎 正	44	11	925	1993	3:解説	A06.	マグネシウムダイキャスト、粉体
5024	超薄切片法によるマグネシウム陽極酸化皮膜の断面微細構造	小野幸子, 増子 昇	44	11	927	1993	3:解説	B07.	マグネシウム合金、陽極酸化皮膜、多孔質層、ウルトラマイクロトーム、マグネシウム合金、自動車用ホイール、ダイキャスト、表面処理、腐食抵抗
5025	自動車用マグネシウムホイールの表面処理	井藤忠男, 森田 彰	44	11	930	1993	3:解説	A05.	腐食抵抗
5026	YAGレーザー照射によるZn/Ni二層めっき皮膜表面層合金化の最適条件	日野 実, 西田典秀, 平松 実, 秋山光一, 勝村宗英	44	11	933	1993	6:技術論文	B09.	YAGレーザー、合金化、Zn-Ni合金皮膜
5027	硬質皮膜特性のチャージ間の違いを評価するスクラッチ試験と残留応力測定に関するイオン窒化法による銅合金の表面硬化	中沢洋二, 佐藤仁志, 浅見克敏, 杉山中田一博, 眞喜志隆, 塔本健次, 松田鈴木芳博, 高橋昭雄, 赤星晴夫, 和嶋元世, 奈良原俊和, 青木公二, 鷹野 修, 中田達也	44	11	938	1993	6:技術論文	A01.	スクラッチ試験、残留応力、硬質皮膜、チャージ
5028	イオン窒化法による銅合金の表面硬化	西羅正芳, 山岸憲史, 鷹野 修	44	11	944	1993	5:原著論文	A10.	窒化、プラズマ窒化、イオン窒化、表面硬化、銅合金
5029	触媒プロセスによる銅上への無電解ニッケルめっき膜の析出機構	鈴木芳博, 高橋昭雄, 赤星晴夫, 和嶋元世, 奈良原俊和, 青木公二, 鷹野 修, 中田達也	44	11	950	1993	5:原著論文	B03.	銅表面処理、無電解ニッケルめっき、プリント配線板、密着
5030	無電解Ni-Pd-P合金めっき皮膜の電気接点特性について	西羅正芳, 山岸憲史, 鷹野 修	44	11	957	1993	5:原著論文	B03.	無電解めっき、Ni-Pd-P合金、電気接点特性
5031	無電解Ni-B-Graphite複合めっき皮膜の作製とその特性	千田厚生, 森田一弘, 高野良比古	44	11	961	1993	5:原著論文	B03.	複合めっき、無電解ニッケルめっき、摩擦、摺動特性
5032	無電解めっきによるスズ皮膜の形成	千田厚生, 森田一弘, 高野良比古	44	11	966	1993	5:原著論文	B03.	無電解めっき、スズ皮膜、三酸化チタン、炭酸ナトリウム
5033	部分スズめっき鋼板上への金属クロム析出挙動の検討	森田順一, 吉田光男	44	11	972	1993	5:原著論文	B02.	電気スズめっき、カソード皮膜、カソード分極、定電位分極、水素過電圧
5034	Zn-Ni-SiO2分散めっき鋼板の共析挙動	高橋 彰, 三吉康彦, 羽田隆司	44	11	977	1993	5:原著論文	B02.	電気めっき、Zn,Ni,SiO2共析、複合
5035	通常濃度のシアン化銀浴からの厚付け銀めっき	斉藤明夫, 右田泰治	44	11	983	1993	5:原著論文	B02.	厚付け銀めっき、電気めっき、配向性、炭酸カリウム、水酸化カリ
5036	光沢ニッケルめっき膜表面の酸化膜特性とはんだぬれ性に及ぼす洗浄工程の影響	中岡康幸, 庄野友	44	11	988	1993	5:原著論文	B02.	ニッケルめっき表面、洗浄工程、酸化皮膜、はんだぬれ性
5037	食塩水中におけるTiN被覆軟鋼と無被覆軟鋼の腐食摩耗について	榎木敏幸, 湯浅 真, 関根 功	44	11	993	1993	5:原著論文	A10.	イオンブレーティング、TiN、軟鋼、腐食摩耗、ガルバニック腐食
5038	SUS304ステンレス鋼のHCl/エタノール及びNaCl/エタノール水溶液中における孔食特性	榎渡洋一郎	44	11	998	1993	5:原著論文		孔食、アノード分極、電位走査速度
5039	立方晶窒化ホウ素表面での燃焼炎法によるダイヤモンドエピタキシー	今林義考, 斎藤秀俊, 浦尾亮一, 小林美紀, 千葉和則, 中澤育子, 吉村俊一, 吉原佐知雄, 佐藤栄一, 陶村 貴, 阿部一浩, 小林達朗, 佐藤正寿, 吉原佐知雄, 佐藤栄一	44	11	1004	1993	7:速報論文	A10.	ダイヤモンド、立方晶BN、エピタキシー、燃焼炎法
5040	置換金めっき過程への水晶振動子マイクロバランス法の適用	則, 中澤育子, 吉村俊一, 吉原佐知雄, 佐藤栄一, 陶村 貴, 阿部一浩, 小林達朗, 佐藤正寿, 吉原佐知雄, 佐藤栄一	44	11	1006	1993	7:速報論文	B03.	水晶振動子マイクロバランス法、置換めっき、金
5041	W/0エマルジョンの相変化の光音響的手法による評価	山下嗣人, 林 武志	44	11	1008	1993	7:速報論文		W/エマルジョン、光音響的手法、相変化
5042	ニッケル-リン合金の電析反応過程	山下嗣人, 林 武志	44	11	1010	1993	7:速報論文	B02.	電極反応、Ni-P析出、アモルファス、回転電極法
5043	巻頭言: 表面技術協会誌の役割とこれからの課題	逢坂哲彌	44	12	1019	1993	1:巻頭言	*	
5044	エレクトロニクス部品材料における表面処理技術の展開と今後の課題	二瓶公志	44	12	1020	1993	2:総説	*	エレクトロニクス部品と材料、情報通信技術の動向、通信処理技術の動向、電子デバイスの動向、エレクトロニクス表面処理
5045	半導体への表面処理 - 金はんだパンブ	大塚寛治	44	12	1028	1993	3:解説	B02.	LSIウェハー上のめっき、金パンブ、はんだパンブ
5046	プラスチックパッケージ用リードフレームの表面処理	加藤凡典	44	12	1038	1993	3:解説	B02.	リードフレーム、プラスチックパッケージ
5047	樹脂封止半導体の接着性と信頼性	田畑晴夫	44	12	1044	1993	3:解説	A10.	エポキシ封止剤、接着力、耐湿性、耐はんだリフロー性、表面
5048	半導体パッケージアウターリードへの基板実装用はんだめっき	西村晴矢, 前嶋義久, 太田篤住	44	12	1049	1993	3:解説	B02.	
5049	スパーソルダ - によるプリコートソルダリング	小菅 泉	44	12	1057	1993	3:解説	A10.	スーパーソルダー、プリコートソルダリング、ファインピッチ
5050	ソルダ・インジェクション法による高密度基板パンブの作製	塚田 裕	44	12	1063	1993	3:解説	A10.	フリップチップ実装、表面ラミネーター
5051	コネクター材料の表面処理	下条武美, 安藤和臣	44	12	1068	1993	3:解説	B02.	金めっき、はんだめっき、パラジウムめっき
5052	超純水の製造技術と表面洗浄	今岡孝之	44	12	1074	1993	3:解説	C06.	超純水製造、表面洗浄、シリコンウェハー
5053	"特集 / 電子部品の表面処理"に寄せて	八木 裕	44	12	1078	1993	*企画趣旨	*	
5054	無電解銅めっき浴におけるPd(II)及びSn(II)イオンの作用機構	松岡政夫, 吉田泰樹, 岩倉千秋	44	12	1079	1993	5:原著論文	B03.	無電解銅めっき、延性、内部応力、拡散性水素、メチレングリコールアニオン
5055	無電解ニッケルによるアルミニウム上への直接回路形成	本間英夫, 小林 健	44	12	1084	1993	5:原著論文	B03.	無電解ニッケルめっき、置換反応、密着強度、パンブ形成
5056	無電解ニッケル系合金めっき皮膜の電気接点特性	青木公二, 鷹野 修, 高須一郎	44	12	1089	1993	5:原著論文	B03.	電気接点特性、無電解ニッケル合金めっき
5057	ラビングによるポリイミド薄膜の化学構造、帯電性、光電子放射特性の変化	百瀬義広, 萩野雅彦, 北村輝夫, 横倉久男, 沼田俊一	44	12	1094	1993	5:原著論文	*	ラビング、ポリイミド、XPS、表面電位、光電子放出
5058	無電解コバルト合金二層膜の結晶配向制御	本間敏之, 黒川義昭, 山本真由美, 達	44	12	1099	1993	5:原著論文	B03.	無電解めっき、磁気記録媒体、結晶配向性、二層膜
5059	B ₂ O ₃ を含まない研磨剤によるInP及びInSbの鏡面研磨	森沢祐二, 菊間 勲, 高山直紀, 竹内 学	44	12	1104	1993	5:原著論文	C01.	鏡面研磨、InP, InSb, 表面粗さ

5060	スパック法による酸化Ta ₂ O ₅ 薄膜の形成とそれによるMOS基板のプラズマ損傷	増井寛二 野村 毅 権 植浩	44	12	1108	1993	5:原著論文	A10.	スパッタリング、プラズマ損傷、酸化タンタル薄膜、MOS構造ダイオード、フラットバンド電位
5061	CoFe電着薄膜の磁気特性	篠浦 治.上島聡史	44	12	1114	1993	5:原著論文	B02.	軟磁性特性、電析CoFe膜、高飽和磁束密度、磁気異方性
5062	プリント配線基板用Cu箔作製工程における添加剤の効果	飯村修志.前田重之.吉原佐知雄.佐中西和美.橋高秀吉.弘永万一.常光幸美.柏原 智.林 安德	44	12	1119	1993	5:原著論文	B02.	銅箔、添加剤、PAS、ゼラチン、チオ尿素
5063	P(VDF/InSe)及びP(VDF・TFE)/InSe接合系の電気特性	吉 弘永万一	44	12	1123	1993	5:原著論文	A01.	PVDF,P(VDF・TFE),PVDF/InSe接合、InSe
5064	電析による磁性Co/Pt多層膜の作製	高井まどか.影山謙介.本間敬之.達板菅沼栄一.丹野裕司.伊藤 武.船越山賀賢史.吉野隆子.馬場宜良	44	12	1128	1993	5:原著論文	B02.	電析、反射電子顕微鏡、コバルト/白金多層膜、磁性人工超格子
5065	無電解CoB薄膜の軟磁気特性と微細構造	高井まどか.影山謙介.本間敬之.達板菅沼栄一.丹野裕司.伊藤 武.船越山賀賢史.吉野隆子.馬場宜良	44	12	1134	1993	5:原著論文	B03.	軟磁性薄膜、無電解めっき、微細構造
5066	塩酸溶液中の矩形波パルス電流エッチングで生ずるアルミニウムのビット形態と表化学析出法により作製したルテニウム化合物薄膜のエレクトロクロミック特性	菅沼栄一.丹野裕司.伊藤 武.船越山賀賢史.吉野隆子.馬場宜良	44	12	1138	1993	5:原著論文	C03.	アルミニウム、パルス電流エッチング、表面皮膜
5067	電析パラジウム-ニッケル-ホウ素合金の皮膜性状に及ぼすリン共析の影響	水木省三.縄丹秀美.岡田 隆.芳賀正珍.田 聡.吉岡 修.小泉良一	44	12	1143	1993	5:原著論文	B09.	エレクトロクロミック、ルテニウム化合物薄膜、化学析出
5068	電析パラジウム-ニッケル-ホウ素合金の皮膜性状に及ぼすリン共析の影響	水木省三.縄丹秀美.岡田 隆.芳賀正珍.田 聡.吉岡 修.小泉良一	44	12	1149	1993	5:原著論文	B02.	電析、Pd-Ni-P合金、リン共析、内部応力、耐食性
5069	パラジウムめっきリードフレームの熱処理後の特性	小泉良一	44	12	1154	1993	4:技術解説	B02.	パラジウムめっき、熱処理、はんだ付性、ワイヤボンディング性、
5070	無電解はんだめっきによる表面実装	久保元伸.上玉利徹.堀田輝幸.木曾雅之.内田廣記.大	44	12	1158	1993	4:技術解説	B03.	置換めっき型、はんだめっき、表面実装
5071	アルミニウム陽極酸化時の高電圧領域における挙動	立花和弘.松木健三	44	12	1164	1993	5:原著論文	B07.	アノード酸化、アルミニウム、サイクリックボルタモグラム、インピーダンス、ポテンショスタット
5072	有機酸系無電解はんだめっき浴での添加物の影響(2) - 界面活性剤及び酸化防止剤の検討	湯浅 真.斉藤正巳.糸内友一.松本雄行.関根 功.珍田聡.吉岡 修	44	12	1166	1993	5:原著論文	B03.	はんだめっき、置換めっき、有機酸系浴、界面活性剤、酸化防止剤
5073	亜リン酸塩を還元剤とする無電解Pd-P合金めっき皮膜のはんだ付け性及び接触イリジウム電析に及ぼす有機化合物の影響	芳賀正記.内田 衛.水木省三.縄丹秀美.斎藤由美子.来田勝継	44	12	1170	1993	5:原著論文	B03.	無電解Pd-Pめっき、亜リン酸塩、はんだ付け性、接触抵抗
5074	低リン含有の無電解ニッケル-リン合金めっき皮膜の電気接点特性	斎藤由美子.来田勝継	44	12	1173	1993	7:速報論文	B02.	イリジウム析出、有機化合物、電流-電位曲線
5075	非晶質銅フタロシアニン蒸着膜のガスセンサへの応用	青木公二.鷹野 修.田中正昭.笹原正光.和田達明.舛井正義.和野達明.袁 玖植.安西光利	44	12	1175	1993	7:速報論文	B03.	電気接点特性、無電解ニッケル-リン合金、低リン含有膜
5076	非晶質銅フタロシアニン蒸着膜のガスセンサへの応用	青木公二.鷹野 修.田中正昭.笹原正光.和田達明.舛井正義.和野達明.袁 玖植.安西光利	44	12	1177	1993	7:速報論文	A01.	非晶質銅フタロシアニン、蒸着膜、ガスセンサー
5077	青色発光有機薄膜EL素子	竹内 学.舛井正義.和野達明.袁 玖植.安西光利	44	12	1179	1993	7:速報論文	A01.	有機EL素子、トリフェニルジアミン誘導体
5078	磁界変調光磁気ディスクUV樹脂膜の潤滑性の検討	川崎 実	44	12	1181	1993	7:速報論文	A10.	潤滑性の検討、UV樹脂膜、光磁気ディスク、磁界変調
5079	金の電析反応過程に及ぼすクエン酸塩カチオンの影響	山下嗣人.高橋正樹.岩城泰彦.野沢文恵.藤井浩之.中島 靖.生方雅美.村上幹男	44	12	1183	1993	7:速報論文	B02.	電極反応、金電析、クエン酸カチオン、電析金の構造
5080	液晶高分子薄膜のLCD用配向膜への応用-新規ラビングレス配向方法の試み	加藤浩司.金子富士男.舛井正義	44	12	1185	1993	7:速報論文	*	液晶高分子、配向膜、液晶表示
5081	銅フタロシアニン蒸着膜のエレクトロクロミズムの構造依存性	加藤浩司.金子富士男.舛井正義	44	12	1187	1993	7:速報論文	A01.	銅フタロシアニンの構造、蒸着膜、エレクトロクロミズム、ボルタ
5082	Ni/Feの多層電析膜からのNi-Fe合金層の作製	吉村俊一.吉原佐知雄.白樺高史.佐藤栄一	44	12	1189	1993	7:速報論文	E02.	NiFe熱処理、多層膜、磁気特性
5083	巻頭言:表面技術のイメージ	鷹野 修	45	1	1	1994	巻頭言(エッセイ)	*	
5084	生産現場から見た表面制御技術の重要	小池淳義	45	1	2	1994	技術解説	洗浄	自然酸化膜表面調整.汚染
5085	ウエ-ハ表面の金属汚染評価技術	味岡恒夫	45	1	6	1994	技術解説	洗浄	金属汚染分析.LSI製造
5086	シリコンの自然酸化膜	服部健雄	45	1	12	1994	解説	洗浄	Si:自然酸化膜
5087	原子間力顕微鏡によるシリコン表面のラベス評価	鈴木峰晴	45	1	17	1994	解説	洗浄	表面粗さ.Si:原子間力顕微鏡.酸化物表面
5088	シリコン結晶の清浄表面構造	高柳邦夫	45	1	22	1994	解説	洗浄	Si:結晶.清浄表面.表面構造
5089	金属表面のCr2O3及びNiF2不動態処理	大見忠弘	45	1	26	1994	解説	熱処理(酸化・窒化・炭化)	Cr2O3.不動態.NiF2.耐食性.非触媒性.耐プラズマ.in-situ装置.洗浄
5090	薬品の高純度化	米沢 昂	45	1	32	1994	技術解説	洗浄	清浄分析.清浄実験室.化学的精内面処理.アルミニウム酸化膜.フッ素樹脂膜.モニシラン除去
5091	半導体材料ガスの高純度化	池田拓也	45	1	38	1994	技術解説	その他(新技術を含む)	
5092	"小特集/LSI製造における表面制御技術"に於て	飯本周邦	45	1	43	1994	随想	*	
5093	アルミニウムのトンネルエッチングのその場観察法	牧野英司.柴田隆行.池田正幸.菅沼	45	1	44	1994	解説	化学エッチング.電解エッチング	Al:トンネルエッチング.In-situ観察
5094	PCMの機能拡大について	河合宏紀	45	1	49	1994	解説	塗布.塗装	プレコート金属.基本機能.環境保護.生活環境改善
5095	CVDによる素材加工法(CVI)	杉山幸三	45	1	55	1994	武井記念シリーズ	化学蒸着(CVD)	CVD.CVI.パルスCVI.SiC
5096	単色陽電子ビームによる表面層欠陥の評価	藤浪真紀	45	1	62	1994	その他(新技術を含む)	その他(新技術を含む)	ボジトロピーム.空孔型欠陥.Si:SiO2.イオン充填
5097	シリーズ/表面物性評価技術-表面状態の解析(30)-レーザ照射によるTiの着色皮膜形成	相馬英明.田中壽晃.田頭孝介.山口栄.内見寿雄	45	1	67	1994	原著論文(研究.研究論文)	熱処理(酸化・窒化・炭化)	Ti:レーザ.着色.表面硬化.耐摩耗性
5098	アルミニウム陽極酸化多孔質皮膜へのNi無電解析出	益田秀樹.西澤 徹.馬場宜良	45	1	73	1994	原著論文(研究.研究論文)	無電解めっき	Al:アノード酸化.多孔質.Ni:無電解めっき.触媒.修酸
5099	銀/ニッケルめっき間の耐熱密着性及びCuストライクめっきの効果	珍田 聡.吉岡 修	45	1	78	1994	原著論文(研究.研究論文)	電気めっき・電鍍	Cu.ストライクめっき(フラッシュめっき).Ag.電気めっき.密着性.熱処理.AES
5100	ニッケルめっき膜の結晶配向性とその残留すみに及ぼすホウ酸及び溶液pHの部分スズめっき鋼板上へのクロムめっき技術	津留 豊.井元宏幸.高松亮太.細川邦典	45	1	82	1994	原著論文(研究.研究論文)	電気めっき・電鍍	Ni:電気めっき.pH.ほう酸.内部ひずみ.ひずみ計
5101	ポリ塩化ビニル被覆鋼板用の低温硬化可能な裏面塗料の開発	森田順一.吉田光男	45	1	88	1994	原著論文(研究.研究論文)	電気めっき・電鍍	Sn.Cr:部分めっき.電流密度.酸化物膜.塗料剥離
5102	ポリ塩化ビニル被覆鋼板用の低温硬化可能な裏面塗料の開発	林芳 夫.中本哲男.小池一幸.神田勝美	45	1	93	1994	原著論文(研究.研究論文)	塗布.塗装	ポリ塩化ビニル(PVC).鋼板.エポキシウレタン塗料.メラミン.架橋
5103	NaHS及びNa2S水溶液によるAu-Ag合金の腐食	中田正隆.大沢正人.鹿園直建.本間久英.塚本師子	45	1	98	1994	原著論文(研究.研究論文)	その他(新技術を含む)	Au.Ag.合金.腐食.NaHS.Na2S.Ag2S
5104	PVD法によってTiNあるいはTiCを被覆した超硬合金における破壊靱性の比較	伊藤 亨.肥田 昭	45	1	103	1994	研究ノート	物理蒸着(PVD)	破壊靱性.固溶炭素.TiN.TiC.PVD
5105	プラズマ浸炭窒化したチタン上でのダイヤモンド合成	佐藤貴康.根岸 学.明石和夫	45	1	106	1994	速報論文	熱分解-ゾル-ゲル法	ダイヤモンド.プラズマ.浸炭窒化.TiCN

5106	自己触媒型無電解はんだめっき	本間英夫・斎藤彰典・小林 健	45	1	108	1994	速報論文	無電解めっき	無電解めっき.Pb.Sn.合金.自己触媒.表面状態
5107	STMによるポリアニリンの電気化学的重合過程の"その場"観察	遠藤浩二・高田昌弥・吉原佐知雄・佐和田建二・外村毅・堤 正幸	45	1	110	1994	速報論文	電解加工	ポリアニリン.In-situ STM.電解重合
5108	アルミニウムの交流電解皮膜の積層構造	松原 浩・内 秀則・山田明文	45	1	112	1994	速報論文	アノード酸化	アノード酸化膜.交流電解.積層構造.水処理.密着性
5109	アルミニウム箔の化学エッチングモフォロジーの観察	松原 浩・内 秀則・山田明文	45	1	114	1994	速報論文	化学エッチング・電解エッチング	Al.化学エッチング.表面状態.微細構造.TEM
5110	巻頭言:第89回講演大会を横浜に迎えて生体膜表面における化学識別 - 化学受容膜を例として	佐藤祐一	45	2	135	1994	巻頭言(エッセイ)		
5111	NMRによりタンパク質の表面環境を探る	神藤平三郎	45	2	143	1994	解説	その他(新技術を含む)	におい識別.応答経路.非受容機構.嗅覚
5112	細胞特異性材料による表面修飾と細胞機能抑制	小林 明・赤池敏宏	45	2	152	1994	解説	吸着	タンパク質表面.水和水.NMR.核オーバーハウザー効果 肝細胞.アシアロ糖タンパク質.分化
5114	イオンビーム照射とバイオ表面の改質	岩木正哉	45	2	160	1994	解説	イオン注入	イオンビーム照射.バイオ.表面改質.生適合性
5115	マメ科植物の根の生育表面の電位測定でさぐる	高村 勉・渡辺由美	45	2	167	1994	解説	その他(新技術を含む)	植物根表面.負電極電位.プロトンイオンポンプ.豆.芽芽.側根
5116	表面増強赤外吸収分光法による皮膚表面の計測	西川雄司・大澤雅俊	45	2	172	1994	解説	その他(新技術を含む)	表面増強赤外吸収分光法.Ag膜.FT-IR.高分子膜.皮膚表面
5117	"小特集/バイオ表面をみる"によせて	楠 文代	45	2	173	1994			
5118	溶射法の進歩	蓮井 淳	45	2	180	1994	解説	溶射	溶射.表面改質
5119	高速電流反転電解による脱脂.活性化及び研磨方法の開発	大久保敬吾	45	2	185	1994	解説	化学研磨・電解研磨	反転電流.脱脂.活性化.電解研磨
5120	多層プリント配線板用内層銅箔処理	中祖昭士	45	2	192	1994	解説	その他(新技術を含む)	プリント配線基板.内層銅箔.酸化銅処理.化学還元
5121	熱拡散法により作製した光沢スズ - ニッケル合金皮膜の構造と物性	園田 司・松田好晴	45	2	197	1994	原著論文(研究.研究論文)	拡散皮膜	光沢めっき.Ti.Ni.合金.結晶構造.接触抵抗
5122	無電解めっき法によるNi - Fe - P合金系磁性膜の作製条件について	金 東賢・松田 均・青木公二・鷹野 修二	45	2	202	1994	原著論文(研究.研究論文)	無電解めっき	無電解めっき.合金めっき.Ni.Fe.軟磁性薄膜.浴安定性
5123	定電位法による電解コデンサ用Al箔のエッチング特性	日比野淳興・戸正純・沖 猛雄	45	2	207	1994	原著論文(研究.研究論文)	化学エッチング・電解エッチング	Al.定電位電解.電解エッチング.ビット形態
5124	CoB軟磁性膜の磁場中熱処理による透磁率の制御	逢坂哲彌・高井まどか・影山謙介	45	2	213	1994	原著論文(研究.研究論文)	熱処理(酸化・窒化・炭化)	軟磁性薄膜.Co.B.合金.透磁率.磁場中熱処理
5125	電析パラジウム - ニッケル - リン合金の結晶構造と皮膜特性	水本省三・縄舟秀美・岡田 隆・芳賀正	45	2	218	1994	原著論文(研究.研究論文)	電気めっき・電鍍	電気めっき.Pd.Ni.P.合金めっき.結晶構造.硬さ.接触電気抵抗
5126	イオンブレイディング法によるTiN皮膜のスクラッチ試験における密着性の評価	大中年樹・広橋光治	45	2	233	1994	原著論文(研究.研究論文)	物理蒸着(PVD)	TiN.ひっかけ試験.密着性.臨界荷重.摩擦力
5127	巻頭言:協会とパブル	小林賢三	45	3	233	1994	巻頭言(エッセイ)		
5128	溶融亜鉛めっき鋼板の表面分析	黒沢 進	45	3	234	1994	技術解説	溶融めっき	表面分析.溶融亜鉛めっき鋼板.金属間化合物.微細構造.電析
5129	亜鉛系電気めっき鋼板の解析技術	名越正泰・近藤隆明	45	3	239	1994	技術解説	電気めっき・電鍍	電気亜鉛めっき鋼板.Zn.亜鉛基合金.表面分析.解析技術.
5130	缶用鋼板の表面解析	堀口 誠	45	3	244	1994	技術解説	電解加工	表面解析.鋼板.缶体.表面分析.顕微鏡観察
5131	塗装鋼板の表面分析	山辺秀敏	45	3	250	1994	技術解説	塗布.塗装	表面分析.塗装鋼板.密着性
5132	プレコート鋼板の表面性状と塗装性能	小川 進・石原真興	45	3	254	1994	技術解説	塗布.塗装	プレコート鋼板.高機能.結晶化.メラミン.フッ素樹脂
5133	自動車の化成処理と構造解析	佐藤 登	45	3	259	1994	技術解説	化成処理	リン酸亜鉛処理.hopite結晶.電子線共鳴吸収スペクトル(ESR).レーザーラマンスペクトル(LRS).E化学複合被覆.表面分析.家電製品.建材.クロメート処理
5134	家電製品または建材の化成処理と表面解析	鈴木正教・小泉宗栄	45	3	266	1994	技術解説	化成処理	
5135	"小特集/表面処理鋼板の解析技術"によせて	近藤隆明	45	3	272	1994	随想		
5136	強誘電性液晶の開発と応用	石原重喜	45	3	273	1994	解説	その他(新技術を含む)	強誘電性液晶.分子設計
5137	シリーズ/表面物性評価技術 - 表面状態の解析(3) - Rietveldによる結晶構造解	秋葉悦男	45	3	278	1994		その他(新技術を含む)	Rietveld法.結晶構造.粉末法.X線回折
5138	無電解めっきによるスズ - 鉛合金皮膜の形成	千田厚生・高野比古・森田一弘	45	3	283	1994	技術論文	無電解めっき	無電解めっき.Sn.Pb.合金薄膜.TiC3.Na2CO3
5139	N.基自溶合金溶射皮膜のプラズマ浸炭	金山信幸・堀江 譲	45	3	290	1994	原著論文(研究.研究論文)	熱処理(酸化・窒化・炭化)	表面硬化.浸炭.グロー放電(プラズマ).自溶合金.溶射
5140	セラミックス皮膜のスクラッチ試験時に発生するAE信号の特性評価	石川宏美・大中年樹・広瀬光治	45	3	296	1994	原著論文(研究.研究論文)	物理蒸着(PVD)	ひっかけ試験.アコースティックエミッション(AE).密着性.セラミックコーティング
5141	電析Zn - 7wt%Cr合金めっき皮膜の構造	高橋 彰・三吉康彦・羽田隆司	45	3	301	1994	原著論文(研究.研究論文)	電気めっき・電鍍	Zn.Cr.合金めっき.電気めっき.結晶構造.熱処理.結晶化
5142	電気亜鉛めっき鋼板のはんだ付け性に及ぼす後処理の影響	小池一幸・藤本準一・神田勝美	45	3	307	1994	原著論文(研究.研究論文)	塗布.塗装	電気亜鉛めっき鋼板.後加熱処理.はんだ付け性.耐食性
5143	有機アルカリ性浴(コリン - フッ化物基液)中でのアルミニウムの陽極酸化における有機酸塩添加の効果	野口駿雄・吉村長蔵	45	3	313	1994	原著論文(研究.研究論文)	アノード酸化	有機アルカリ浴.Al.陽極酸化.塩化物浴.フッ化物浴
5144	焼結クロムのプラズマ浸炭	金山信幸・堀江 譲	45	3	318	1994	研究ノート	熱処理(酸化・窒化・炭化)	浸炭.グロー放電(プラズマ).焼結クロム.表面硬化.炭化クロム
5145	多量化コバルトポルフィリン/高分子配位子系を表面修飾した電極による酸化還元	湯浅 真・鳥居広康・桑内友一・関根 功	45	3	321	1994	速報論文	その他(新技術を含む)	多量化コバルトポルフィリン.高分子配位子.多分子錯体.修飾電極.酸素還元触媒
5146	プラズマ浸炭による再溶融処理したNi.基自溶溶射皮膜の改質	金山信幸・堀江 譲	45	3	323	1994	速報論文	熱処理(酸化・窒化・炭化)	表面硬化.浸炭.グロー放電(プラズマ).自溶合金.溶射
5147	巻頭言:表面技術史と産業史の研究を	寺島慶一	45	4	331	1994	巻頭言(エッセイ)		
5148	セラミックスの表面処理	松原秀彰・柴田典義	45	4	332	1994	総説	気相エッチング	表面処理.セラミックス.機能性セラミックス.構造用セラミックス.コーティング
5149	セラミックスセンサ -	臼井俊雄	45	4	337	1994	解説	その他(新技術を含む)	セラミックスセンサー.半導体センサー.湿度センサー.ジルコニア酸素センサー.pn-ヘテロ接触センサー.人工骨.ハイドロアパタイト.コーティング.癌治療.多孔質セラミック
5150	バイオセラミックス	龜山哲也	45	4	343	1994	解説	その他(新技術を含む)	セラミックパッケージ.電気めっき.無電解めっき.薄膜.機能性
5151	セラミックスパッケージと表面処理技術	若林信一	45	4	351	1994	技術解説	無電解めっき	表面実装部品.表面処理.はんだ付け.
5152	表面実装部品と表面処理	上原孝行	45	4	359	1994	技術解説	電気めっき・電鍍	超微粒子.コーティング.プラズマ.粉体.繊維
5153	セラミックス粉末・繊維への超微粒子コーティング	山田幸良	45	4	365	1994	技術解説	その他(新技術を含む)	CVD.コーティング.ダイヤモンド.切削性.イオン注入
5154	セラミックス工具及び機械部品の表面処理	八木 優	45	4	372	1994	技術解説	化学蒸着(CVD)	

5155	"小特集 / セラミックスと表面処理"によせ	澁木邦夫	45	4	376	1994	随想		
5156	バルブ金属のアノード酸化と皮膜構造	瀬尾真浩	45	4	377	1994	解説	アノード酸化	バルブ金属アノード酸化酸化皮膜膜構造
5157	高出力YACレーザによる炭素鋼の表面硬化処理	日野 実 栢野康彦 安岡アツ桂子 平松 実 秋山光一	45	4	383	1994	技術論文	熱処理(酸化・窒化・炭化)	YAGレーザレーザ硬化炭素鋼表面レーザ処理
5158	Al - Fe合金のNaOH溶解挙動に及ぼす溶液温度の影響	世利修美	45	4	388	1994	技術論文	化学エッチング・電解エッチング	化学エッチングNaOH浴温Al.Fe合金
5159	窒化チタンの半導体特性とアノード溶解反応	田口正美	45	4	394	1994	原著論文(研究研究論文)	物理蒸着(PVD)	Ti.N半導体特性溶解反応硫酸光電分極光電位
5160	狭幅長尺めっきセルにおけるめっき液供給口形状のめっき電流分布に及ぼす影響	森田順一 吉田光男	45	4	400	1994	原著論文(研究研究論文)	電気めっき・電鍍	Sn.電気めっきアノードロール不溶性電極ラプラス方程式ガウスシールド法
5161	1.1.1 - トリクロロエタンによるアルミニウムの溶解反応に対する有機試薬の抑制効果に関する統計解析	安田守宏 渡部清一 安川真巳 安川 三郎	45	4	406	1994	原著論文(研究研究論文)	洗浄	Al.洗浄1.1.1-トリクロロエタン有機インヒビター変化解析
5162	無電解Co合金皮膜の磁気特性に及ぼす熱処理の影響	齋藤哲男 山口ひと み 佐藤栄一 吉原	45	4	411	1994	原著論文(研究研究論文)	無電解めっき	Co.無電解めっき合金めっき.N.熱処理磁気特性結晶構造.S.E.A.g.光沢めっき電気めっき非シアン浴添加剤
5163	高光沢非シアン化銀めっきに及ぼす添加剤の影響	魏 永康 沖 猛雄	45	4	416	1994	原著論文(研究研究論文)	電気めっき・電鍍	溶解塩Ti.電解析出配向性モルフロジー耐食性
5164	硫酸塩電析によるチタン薄膜の形成及び添加元素の効果	魏 大維 興戸正純 沖 猛雄	45	4	422	1994	原著論文(研究研究論文)	電気めっき・電鍍	金属間化合物TiAl.Ni.電気めっきAl.析出浸透法高温酸化耐酸
5165	ウェット - ドライブプロセスの組合せによってNi - Al複合被覆したTiAlの高温酸化	笠原和男 武井 厚 山下嗣人	45	4	428	1994	研究ノート	拡散皮膜	
5166	高飽和磁化軟磁性用FeP電析浴の開発	高井まどか 中村明 義 浅富士夫 逢坂	45	4	431	1994	Letters	電気めっき・電鍍	電解析出軟磁性特性FeP
5167	明治・大正・昭和前期刊行表面処理関係図書目録	寺島慶一	45	4	433	1994	資料	その他(新技術を含む)	図書目録表面処理明治昭和 大正
5168	巻頭言:協会とエンジニアリング	松坂菊生	45	5	449	1994	巻頭言(エッセイ)		
5169	有機高分子材料とフィルム	伊藤栄子	45	5	450	1994	総説	その他(新技術を含む)	有機高分子フィルム表面からみあい
5170	メタライジングフィルム	西川忠寛 秋山良治	45	5	456	1994	技術解説	物理蒸着(PVD)	スパッタリング無電解めっき電気めっきコンデンサー
5171	有機フィルムのエレクトロニクスへの利用 - 磁気記録(テ - プ.フロッピーディスク)	三宅 明	45	5	464	1994	技術解説	その他(新技術を含む)	磁気記録ビデオテープフロッピーディスクポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム
5172	透明電導性フィルム	岡庭 宏	45	5	470	1994	技術解説	化学蒸着(CVD)	透明電導性フィルムITO
5173	食品保存のための有機フィルム	葛良忠彦	45	5	477	1994	技術解説	塗布・塗装	プラスチックフィルム食品保存コーティングラミネートガスバリ写真フィルムセルローストリアセテート(TAC).ポリエチレンテレフタレート(PET).下塗り透明バック層耐傷性ハレーション防止印刷技術プラスチックフィルムイ
5174	写真用フィルムの表面機能付与	品川幸雄	45	5	484	1994	技術解説	塗布・塗装	
5175	プラスチックフィルムと印刷技術	鈴木 侃	45	5	491	1994	技術解説	塗布・塗装	
5176	"小特集 / 有機フィルムと表面処理"による酸化亜鉛薄膜を中間層に用いる新無電解めっき法	大工原茂樹 吉識 肇 橋本和仁 藤嶋 昭	45	5	495	1994	随想	無電解めっき	ZnO.無電解めっき密着性フィンパターン
5177	耐指紋処理鋼板の高温塗膜密着性に及ぼす鋼板表面及び試験環境の影響	河崎智恵香子 高尾 研治 戸塚信夫 森 戸延行 本庄 徹 大	45	5	503	1994	技術論文	塗布・塗装	塗膜密着性クロメート皮膜Zn.電気めっき鋼板プリント配線基板
5178	耐指紋処理鋼板の高温塗膜密着性に及ぼす電気亜鉛めっき層中の不純物の影響	河崎智恵香子 高尾 研治 戸塚信夫 森 戸延行 本庄 徹 大	45	5	509	1994	技術論文	塗布・塗装	塗膜密着性クロメート皮膜Zn.電気めっき鋼板プリント配線基板
5180	アルミニウムの硫酸浴陽極酸化における増粘剤添加の影響	青木公二 福田元 保金 東賢 鷹野	45	5	515	1994	原著論文(研究研究論文)	アノード酸化	硫酸イオン輸率生成皮膜効率増粘剤
5181	無電解Ni - S - P合金めっき皮膜 - 電極材料の作製	青木公二 福田元 保金 東賢 鷹野	45	5	519	1994	原著論文(研究研究論文)	無電解めっき	無電解めっきNi.S.P.合金めっき電極材料
5182	無電解Ni - S - P合金めっき皮膜 - 電極特性	青木公二 福田元 保金 東賢 鷹野	45	5	524	1994	原著論文(研究研究論文)	無電解めっき	無電解めっきNi.S.P.合金めっき電極特性
5183	硫酸亜鉛浴からのアルミナ複合めっきにおける溶液pHの影響	津留 豊 近藤一雄 細川邦典 山田隆裕	45	5	529	1994	原著論文(研究研究論文)	電気めっき・電鍍	複合めっきAlミナ硫酸亜鉛浴pH.Zn(OH)2
5184	ダイヤモンド砥粒を含むNi電着膜の密着性	横山俊雄 佐藤金 司 鈴木敦夫	45	5	535	1994	原著論文(研究研究論文)	電気めっき・電鍍	複合めっきNi.ダイヤモンド砥粒密着性電気めっき
5185	1.1.1 - トリクロロエタンによるアルミニウムの溶解反応に対する有機試薬の抑制効果に関する相関分析	安田守宏 渡部修一 安川真巳 安川 三郎	45	5	539	1994	原著論文(研究研究論文)	洗浄	Al.洗浄1.1.1-トリクロロエタン有機インヒビター相関分析
5186	無電解Ni - P皮膜物性に与える錯化剤の影響	初川拓朗 逢坂哲 彌 千葉国雄 福田 豊 中尾英弘	45	5	543	1994	原著論文(研究研究論文)	無電解めっき	Ni.P.無電解めっき錯化剤リン濃度物理的性質
5187	酸素・オゾン - テトラメチルSn系光CVDによるSnO2膜の低温化合成	朴 正一 石田 正 木村三郎 田村繁 治 三原敏行 田畑	45	5	547	1994	速報論文	化学蒸着(CVD)	SnO2.薄膜光CVD.CVD
5188	無電解銅めっきにおける2,9 - ジメチル - 1,10 - フェントロリン添加剤の挙動	老田昌弘 本城克彦	45	5	549	1994	Letters	無電解めっき	Cu.無電解めっき添加剤フェントロリン分光分析
5189	S ₁ 結晶中の加工歪みとデバイス特性	名倉英明 藤原誠 司 山田博之 横沢	45	5	551	1994	資料	機械研磨・研削	降伏特性研磨研磨ひずみ層シリコン結晶(Si)
5190	幕末・明治期刊行図書にみる電気めっき受容の一断面	寺島慶一 海老名延 郎	45	5	554	1994	資料	その他(新技術を含む)	歴史幕末明治図書電気めっき
5191	巻頭言:協会の健全な発展のために	松本誠臣	45	6	567	1994	巻頭言(エッセイ)		
5192	高エネルギー密度二次電池の現状と表面処理技術	逢坂哲彌	45	6	568	1994	総説	その他(新技術を含む)	表面処理技術二次電池高エネルギー密度
5193	燃料電池の電極触媒における表面技術	渡辺政廣	45	6	574	1994	解説	その他(新技術を含む)	燃料電池電極触媒Pt.合金腐食結晶構造
5194	ニッケル - 水素二次電池と表面処理	境 哲男	45	6	581	1994	解説	その他(新技術を含む)	水素吸蔵合金金属水素化物水素電池Ni - MH電池表面修飾
5195	リチウム二次電池における表面処理	山木準一	45	6	587	1994	解説	その他(新技術を含む)	Li二次電池陽極保護膜
5196	電池セパレータの表面改質	海谷英男	45	6	593	1994	解説	その他(新技術を含む)	電池セパレータグラフト重合アルカリ二次電池スルホン化
5197	湿式太陽電池と表面処理	八重真治 中戸義禮	45	6	599	1994	解説	その他(新技術を含む)	半導体電極表面状態光起電力超微粒金属光触媒反応
5198	電気二重層コンデンサにおける表面技術	森本 剛	45	6	605	1994	解説	その他(新技術を含む)	コンデンサー電気二重層界面活性炭有機電解質
5199	"小特集 / 電池における表面技術"によせ	森田昌行	45	6	612	1994	随想		
5200	反応性DCスパッタリングによるTi - 6Al - 4V合金へのTiO ₂ 被覆に及ぼす酸素流量の影響	園田 勉 加藤 誠	45	6	613	1994	原著論文(研究研究論文)	物理蒸着(PVD)	反応性直流スパッタリングTi-O被覆Ti - 6Al - 4V合金(生体適合性)

5201	Ti - C - N皮膜の摩擦特性とサイドトリマーの適用	田村元紀・安藤文和・西田耕三・岩崎好孝・小寺孝正	45	6	619	1994	原著論文(研究・研究論文)	物理蒸着(PVD)	サイドトリマー・イオンブレーティング・工具寿命・Ti - C - N被覆・剪断・硬度・耐水性
5202	パルス電着したZn - Ni合金めっき鋼板の構造と耐食性	高橋 彰・三吉康彦	45	6	625	1994	原著論文(研究・研究論文)	電気めっき・電鍍	パルス電着めっき・Zn・Ni合金めっき・結晶構造・腐食
5203	フレキシブルなWO3 / PPTA複合電析膜の試作とそのエレクトロミック特性	山崎澄男・古賀一成・中曾修一・大浦博昭・津留寿昭・高李 明勲・小塚 巧・沖 猛雄	45	6	630	1994	原著論文(研究・研究論文)	電気めっき・電鍍	WO3ポリパラフェニレンテレフタルアミド(PPTA)複合電着・エレクトロミック特性・機械的特性
5204	PVD法により作製したマグネシウム薄膜の結晶配向性とモルフォロジー及びの耐電析非晶質Ni - Mo - P合金膜の作製と腐食挙動	姚 素薇・曾 躍・郭鶴桐・小若正倫	45	6	636	1994	原著論文(研究・研究論文)	物理蒸着(PVD)	PVD・Mg結晶配向・表面状態・耐食性
5205	炭酸ガスレーザによる表面処理助剤としてのBNの利用	志村洋文・鈴木正弘・深見 肇・廣實常	45	6	648	1994	原著論文(研究・研究論文)	熱処理(酸化・窒化・炭化)	BN・レーザ吸収剤・レーザ焼きなまし・レーザクラッド
5207	電気めっきで得られるNi - P合金めっきの歪みとリン含有量の関係	津留 豊	45	6	653	1994	速報論文	電気めっき・電鍍	Ni・P皮膜・電気めっき・合金めっき・内部ひずみ・ひずみ計・P含有量・即発ガンマ線分析(PGA)・アノード酸化皮膜(AI)
5208	アルミニウム陽極酸化皮膜中のホウ素の分布	森崎重喜・小川吉寛・長瀬裕和	45	6	655	1994	速報論文	アノード酸化	Au・電気めっき・ポリエチレンイミン誘導体・レベリング・耐食性
5209	酸系電析めっき浴でのポリエチレンイミン誘導体添加物の影響とその金膜の耐食性	関根 功・鎌田聡明	45	6	657	1994	Letters	電気めっき・電鍍	
5210	巻頭言：表面改質の多様性を求めて	山川宏二	45	7	667	1994	巻頭言(エッセイ)		
5211	プリント配線板技術の現状と将来	中井 通・國嶋真文	45	7	668	1994	解説	その他(新技術を含む)	プリント配線板・電子部品・高集積回路・無電解めっき
5212	自動車用鋼板の表面処理技術動向	森田順一	45	7	673	1994	解説	電気めっき・電鍍	プレコート鋼板・耐食性・成型性・塗装容易性
5213	自動車用プラスチックの表面処理技術	奥本忠興	45	7	678	1994	解説	電気めっき・電鍍	プラスチック表面改質・金属化・トリクロロエタンエッチング・加飾
5214	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(32) - 表面増強赤外分光法によるパラジウムめっき鉄合金材の耐食性に及ぼす下地ニッケルめっき析出時のパルス	安宅憲一・西川雄司・大澤雅俊	45	7	686	1994	技術論文	物理蒸着(PVD)	表面増強赤外分光法(SEIRA S)・FT - IR・固液界面・高分子表
5215	近藤市治・近藤憲司・竹中 修・金原桑野三郎・真野 毅・沖 猛雄	45	7	691	1994	技術論文	電気めっき・電鍍	Pd・下地めっき・Ni・パルスめっき・Fe合金材・耐食性	
5216	Ti薄膜 / Si基板の界面構造と密着性	近藤市治・近藤憲司・竹中 修・金原桑野三郎・真野 毅・沖 猛雄	45	7	695	1994	原著論文(研究・研究論文)	物理蒸着(PVD)	密着性・薄膜・スパッタリング・イオンボンバード・Ti・Si・Ar
5217	反応性イオンブレーティングによる積層皮膜の形成とその評価	王 立鏢・沖 猛雄	45	7	700	1994	原著論文(研究・研究論文)	物理蒸着(PVD)	イオンブレーティング・Ti・Cr・TiN・積層皮膜
5218	ろう接によるジルコニア・金属の接合強度に及ぼす活性金属Ti及びその反応層の陰分極法によるDLC膜の欠陥面積の決定	田中慎一・斎藤英樹・森河和雄・棚木小野寺元伸・清水一夫・土屋武司・渡辺田代雄彦・千葉国雄・福田 豊・中尾英弘・本岡英夫	45	7	705	1994	原著論文(研究・研究論文)	その他(新技術を含む)	活性金属・ろう付け・Ti箔・ジルコニア接合力・TiO層
5219	電析めっきによるNi - Co - B非晶質軟磁性多層膜の作製	田中慎一・斎藤英樹・森河和雄・棚木小野寺元伸・清水一夫・土屋武司・渡辺田代雄彦・千葉国雄・福田 豊・中尾英弘・本岡英夫	45	7	710	1994	原著論文(研究・研究論文)	化学蒸着(CVD)	ダイヤモンド状炭素(DLC)・溶存酸素・カソード分極
5220	アルミニウム上への無電解Niめっきの前処理と初期析出の関係	日比野淳・興戸正純・沖 猛雄	45	7	714	1994	原著論文(研究・研究論文)	電気めっき・電鍍	Ni・Co・B合金めっき・電気めっき・非晶質・多層膜・軟磁性
5221	界面インピーダンス法による電解コンデンサ用Al箔のエッチング特性の検討	吉村長蔵・三村雅勇	45	7	720	1994	原著論文(研究・研究論文)	無電解めっき	ダブルジーンケート法・初期析出過程・Ni・無電解めっき
5222	Alの硫酸浴陽極酸化における超音波照射の効果	千葉 淳・古郡貴志・吳 文昌	45	7	726	1994	原著論文(研究・研究論文)	化学エッチング・電解エッチング	交流インピーダンス・Al電解エッチング・ビット形状
5223	ジクロロメタンの超音波分解	森本純司・山口昭雄・亀川美幸	45	7	731	1994	原著論文(研究・研究論文)	アノード酸化	Al・アノード酸化・超音波効果・硫酸浴
5224	電解浸蝕処理によるNi - Cr合金溶射皮膜の改質	木内正人・茶谷原昭義・嶋岡智司・長坂浩志・土屋直樹	45	7	735	1994	原著論文(研究・研究論文)	洗浄	超音波・分解・ジクロロメタン
5225	ダイナミックミキシング法による窒化チタン厚膜の形成	秋葉幸雄・広瀬洋一・黒須橋生・飯田馬飼野信一・川口明廣・山崎龍一・森 修・五十嵐英郷	45	7	739	1994	速報論文	拡散皮膜	溶射・Ni・Cr合金被覆・ホウ化層・微小硬度
5226	成長中の半導体ダイヤモンド薄膜の伝導タイプとその場測定	村川享男	45	7	741	1994	速報論文	物理蒸着(PVD)	TiN・イオンビーム・厚膜・無欠陥被覆
5227	インピーダンス測定による金属洗浄過程のIn - Situモニタリング	五十嵐高	45	7	743	1994	速報論文	化学蒸着(CVD)	半導体ダイヤモンド・電子親和力・In - situ測定・伝導タイプ
5228	巻頭言：協会と産学協同	前田重義	45	7	745	1994	Letters	洗浄	洗浄・In - situ測定・インピーダンス・油・電気抵抗
5229	表面・界面制御技術から見た有機皮膜の密着性	磯山永三・田中克美	45	8	751	1994	巻頭言(エッセイ)	その他(新技術を含む)	表面汚染・アンカー効果・密着力・低凝集力層(WBL)
5230	高分子のレオロジーと接着	小泉宗栄	45	8	752	1994	総説	その他(新技術を含む)	密着性・破壊強度・ひずみ・粘度は量子化学・密着性・高分子・金属界面
5231	高分子・金属接着界面の量子化学	文 慶萬・沖 猛雄	45	8	757	1994	解説	その他(新技術を含む)	表面分析・密着性・金属・有機高分子・被覆
5232	金属と高分子材料接着系における密着性評価方法	森谷 茂・菅沼栄一・佐藤 昇	45	8	763	1994	解説	その他(新技術を含む)	
5233	"小特集 / 有機皮膜の密着性"によせてクロム酸溶液中でのクロム電着に対する分極挙動	文 慶萬・沖 猛雄	45	8	769	1994	解説	その他(新技術を含む)	
5234	イオンブレーティング法により作製した窒化チタン皮膜の高温特性	文 慶萬・沖 猛雄	45	8	778	1994	随想		三価クロムイオン・六価クロムイオン・電気めっき・カソード分極曲線
5235	無電解ニッケルめっき廃液の酸化処理	森谷 茂・菅沼栄一・佐藤 昇	45	8	779	1994	原著論文(研究・研究論文)	電気めっき・電鍍	TiN・イオンブレーティング・TiO2層・放物線速度定数
5236	Zn / Ni二層めっき皮膜の耐食性に及ぼすYAGレーザ処理の影響	日野 実・西田典秀・平松 実・秋山光一・川崎仁士・勝村宗英	45	8	786	1994	原著論文(研究・研究論文)	物理蒸着(PVD)	無電解めっき液・廃液処理・酸化・触媒過程
5237	スパッタリングによる半導体TiO2薄膜の形成とNOガス感知特性の評価	桑野三郎・伊藤芳典・島山義則・田中小浦延幸・加藤俊雄・湯本英一郎	45	8	791	1994	原著論文(研究・研究論文)	無電解めっき	耐食性・YAGレーザ合金化・Zn - Ni合金薄膜・電気めっき
5238	常温形溶融塩浴からのNb - Al合金電析熱酸化皮膜に覆われたアルミニウムのアノード酸化 - アノード酸化皮膜の成長挙動に及ぼすアノード酸化温度の影響	高橋英明・大楽 貢・瀬尾真浩	45	8	800	1994	原著論文(研究・研究論文)	物理蒸着(PVD)	スパッタリング・TiO2半導体薄膜・NO感度
5239	ポリエステル樹脂系接着剤を塗布したポリ塩化ビニル被覆鋼板の交流インピーダンス法による耐久性評価	林 芳夫・藤井行治・小池一幸・神田勝美・松田好晴	45	8	805	1994	原著論文(研究・研究論文)	電気めっき・電鍍	Nb・Al合金めっき・電気めっき・常温溶融塩
5240	交流インピーダンス法によるポリ塩化ビニル被覆鋼板の耐食性に及ぼす下地鋼板の影響の測定	林 芳夫・藤井行治・小池一幸・神田勝美・松田好晴	45	8	810	1994	原著論文(研究・研究論文)	アノード酸化	Al加熱酸化膜・アノード酸化膜・バリアー酸化膜
5241	飲料缶用材料の塗膜下腐食挙動	森田順一・吉田光男	45	8	818	1994	原著論文(研究・研究論文)	塗布・塗装	ポリ塩化ビニル・鋼板・耐食性・交流インピーダンス
5242	FTIR・ATR法による無電解パラジウム - リン合金めっき浴中の浴成分のモニタリング	縄秀美・水本省三・小橋康人・杉本直己・芳賀正記	45	8	824	1994	原著論文(研究・研究論文)	塗布・塗装	ポリ塩化ビニル・鋼板・耐食性・交流インピーダンス
5243	高周波グロー放電発光分光法によるAl上樹脂被覆材の分析	林 孝行・鈴木木一	45	8	830	1994	原著論文(研究・研究論文)	塗布・塗装	塗膜下腐食・塗膜は(離・ティンフリー鋼板・すずめっき鋼板・カソードリ工変換赤外反射(FTIR - ATR)法・無電解めっき浴・Pd・P合金めっき・モニタリング
5244			45	8	835	1994	研究ノート	無電解めっき	グロー放電発光分光(HF - GDF)分析・樹脂被覆・スパッタリング
5245			45	8	838	1994	速報論文	ライニング	

5247	クロムイオン注入によるAlloy 690の高温高圧水中での溶解抑制	柴田俊夫・藤本慎司・大谷 豊・渡邊正則・平尾亨三・奥本賢・芝池博之	45	8	840	1994	速報論文	イオン注入	イオン注入・高温水・690合金・不働態・XPS
5248	酸系電析金めっき浴での有機添加物及びパルスめっき法の相乗効果とその金めっき膜の耐食性	湯浅 真・塘 健夫・宮館康夫・大谷三郎・関根 功・葛島俊	45	8	842	1994	Letters	電気めっき・電鍍	Au・電気めっき・有機添加剤・パルスめっき・耐食性
5249	熱拡散法により作製したスズ-ニッケル合金皮膜の耐食性に及ぼす熱処理の影響	園田 司・松田好晴	45	8	844	1994	Letters	拡散皮膜	Sn・Ni・合金・熱拡散法・耐食性
5250	巻頭言・第90回講演大会を迎えて	瀬尾真浩	45	9	851	1994	巻頭言(エッセイ)		
5251	水質保全対策の実施状況	柏葉清志	45	9	852	1994	総説	その他(新技術を含む)	水質・環境基準・排水基準・水質保
5252	分離・回収技術 - イオン交換樹脂による排水及び金属の回収	福田 正	45	9	860	1994	技術解説	電気めっき・電鍍	回収・イオン交換樹脂・廃水
5253	分離・回収技術 - イオン交換膜を用いた電気透析法による無電解ニッケルめっき液の廃液減少化方法	奥野和義・久保井義夫	45	9	865	1994	技術解説	無電解めっき	イオン交換膜・電気透析・Ni・無電解めっき
5254	分離・回収技術 - 膜分離技術による環境対策事例	川島敏行・多田直樹	45	9	869	1994	技術解説	その他(新技術を含む)	有機蒸気分離・浄化システム・工場廃水・再利用・膜分離
5255	分離・回収技術 - 油分離とリサイクル	星野芳明	45	9	875	1994	技術解説	洗浄	油分離・水系脱脂洗浄剤・リサイクル
5256	分離・回収技術 - 水系脱脂剤を用いた洗浄と管理	鈴木征夫	45	9	881	1994	技術解説	洗浄	洗浄剤・洗浄システム・非フロン洗浄・水系脱脂液
5257	海外における環境規制とその対応技術 - 米国における規制の状況	Frank-ALTMAYER・CEF(訳)・小坂幸夫・上谷正明・横井池加子	45	9	887	1994	解説	その他(新技術を含む)	US規制・環境保護・廃水浄化・有害化学物質
5258	海外における環境規制とその対応技術 - ドイツにおける環境規制 - 特に排水規制	村横利弘	45	9	893	1994	解説	その他(新技術を含む)	廃水・環境規制・ドイツ
5259	東南アジアにおける環境規制	豊永 実	45	9	898	1994	解説	その他(新技術を含む)	廃水・環境規制・NIE・S・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン
5260	金属アレルギーと表面処理	小林道雄	45	9	907	1994	解説	その他(新技術を含む)	金属アレルギー・アレルゲン・Ni・Cu - Sn合金・表面
5261	座談会 - テ - マノ表面処理業界と環境保全 - 環境保全のあるべき姿を語る	石井 博・小坂幸夫・古賀孝昭・斉藤光雄・矢部 賢・山崎龍	45	9	914	1994	座談会	その他(新技術を含む)	日本・海外・廃水処理・リサイクル
5262	"小特集 / 表面処理業界と環境保全"による無電解めっきによるインジウム - アンチモン合金薄膜の形成	古賀孝昭・千田厚生・高野良比古・上林義広・森田一弘	45	9	923	1994	技術論文	無電解めっき	無電解めっき・In - Sb合金めっき・TiCl3
5264	高光沢非シアン化銀めっき浴の分極挙動に及ぼすチオ硫酸ナトリウム添加の影響	稲 永康・沖 猛雄	45	9	929	1994	原著論文(研究・研究論文)	電気めっき・電鍍	Ag・光沢めっき・非シアン・電気めっきめっき浴・カソード分極・Na
5265	W / Oエマルジョンの状態変化の光音響的手法による評価	佐藤正壽・阿部一浩・小林達朗・吉原佐知雄・佐藤栄一・白樫高史	45	9	934	1994	原著論文(研究・研究論文)	その他(新技術を含む)	油 / 水(W / O)エマルジョン・光音響分光法(PAS)・相状態変化
5266	薄膜の非破壊的付着強度評価法	柴田隆行・三上 強・尾関和秀・牧野英司・池田正幸	45	9	938	1994	原著論文(研究・研究論文)	化学蒸着(CVD)	密着性・密着力測定法・ダイヤモンド薄膜・熱フラメントCVD・アコースティックエミッション(AE)
5267	ステンレス鋼基板電着ダイヤモンド砥石の作製と研削性能に及ぼす砥粒分布密度の影響	佐藤金司・鈴木木数夫・横山俊雄・加川穂積	45	9	942	1994	原著論文(研究・研究論文)	電気めっき・電鍍	ダイヤモンドホイール・電着ホイール・ステンレスホイール基盤・砥石・砥粒分布
5268	多量エネルギー・B+イオン注入によるTiC - N膜の結晶構造変化	田村元紀・大谷三郎	45	9	948	1994	原著論文(研究・研究論文)	イオン注入	イオン注入・B・結晶構造・TiCN被覆・微少硬度
5269	ダイナミックキシング法による透光性TiN超薄膜の形成	木内正人・茶谷原昭義	45	9	954	1994	速報論文	物理蒸着(PVD)	イオンビーム・透明・電気伝導・TiN
5270	電気化学計測法と組合せたIn-Situ薄膜X線回折法 - パラジウムカソード内への重水素吸蔵過程への適用	松崎 晃・仁科辰夫・内田 勇	45	9	956	1994	Letters	その他(新技術を含む)	In-situ X線回折(XRD)・低入射角XRD・重水素吸蔵・Pdカソード
5271	CAS試験によって生じた光沢Ni - Crめっき鋼板における孔食数の分布	藤田 実・横山真一郎・松本誠臣	45	9	958	1994	Letters	電気めっき・電鍍	光沢Niめっき・Ni - Cr二層めっき・電気めっき・CAS試験・孔食数・孔食深さ・対数平均モデル
5272	巻頭言・転機を迎えた表協セミナー -	海老名延郎	45	10	967	1994	巻頭言(エッセイ)		
5273	腐食測定法の現状と将来	柴田俊夫	45	10	968	1994	総説	その他(新技術を含む)	腐食測定法・電気化学的方法・化学的方法・物理的方法・走査腐食・分極法・交流インピーダンス法・分極抵抗
5274	直流分極法と交流インピーダンス法	馬飼野信一	45	10	973	1994	解説	その他(新技術を含む)	電気化学的ノイズ・孔食・周波数分析(FET)・腐食モニタリング・不働態破壊
5275	電気化学的ノイズ解析	橘 孝二	45	10	979	1994	解説	その他(新技術を含む)	分光エリプソメトリー・赤外線エリプソメトリー・薄膜
5276	新しいエリプソメトリー - 分光エリプソメトリーと赤外線エリプソメトリー	呉 徹・杉本克久	45	10	985	1994	解説	その他(新技術を含む)	走査トンネル顕微鏡(STM)・原子間力顕微鏡(AFM)・水溶液雰囲気・原子・ナノプロセス
5277	走査プローブ顕微鏡	升田博之	45	10	992	1994	解説	その他(新技術を含む)	原波形・モーメントテンソル・Clnvers Problem・反射バター
5278	アコースティック・エミッション - 原波形とモーメントテンソル解析	竹本幹男	45	10	997	1994	解説	その他(新技術を含む)	水晶振動微量天秤法(QCM)・金属薄膜・微量腐食・大気腐食・水溶液腐食
5279	水晶振動微量天秤法(QCM)	瀬尾真浩	45	10	1003	1994	解説	その他(新技術を含む)	カレントインタラプタ・有機被膜・下層腐食
5280	カレントインタラプタ法による塗膜下腐食測定	田辺弘往	45	10	1009	1994	解説	塗布・塗装	劣化・診断・塗膜・鋼構造物
5281	フィールド用交流インピーダンス測定装置による鋼構造物塗装の劣化診断	松岡和巳・本間宏	45	10	1015	1994	解説	塗布・塗装	
5282	"小特集 / 腐食測定法の現状と将来"によるチャージ間のTiN及びTiC皮膜特性評価	馬飼野信一	45	10	978	1994	随想		
5283	- X線法による残留応力測定の有効性	中沢洋二・浅見克敏・佐藤仁志	45	10	1021	1994	技術論文	物理蒸着(PVD)	硬質膜・残留応力・チャージ・X線法・ひっかけ試験
5284	モリブデンオキシ水酸化物を利用したアルミニウムアノード酸化皮膜の物性の向上	横山一男・金野英隆・馬場優子・古市隆三郎	45	10	1026	1994	技術論文	アノード酸化	カソード析出・モリブデンオキシ水酸化物膜・酸化物被覆・Al・陽極酸化・硬質陽極酸化処理
5285	光沢非シアン化銀めっきに及ぼすpH及び温度の影響	稲 永康・沖 猛雄	45	10	1029	1994	原著論文(研究・研究論文)	電気めっき・電鍍	Ag・光沢めっき・非シアン・電気めっきめっき浴・pH・浴温
5286	酸性溶液中における金属Coと無電解Co - B合金めっきの耐食性評価	江面郁子・斎藤哲男・佐藤栄一	45	10	1036	1994	原著論文(研究・研究論文)	無電解めっき	Co・B・無電解めっき・合金めっき・分極挙動・X線光電子分光(XPS)・スペクトル・アノード溶解機構
5287	無電解Pd - P合金めっき浴における分極特性	縄舟秀美・水本省三・西川憲以・芳賀小池一幸・藤本準一・矢崎勝仁・神田	45	10	1042	1994	原著論文(研究・研究論文)	無電解めっき	Pd・P・合金めっき・無電解めっき・分極・混成電位理論
5288	電気Znめっき鋼板のはんだ付け性に及ぼすめっき液添加剤の影響	小池一幸・藤本準一・矢崎勝仁・神田	45	10	1047	1994	原著論文(研究・研究論文)	電気めっき・電鍍	電気亜鉛めっき鋼板・めっき浴添加物・ハンダ付け性

5289	プレコート鋼板の耐汚染性に及ぼす樹脂物性の影響	重国智文,大岸英夫,成瀬義弘,森戸鐘 暉,興戸正純,冲猛雄	45	10	1053	1994	原著論文(研究,研究論文)	塗布,塗装	ポリエステル,メラミン橋かけ密度,耐汚染性
5290	電位制御によるアルミニウム箔の交流エッチング特性	津留壽昭,小林繁夫,山崎澄男,柳ヶ瀬津留壽昭,白水 森,小林繁夫,山崎澄男,柳ヶ瀬勉	45	10	1059	1994	原著論文(研究,研究論文)	化学エッチング,電解エッチング	交流エッチング,Alは,電位規制,ビット形状
5291	超音波照射下におけるPt-Mo合金電着	津留壽昭,小林繁夫,山崎澄男,柳ヶ瀬津留壽昭,白水 森,小林繁夫,山崎澄男,柳ヶ瀬勉	45	10	1066	1994	研究ノート	電気めっき,電鍍	超音波照射,Pt,Mo,合金めっき,電気めっき
5292	電析Pt-Mo合金皮膜の透過電子顕微鏡による観察	津留壽昭,小林繁夫,山崎澄男,柳ヶ瀬津留壽昭,白水 森,小林繁夫,山崎澄男,柳ヶ瀬勉	45	10	1068	1994	速報論文	電気めっき,電鍍	電気めっき,Pt,Mo,合金めっき,透過電子顕微鏡(TEM),微結晶
5293	アルミニウム多孔質アノード酸化皮膜の水和封孔に対する皮膜含有アニオンの効果	小野幸子,増子 昇	45	10	1070	1994	速報論文	アノード酸化	Al,アノード酸化膜,封孔処理,水和处理,透過電子顕微鏡(TEM),皮膜含有アニオン
5294	鉄/金u電着膜界面への転位の導入	釜崎清治,池淵 博,田辺良美	45	10	1072	1994	Letters	電気めっき,電鍍	電気めっき,二層めっき,Fe,Au,エピタキシャル成長,界面,転位
5295	巻頭言:地球環境と資源のこと	児玉俊一	45	11	1079	1994	巻頭言(エッセイ)		
5296	無機分離膜への期待	木村尚史	45	11	1080	1994	解説	その他(新技術を含む)	分離膜,無機メンブラン,セラミックメンブラン,ガス分離,モレキュラーシーメンブラン
5297	高温超伝導体物質開発における最近の進展	上原政智,秋光 純	45	11	1084	1994	解説	その他(新技術を含む)	高温超伝導体,Hg基超伝導体,Cu-CO3系,無限層構造,高圧合イオンレーティング,被覆,酸化,拡散,活性化エネルギー
5298	Ti,N,(Ti,Al)N,CrN膜の高温酸化	市村博司	45	11	1090	1994	解説	物理蒸着(PVD)	合金めっき,設計された合金めっき,準安定合金,安定度,合金析出機構,クラスター化学
5299	合金めっきの機能化と材料設計	小見 崇	45	11	1096	1994	解説	電気めっき,電鍍	合金めっき,設計された合金めっき,準安定合金,安定度,合金析出機構,クラスター化学
5300	ブリッジマン法による金属単結晶の作製と表面処理研究への応用	渡辺 徹,中田 毅	45	11	1100	1994	解説	その他(新技術を含む)	単結晶,ブリッジマン法,表面処理
5301	シリーズ/表面物性評価技術-表面状態の解析(33)-紫外光電子分光法(UPS),逆光電子分光法(IPE S)	真田則明,福田安生	45	11	1106	1994	原著論文(研究,研究論文)	その他(新技術を含む)	紫外光電子分光法(UPS),逆光電子分光法(IPE S),不動態化,C60
5302	シリーズ/表面物性評価技術-表面状態の解析(34)-高分解電子エネルギー損失分光法	大島忠平	45	11	1111	1994	原著論文(研究,研究論文)	その他(新技術を含む)	高分解電子エネルギー損失分光法(HREELS),表面フォノン,ポラリトン,双極子散乱,衝突散乱
5303	窒素中での銀/ニッケルめっき間の銅ストライクめっきの熱拡散挙動	珍田 聡,吉岡 修	45	11	1117	1994	技術論文	電気めっき,電鍍	Cu,フラッシュめっき,拡散,熱処理,Ag,Ni,合金めっき,オージェ分光分析法(AES)
5304	ニッケルめっきのはんだ付け性に及ぼす酸化皮膜の影響	呉 文昌,千葉 淳	45	11	1121	1994	技術論文	電気めっき,電鍍	はんだ付け性,NiO膜,カソード還元
5305	ArプラズマによるダイヤモンドのプラズマCVD	祖父江和治,光田好孝,増子 昇,今井八	45	11	1126	1994	原著論文(研究,研究論文)	化学蒸着(CVD)	ダイヤモンド合成,Arプラズマ,プラズマCVD,プラズマガス,原子状
5306	マイクロ波プラズマCVDによるニッケル多結晶へのダイヤモンド合成	坂本幸弘,高谷松文	45	11	1130	1994	原著論文(研究,研究論文)	化学蒸着(CVD)	ダイヤモンド合成,マイクロ波プラズマ,Ni,単結晶
5307	熱拡散法により作製したスズ-ニッケル合金皮膜の分極特性に及ぼす熱処理の影響	園田 司,松田好晴	45	11	1136	1994	原著論文(研究,研究論文)	拡散皮膜	Sn,Ni,合金化,熱拡散,分極特性
5308	クロムめっき浴からの窒化クロムの誘起共析	森河 務,横井昌幸	45	11	1141	1994	原著論文(研究,研究論文)	電気めっき,電鍍	Cr,電気めっき,N,CrN,化学状態,X線光電子分光分析(XPS)
5309	無電解NiReP合金薄膜抵抗体へのパルス加熱法の適用	川口 純,達坂哲彌	45	11	1146	1994	原著論文(研究,研究論文)	無電解めっき	Ni,Re,P,合金めっき,無電解めっき,電気抵抗,非晶質膜,パル
5310	ホウ酸硫酸混合電解液を用いるアルミニウムの陽極酸化とホウ素含有量	森崎重喜,長瀬裕和	45	11	1152	1994	原著論文(研究,研究論文)	アノード酸化	Al,アノード酸化,即発ガンマ線スペクトル分析(PGA),B含有量
5311	エポキシ樹脂塗装AZ91Dマグネシウム合金の腐食挙動	佐藤文博,浅川義彦	45	11	1158	1994	原著論文(研究,研究論文)	塗布,塗装	Mg,エポキシ樹脂,被覆,腐食挙動
5312	軟鋼の腐食に対するポリビニルピリジン塩酸塩の抑制効果	岡原治男,香西道雄,松田好晴	45	11	1164	1994	速報論文	その他(新技術を含む)	腐食抑制効果,ポリビニルピリジン塩酸塩,軟鋼,腐食,塩酸
5313	巻頭言:会誌編集委員会から	内田 勇	45	12	1171	1994	巻頭言(エッセイ)		
5314	薄膜技術と表面技術	達坂哲彌,黒川義昭	45	12	1172	1994	総説	その他(新技術を含む)	表面処理技術,薄膜,湿式製膜法,乾式製膜法
5315	新しい電気,電子,磁気特性の発現を探る-湿式法による酸化物超伝導膜の作製	小浦延幸,根岸秀之	45	12	1179	1994	解説	塗布,塗装	酸化物,超伝導体,薄膜,湿式製膜法,電気泳動電着,塗布熱分解,ゾル-ゲル法
5316	新しい電気,電子,磁気特性の発現を探る-電解による複合酸化物薄膜の作製	松本泰道	45	12	1184	1994	解説	アノード析出	電気化学的合成,酸化物薄膜,ペロブスカイト
5317	新しい電気,電子,磁気特性の発現を探る-有機機能性分子の薄膜化技術	志村美知子	45	12	1189	1994	解説	その他(新技術を含む)	分子薄膜,フタロシアニン,分子配向,ラングミュアー(LB)法,分子線エピタキシー(MBE)法,蒸着重量子井戸,共鳴トンネル構造,界面平坦性,有機金属気相成長法(MOVPE)法,分子線エピタキ水素吸蔵合金,金属水素化合物,薄膜
5318	新しい電気,電子,磁気特性の発現を探る-半導体超薄膜と量子井戸	篠原正典,井上直久	45	12	1194	1994	解説	その他(新技術を含む)	光磁気ディスク,磁性多相膜,磁性薄膜
5319	新しい電気,電子,磁気特性の発現を探る-水素吸蔵合金薄膜	釜崎清治	45	12	1198	1994	解説	物理蒸着(PVD)	ダイヤモンド,薄膜,析出,プラズマ,多結晶
5320	新しい電気,電子,磁気特性の発現を探る-高密度光磁気記録用薄膜	金子正彦	45	12	1203	1994	解説	その他(新技術を含む)	プラズマCVD,薄膜,Si3N4-SiC膜,ダイヤモンド状炭素(DLC),表面処理鋼板,PVD,CVD,金属皮膜,セラミック皮膜
5321	薄くて強い膜-ダイヤモンド膜の作製	明石和夫	45	12	1208	1994	解説	化学蒸着(CVD)	亜鉛めっき鋼板,クロメート皮膜,樹脂膜,耐食性,塗料密着性
5322	薄くて強い膜-プラズマCVD法によるアモルファス炭化,窒化物膜	鎌田喜一郎	45	12	1215	1994	解説	化学蒸着(CVD)	ゾルゲル法,ステンレス鋼,コーティング法,耐熱性,耐酸性,撥水
5323	薄くて強い膜-ドライプロセスによる新表面処理鋼板の開発	木部 洋	45	12	1220	1994	解説	化学蒸着(CVD)	湿式製膜法,機能材料,防食,機械特性,電気特性,物理特性
5324	薄くて強い膜-亜鉛系めっき鋼板の防食コーティング	加藤忠一	45	12	1226	1994	解説	化成処理	Pd,無電解めっき,プリント配線板,表面実装,相互接続
5325	薄くて強い膜-ゾル-ゲル法によるステンレス鋼へのコーティング	和泉圭二	45	12	1230	1994	解説	熱分解-ゾル-ゲル法	超格子,多層めっき,製作方法,薄分散めっき,共析,Cu,S O4系
5326	ウェットプロセスによる材料形成技術	松村宗順	45	12	1235	1994	解説	電気めっき,電鍍	光磁気ディスク,磁界変調法,内部ひずみ
5327	基礎・新技術-表面実装及び相互接続を目的としたプリント配線板の表面処理	縄舟秀美,城戸靖彦	45	12	1240	1994	解説	無電解めっき	反応性スパッタリング,Cu2O,CuO,薄膜,電気抵抗,光導電性
5328	基礎・新技術-超格子薄膜の作製の可能分散めっきにおける共析機構	渡辺 徹	45	12	1244	1994	解説	電気めっき,電鍍	アークイオンレーティング(AIP),Ti-Zr合金,被覆,硬質窒化物,硬質炭化物,セラミック
5329	"特集/薄膜技術の現状と展開によせて"	林 秀考	45	12	1250	1994	解説	電気めっき,電鍍	
5330	NdDyFeCo光磁気ディスク媒体における高感度記録膜の開発	吉原佐智男	45	12	1254	1994	随想		
5331		小川 涉,川崎 実	45	12	1255	1994	技術論文	物理蒸着(PVD)	
5332	反応性スパッタ法により作製した銅酸化物薄膜の電気的性質	中島宏幸,樹井正義,金子富士男,和田達明,竹内 学	45	12	1260	1994	原著論文(研究,研究論文)	物理蒸着(PVD)	
5333	アークイオンレーティング(AIP)法によるTi-Zr合金の炭化物及び窒化物の薄膜作製	姜 求賢,醍醐幸雄,内田裕之,黄 燕清	45	12	1270	1994	原著論文(研究,研究論文)	物理蒸着(PVD)	

5334	高周波プラズマCVD法によって形成された酸化ケイ素膜のガス透過性	並木恒久, 平川叙夫	45	12	1276	1994	原著論文(研究, 研究論文)	化学蒸着(CVD)	プラズマCVD. SiO ₂ . ポリエチレンテレフタレート(PET). ヘキサメチルジシロキサン(HMDSO). ガスダイヤモンド. CVD. マイクロ波プラズマ. 低温成長
5335	マイクロ波プラズマCVDによるダイヤモンドの低温合成	坂本幸弘, 高谷松文	45	12	1276	1994	原著論文(研究, 研究論文)	化学蒸着(CVD)	プラズマ重合. 炭素環状化合物. カソード分極. 膨張黒鉛. X線光電子分光分析(XPS)
5336	C環状化合物プラズマ重合膜による膨張黒鉛上のカソード反応の抑制	百瀬義広, 菅原郁夫, 岩波和英, 西田達也, 藤田 淳	45	12	1282	1994	原著論文(研究, 研究論文)	その他(新技術を含む)	耐食性. Ni, Fe, B. 合金めっき. 無電解めっき. 5% NaCl
5337	無電解Ni - Fe - B合金めっき皮膜の腐食特性	青木公二, 金 東賢, 鷹野 修	45	12	1287	1994	原著論文(研究, 研究論文)	無電解めっき	密着性. 薄膜. Ti, Pt. にかわ効果(Glue-effect)
5338	Ti接着層によるPt / TiO ₂ 間の密着性向上とその影響	近藤市治, 近藤憲司, 竹中 修, 白井誠, 太田 実, 金原釜崎清治, 池淵 博	45	12	1292	1994	原著論文(研究, 研究論文)	熱処理(酸化・窒化・炭化)	Fe. 電気めっき. エピタキシャル成長. 二層膜. 界面転位
5339	Au単結晶薄膜上へのFe電析膜のエピタキシャル成長と界面転位の導入	田辺良美, 伊勢昌伸, 榎本英彦, 中永 陽, 寺田茂巨, 山内英子, 小見	45	12	1297	1994	原著論文(研究, 研究論文)	電気めっき・電鍍	Fe, C. 合金めっき. マルテンサイト. 加熱. 析出硬化
5340	電析Fe - C合金膜の相変態と硬化変化	佐藤守夫, 石田 章, 武井 厚, 宮崎修一	45	12	1302	1994	原著論文(研究, 研究論文)	電気めっき・電鍍	Ti - Ni. 形状記憶合金. スパッタリング. マイクロマシン
5341	Ti - Ni形状記憶合金薄膜の変態温度に及ぼす熱サイクルの効果	上宮成之, 梶原昌高, 古関美保, 小島三井俊明, 金尾絃征	45	12	1308	1994	速報論文	物理蒸着(PVD)	Pd. 複合膜. H ₂ . 製膜. CVD
5342	CVD法によるパラジウム複合膜の作製	高, 古関美保, 小島三井俊明, 金尾絃征	45	12	1310	1994	速報論文	化学蒸着(CVD)	電気めっき. 界面現象. 金属薄膜. Co, P. 合金めっき. 無電解めっき. 電解. 磁気特性
5343	二液相界面における金薄膜の製造	松原 浩, 山田明文	45	12	1312	1994	速報論文	電気めっき・電鍍	電気めっき. 定電位パルス電解. Ni. 薄膜. 表面形状
5344	無電解Co - Pめっきへの電解の併用による磁気特性の変化	吉村俊一, 吉原佐知雄, 白樫高史, 佐藤栄一	45	12	1314	1994	速報論文	無電解めっき	Ti, Ni, TiAlN. 硬質皮膜. マグネトロンスパッタリング. Ti. 下地層
5345	定電位パルス電解によるニッケル薄膜の作製	原田 寛, 平田 章, 小柳 剛	45	12	1316	1994	Letters	電気めっき・電鍍	
5346	TiAlN / Ti薄膜の作製方法		45	12	1318	1994	Letters	物理蒸着(PVD)	